

การพัฒนาสารเคลือบดีแอลซี (DLC) ด้วยวิธีพีอีซีวีดี เพื่อการยืดอายุการใช้งานของ แม่พิมพ์สำหรับการหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียม Development of Diamond-like Carbon (DLC) Coating by PE-CVD Technique for

Improving Aluminium Casting Die Life

วิทิต จันทร์โชคทวี Witit Janchocktawee

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of

Thesis Submittee in Tartial Furniment of the Requirements for the Degree

Master of Engineering in Materials Engineering

Prince of Songkla University

2557

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อวิทยานิพนธ์	การพัฒนาสารเคลือบดีแอลซี (DLC) ด้วยวิธีพีอีซีวีดี เพื่อการยืดอายุการ
	ใช้งานของแม่พิมพ์สำหรับการหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียม
ผู้เขียน	นายวิทิต จันทร์โชคทวี
สาขาวิชา	วิศวกรรมวัสคุ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	คณะกรรมการสอบ
 (คร.วิษณุ ราชเพ็ชร)	ประธานกรรมการ (คร.ชีวิตา สุวรรณชวลิต)
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	กรรมการ (คร.วิษณุ ราชเพีชร)
	กรรมการ (รองศาสตราจารย์ คร.เล็ก สีกง)
	กรรมการ

(คร.สมใจ จันทร์อุคม)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานกรินทร์ อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็น ส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

ขอรับรองว่า ผลงานวิจัยนี้มาจากการศึกษาวิจัยของนักศึกษาเองและได้แสดงความขอบคุณบุคคลที่ มีส่วนช่วยเหลือแล้ว

> ลงชื่อ..... (คร.วิษณุ ราชเพ็ชร) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

> ลงชื่อ..... (นายวิทิต จันทร์ โชคทวี) นักศึกษา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผลงานวิจัยนี้ไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งในการอนุมัติปริญญาในระคับใคมาก่อนและ ไม่ได้ถูกใช้ในการยื่นขออนุมัติปริญญาในขณะนี้

> ลงชื่อ..... (นายวิทิต จันทร์ โชคทวี) นักศึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์ การพัฒนาสารเกลือบดีแอลซีเพื่อยี่ดอายุการไช้งานแม่พิมพ์	โอลูมีเนียม
ด้วยวิธีพีอีซีวีดี	
ผู้เขียน นายวิทิต จันทร์โชกทวี	
สาขาวิชา วิศวกรรมวัสดุ	
ปีการศึกษา 2557	

บทคัดย่อ

ฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชร (DLC) และฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรที่ถูกเจือด้วยธาตุในโตรเจน (NDLC) ถูกเคลือบลงบนเหล็กกล้าเกรด AISI H13 และกระจกสไลด์เกรดการก้า ด้วยเทกนิก พลาสมาซีวีดี โดยใช้ความถี่ 13.56 เมกะเฮิร์ต โดยใช้ก๊าซอาร์กอน, ก๊าซมีเทน และก๊าซไนโตรเจน เป็นสารตั้งต้น ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอัตราการใหลของก๊าซ อุณหภูมิ และกำลังกลื่นวิทยุ หลังจาก การได้เกลือบสารเกลือบบนวัสดุฐานแล้วได้ทำการพิสูจน์หมู่ฟังก์ชั่นบนฟิล์ม และสัดส่วนของ พันธะระหว่างเพชรต่อกราไฟต์ (sp³/sp² carbon bonds) ทำได้โดยเทกนิก Fourier Transform Infrared spectroscopy (FTIR) และเทกนิกรามานสเปกโตรสโกปี ตามลำดับ

คุณสมบัติเชิงกลของฟิล์ม เช่น ความแข็ง (Hardness) แรงยึดเกาะระหว่างฟิล์มและสารตั้ง ต้น (Adhesion force) การสึกหรอของฟิล์มในรูปแบบของสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน และความ ด้านทานอุณหภูมิ ทำได้โดยใช้เทคนิคนาโนอินเดนเทชั่น เครื่องทดสอบความด้านทานต่อการขูดขีด เครื่องไทรโบมิเตอร์ ชนิด Ball-on disk และ Thermalgravimetric Analyzer (TGA) ตามลำดับ

ผลการทดสอบด้วยเทคนิค FTIR พบว่าฟิล์มที่สังเคราะห์ได้พบหมู่ฟังก์ชัน C-H ที่เลขคลื่น 2800-3000 cm⁻¹ ซึ่งเป็นลักษะเฉพาะของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร ผลการทคสอบด้วยเทคนิครา มานสเปกโตรสโคปีพบยอดคลื่นของ D และ G ในช่วง 1360 ± 20 และ 1580 ± 10 ตามลำดับ และ ก่า I_p/I_G ของฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชรที่ต่ำสุดที่ได้มีก่า 0.63 ซึ่งมีสัดส่วนโครงสร้าง sp³ ประมาณ 40-50% ผลการวิเคราะห์สมบัติเชิงกลพบว่าฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชรที่เงือธาตุในโตรเจนมีก่าความ แข็ง แรงยึดเกาะของฟิล์มและความต้านทานอุณหภูมิสูงที่ดีกว่าฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชรที่ไม่ได้ทำ การเงือธาตุในโตรเจน แต่ก่าสัมประสิทธิ์ความเสียคทานของฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชรที่เงือธาตุ ในโตรเจนให้ก่าที่ต่ำกว่าฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชรที่ไม่ได้ทำการเงือธาตุในโตรเจน
 Thesis Title
 Development of DLC Films for Improve Aluminum Die Life by PECVD

 Technique
 Technique

Author Mr. Witit Janchocktawee

Major Program Materials Engineering

Academic Year 2014

Abstract

Diamond-like carbon (DLC) and Nitrogen doped Diamond-like carbon (NDLC) films were deposited on AISI H13 steel and commercial grade slide glass by Plasma Enhance Chemical Vapor Deposition (PECVD) technique at frequency 13.56 MHz by using Argon gas (Ar), Methane gas (CH₄) and Nitrogen gas (N₂) as precursor gases, on varying of precursor gases flow rate, temperature and RF power. To determine functional group and sp^3/sp^2 ratio were using Fourier Transform Infrared (FTIR) and Raman spectroscopy respectively. The mechanicals properties of the films such as hardness, adhesion force between films and substrate, film friction coefficient and thermal resistance were measured by nano-indentation, scratch test, tribometer ball-on disk type and thermalgravimetric analyzer (TGA) respectively. The results of FTIR are shown all of the films have functional group of C-H at wavenumber 2800-3000 cm⁻¹ indicated that our films are DLC. The results of Raman spectroscopy show D and G peak in range 1360 ± 20 and 1580 ± 10 respectively. The NDLC films have a better hardness, adhesion force and thermal resistance than DLC films. But friction coefficient of DLC films was lower than NDLC.

สารบัญ

	หน้า
บทกัดย่อ	-5-
กิตติกรรมประกาศ	-7-
สารบัญ	-8-
รายการตาราง	-12-
รายการรูป	-14-
บทที่	
1.บทน้ำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของการวิจัย	1
1.2 ทฤษฎีและหลักการ	2
1.2.1 คาร์บอน (Carbon,C)	2
1.2.1.1 INV5 (Diamond)	2
1.2.1.2 แกรไฟต์ (Graphite)	3
1.2.1.3 ฟูลเลอรีน (Fullerene)	4
1.2.1.4. ท่อนาโนคาร์บอน (Carbon Nanotubes)	5
1.2.1.5. นาโนโฟม (Nanofoam)	5
1.2.1.6. คาร์บอนคล้ายเพชร (Diamond-like carbon, DLC)	7
1.2.2. พลาสมา	10
1.2.2.1 ความหมายของพลาสมา	10
1.2.2.2 กระบวนการเกิดพลาสมา	11
1.2.3 กระบวนการตกสะสมไอเคมี (Chemical Vapor Deposition, CVD)	12
1.2.3.1 ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาตกสะสมไอเคมี	13
1.2.3.2 ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาตกสะสมไอทางเคมีเสริมพลาสมา	14
1.2.4 เหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อนเกรด AISI H13	17
1.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	18

-8-

สารบัญ (ต่อ)

-9-

ע	
หนา	

	1.4 ขอบเขตของโครงการวิจัย	26
	1.5 วัตถุประสงค์ของโครงการ	27
	1.6ประโยชน์ที่กาดว่าจะได้รับ	27
	1.7 สถานที่ทำการวิจัย	27
2. วิธีก	การคำเนินงานวิจัย	28
	2.1วัสคุและอุปกรณ์การทคลอง	28
	2.2 การดำเนินการทดลอง	37
	2.2.1 การสังเคราะห์ฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร	37
	2.2.1.1 กิจกรรมที่ 1 : การเตรียมชิ้นงานตัวอย่าง	37
	2.2.1.2 กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาสัคส่วนที่เหมาะสมของของแก๊สมีเทนต่อ	37
	การเกิดฟิล์ม DLC	
	2.2.1.3 กิจกรรมที่ 3 : ศึกษากำลังของคลื่นความถี่วิทยุที่เหมาะสมใน	38
	การเกิด DLC ที่อุณหภูมิ 25°C	
	2.2.1.4 กิจกรรมที่ 4 : ศึกษากำลังของคลื่นความถี่วิทยุที่เหมาะสมใน	38
	การเกิด DLC ที่อุณหภูมิ 300°C	
	2.2.1.5 กิจกรรมที่ 5 : ศึกษาสัคส่วนของแก๊สในโตรเจนที่เหมาะสมที่	39
	กำลังของคลื่นความถี่วิทยุ 100 วัตต์	
	2.2.1.6 กิจกรรมที่ 6 : ศึกษาสัคส่วนของแก๊ส ในโตรเจนที่เหมาะสมที่	39
	กำลังของคลื่นความถี่วิทยุ 200 วัตต์	
	2.2.1.7 กิจกรรมที่ 7 : ศึกษาผลของกำลังของคลื่นความถี่วิทยุที่มีต่อ	40
	สมบัติฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชร	
	2.2.2 การทคสอบความแขึ่งของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร	41
	2.2.3 การทคสอบความแข็งแรงในการยึดเกาะของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร	43
	2.2.4 การทคสอบความเสียดทานของฟิล์มคาร์บอนกล้ายเพชร	45

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.2.5 การทคสอบความต้านทานความร้อนของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร	45
3. ผลการทคลองและวิเคราะห์ผลการทคลอง	46
3.1 การศึกษาตัวแปรในการสังเคราะห์ฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรด้วยวิธีตสะสม	46
ใอเกมีเสริมพลาสมา	
3.1.1 ศึกษาสัคส่วนที่เหมาะสมของของแก๊สมีเทนต่อการเกิดฟิล์ม DLC	46
3.1.1.1 ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี	46
3.1.1.2. ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิครามานสเปกโตรสโกปี	47
3.1.1.3 ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเอ๊กซ์เรย์โฟโตอิเล็กตรอนสเปค	53
โตรสโคปี (XPS)	
3.1.1.4 ผลการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (SEM)	55
3.1.2 ศึกษากำลังของคลื่นความถี่วิทยุที่เหมาะสมในการเกิด DLC ที่	56
อุณหภูมิ 25°C และ 300°C	
3.1.2.1 ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี	56
3.1.2.2 ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิครามานสเปกโตรสโคปี	59
3.1.2.3 ผลการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (SEM)	65
3.1.3. สรุปผลการศึกษาตัวแปรเบื้องต้นในการสังเคราะห์สารเคลือบฟิล์ม	66
คาร์บอนคล้ายเพชร	
3.2 การศึกษาการอิทธิพลของธาตุในโตรเจนที่มีผลต่อการสังเคราะห์ฟิล์ม	67
คาร์บอนคล้ายเพชร	
3.2.1 ศึกษาสัคส่วนของแก๊สในโตรเจนที่เหมาะสม ที่กำลังคลื่นความถี่วิทยุ	67
100 วัตต์	
3.2.1.1 ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี	67
3.2.1.2 ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิครามานสเปกโตรส โคปี	68

สารบัญ (ต่อ)

-11-

	หน้า
3.2.1.3 ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเอ๊กซ์เรย์โฟโตอิเล็กตรอนสเปค	75
โตรสโคปี (XPS)	
3.2.2 ศึกษาสัดส่วนของแก๊สในโตรเจนที่เหมาะสม ที่กำลังคลื่นความถี่วิทยุ	77
200 วัตต์	
3.2.2.1 ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี	77
3.2.2.2 ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิครามานสเปกโตรสโคปี	78
3.2.2.3 ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเอ๊กซ์เรย์โฟโตอิเล็กตรอนสเปค	85
โตรส โคปี (XPS)	
3.2.2.4 ผลการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (SEM)	86
3.2.3 สรุปผลการศึกษาการอิทธิพลของธาตุในโตรเจนที่มีผลต่อการ	88
สังเคราะห์ฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชร	
3.3 ผลการวิเคราะห์สมบัติเชิงกลของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร	90
3.3.1 ผลการวิเคราะห์ความแข็ง	90
3.3.2 ผลการวิเกราะห์แรงยึดเกาะ	91
3.3.3 ผลการวิเคราะห์ก่าสัมประสิทธิ์กวามเสียดทาน	93
3.3.4 ผลการวิเคราะห์ความด้านทานต่อความร้อน	96
4.บทสรุปและข้อเสนอแนะ	98
4.1 สรุปผล	98
4.2 ข้อเสนอแนะ	98
บรรณานุกรม	99
ภาคผนวก	103
ประวัติผู้เขียน	110

รายการตาราง

ตารางที่		หน้า
1.1	เปรียบเทียบสมบัติของโครงสร้างอสัณฐาน (amorphous carbons) กับ	9
	(diamond),graphite, C60 และ Polyethylene (Robertson, 2002)	
1.2	องค์ประกอบของธาตุของเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน	17
	เกรด AISI H13 (J.R. Davis, 1996)	
1.3	สมบัติทางกายภาพของเหล็กกล้ำเครื่องมือ AISI H13 (Thai-German	17
	special steel canter, 2010)	
1.4	สมบัติทางกลของเหล็กกล้ำเครื่องมือ AISI H13 (Thai-German special	18
	steel canter, 2010)	
2.1	วัสคุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการทคลอง	28
2.2	พารามิเตอร์ที่ศึกษาอัตราการใหลของ CH4	37
2.3	พารามิเตอร์ที่ศึกษากำลังของคลื่นความถี่วิทยุที่อุณหภูมิห้อง	38
2.4	พารามิเตอร์ที่ศึกษากำลังของคลื่นความถี่วิทยุที่อุณหภูมิ 300°C	38
2.5	พารามิเตอร์ที่ศึกษาอัตราการไหลของ ${ m N_2}$ ที่กำลังของคลื่นความถี่วิทยุ	39
	100 วัตต์	
2.6	พารามิเตอร์ที่ศึกษาอัตราการไหลของ $\mathrm{N_2}$ ที่กำลังคลื่นของความถี่วิทยุ	40
	200 วัตต์	
2.7	พารามิเตอร์ที่ศึกษาฟิลม์คาร์บอนคล้ายเพชรที่โด๊ปไนโตรเจนโคย	40
	ปรับเปลี่ยนกำลังคลื่นของความถี่วิทยุ	
3.1	ตำแหน่ง Peak D, Peak G และ Intensity ratio (I _D / I _G) ของฟิล์ม	51
	คาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการใหลของ CH₄ ต่างกัน และที่กำลังคลื่น	
	ความถี่วิทยุ 100 วัตต์	
3.2	ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XPS	53

รายการตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
3.3	ตำแหน่ง Peak D, Peak G และ Intensity ratio (I _D / I _G) ของฟิล์ม	63
	คาร์บอนคล้ายเพชร ที่กำลังคลื่นความถี่วิทยุต่างกันที่อัตราการไหล	
	ของ CH_4 15 sccm	
3.4	ตำแหน่ง Peak D, Peak G และ Intensity ratio (I _D / I _G) ของฟิล์ม	73
	คาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการใหลของ ${ m N}_2$ แตกต่างกันที่อัตราการ	
	ใหลของ CH4 15 sccm ที่กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 100 วัตต์	
3.5	ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XPS	75
3.6	ตำแหน่ง Peak D, Peak G, I_D , I_G และ Intensity ratio (I_D/I_G) ของฟิล์ม	83
	คาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการใหลของ \mathbf{N}_2 แตกต่างกันที่อัตราการ	
	ใหลของ CH4 15 sccm ที่กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 200 และที่อุณหภูมิ	
	วัสคุฐาน 300°C	
3.7	ค่าความแข็งของฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรที่อัตราการไหลของ N_2	90
	แตกต่างกัน และควบคุมอัตราการใหลของ CH4 ที่ 15 seem กำลังคลื่น	
	ความถี่วิทยุ 200 วัตต์ อุณหภูมิวัสคุฐาน 300°C	
3.8	ค่าแรงที่ใช้ในการทคสอบความแข็งแรงในการยึดเกาะของฟิล์ม	93
	คาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการใหลของ N ₂ แตกต่างกัน และควบคุม	
	อัตราการใหลของ CH4 ที่ 15 sccm กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 200 วัตต์	
	อุณหภูมิวัสคุฐาน 300°C	
3.9	สัมประสิทธิ์ความของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการไหลของ $\mathrm{N_2}$	94
	แตกต่างกัน และควบคุมอัตราการใหลของ CH4 ที่ 15 seem กำลังคลื่น	
	ความถี่วิทยุ 200 วัตต์	

รายการรูป

	۰	
รูปที่		หน้า
1.1	โครงสร้างของเพชร	3
1.2	โครงสร้างของแกรไฟต์	4
1.3	โครงสร้างของฟูลเลอรีน	5
1.4	โครงสร้างของท่อนาโนคาร์บอน	5
1.5	คาร์บอนนาโนโฟม	6
1.6	เปรียบเทียบโครงสร้างของแกรไฟต์ เพชร และคาร์บอนคล้ายเพชร	7
1.7	เฟสไดอะแกรมของคาร์บอน	9
1.8	แสดงปฏิกิริยาการตกสะสมไอเคมี	14
1.9	แสดงภายในเตาปฏิกิริยาการตกสะสมอเคมีเสริมพถาสมา	15
1.10	ความเสียหายที่เกิดขึ้นในแม่พิมพ์เนื่องจากความร้อน	19
1.11	กระบวนการสังเคราะห์ฟิล์มบางด้วยวิธีซีวิดีต่างชนิดกัน	21
1.12	หลักการทำงานของเทคนิคอินฟราเรคสเปคโตรสโคปี	22
1.13	หลักการทำงานของเทคนิครามานสเปกโตรสโกปี	24
2.1	วัสคุฐานที่ใช้ในการทคลอง	30
2.2	อุปกรณ์ที่ใช้ในในการเคลือบฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรในส่วนระบบ	31
	สุญญากาศ(a) Rotary pump (b) Air cooling unit (c) Turbomolecular	
	pump (d) Turbodrive (e) PeeningGauge (f) Pirani Gauge (g) Pressure	
	display unit	
2.3	เครื่องกำเนิดคลื่นความถี่วิทยุ RF Generator CITO 1310	32
2.4	ระบบควบคุมอัตราการใหลของแก๊ส (a) Mass flow controller	32
	(b) 4-Channel readout	
2.5	ระบบควบคุมอุณหภูมิวัสคุฐาน (Heater controller)	32
2.6	อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในในการทำความสะอาควัสคุฐาน	33
	(a)อะซิโตน (Acetone) (b) เครื่องสั่นอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Cleaner)	

รูปที่		หน้า
2.7	แก๊สที่ใช้ในระบบการเคลือบฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร	33
2.8	เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์อินฟราเรคสเปกโตรสโกปี	34
	(Fourier transform infrared spectroscopy, FTIR)	
2.9	เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์รามานสเปกโตรสโกปี	34
2.10	เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์เอ็กซ์เรย์โฟโตอิเล็กตรอนสเปคโตรสโกปี	34
2.11	กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)	35
2.12	Thermal gravimetric Analyzer (TGA)	35
2.13	Nano-indentator	35
2.14	Tribometer (Scratch test)	36
2.15	Tribometer (Ball on disc)	36
2.16	ลักษณะกราฟทดสอบความแข็ง	41
2.17	เครื่องทคสอบความสามารถในการยึดเกาะ	43
2.18	ลักษณะความเสียหายที่เกิดบนผิวเคลือบ	44
3.1	ผลการวิเคราะห์ FTIR ของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรอัตราการใหลของ	48
	CH4 แตกต่างกัน ภายใต้เงื่อนไขอุณหภูมิวัสคุฐาน 300°C และกำลังของ	
	กลื่นกวามถี่ 100 วัตต์	
3.2	รามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการใหลของ	48
	CH₄ แตกต่างกันภายใต้เงื่อนไขอุณหภูมิวัสคุฐาน 300°C และกำลังของ	
	คลื่นความถี่วิทยุ 100 วัตต์	
3.3	รามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มคาร์บอนกล้ายเพชรที่อัตราการใหลของ	49
	CH4 ที่ 5 sccm ที่กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 100 วัตต์	
3.4	รามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการใหลของ	49
	CH4 ที่ 10 sccm ที่กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 100 วัตต์	

รูปที่		หน้า
3.5	รามานสเปกโตรส โคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการไหล	50
	ของ CH4 ที่ 15 seem ที่กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 100 วัตต์	
3.6	รามานสเปกโตรส โคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการไหล	50
	ของ CH4 ที่ 20 seem ที่กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 100 วัตต์	
3.7	รามานสเปกโตรส โคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการไหล	51
	ของ CH4 ที่ 50 sccm ที่กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 100 วัตต์	
3.8	ความสัมพันธ์ระหว่าง ตำแหน่งของ D Peak และ G Peak กับอัตราการ	52
	ใหลของ CH₄ ที่กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 100 วัตต์	
3.9	อัตราส่วน Intensity ratio (${ m I_D}/{ m I_G}$) กับอัตราการไหลของ ${ m CH_4}$ ที่กำลัง	52
	คลื่นความถี่วิทยุ 100 วัตต์	
3.10	ผลการวิเคราะห์ XPS ของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่ อัตราการไหล	54
	ของ CH4 ที่ 5 sccm กำลังคลื่นความถี่วิทยุที่ 100 วัตต์ และ อุณหภูมิ	
	วัสคุฐาน 300°C	
3.11	ผลการวิเคราะห์ XPS ของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่ อัตราการไหล	54
	ของ CH4 ที่ 15 sccm กำลังคลื่นความถี่วิทยุที่ 100 วัตต์ และ อุณหภูมิ	
	วัสคุฐาน 300°C	
3.12	รูปที่ 3.12 ความหนาของฟิล์ม DLC ที่อัตราการไหลของ CH4 ที่	55
	a.) 5 sccm b.) 10 sccm c.) 15 sccm d.) 20 sccm uaz e.) 50 sccm	
3.13	ผลการวิเคราะห์ FTIR ของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่กำลังของคลื่น	56
	ความถี่แตกต่างกันภายใต้เงื่อนไขอัตราการไหลของ CH4 15 sccm	
	อุณหภูมิวัสคุฐานที่ 25 °C	
3.14	ผลการวิเคราะห์ FTIR ของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่กำลังของคลื่น	57
	ความถี่แตกต่างกันภายใต้เงื่อนไขอัตราการไหลของ CH4 15 sccm	
	อุณหภูมิวัสคุฐานที่ 300°C	

	u u u u u u u u u u u u u u u u u u u	
รูปที่		หน้า
3.15	กราฟแสดงผลการวิเคราะห์รามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มคาร์บอน	59
	คล้ายเพชรที่กำลังคลื่นความถี่วิทยุแตกต่างกัน และอัตราการใหลของ	
	CH4 15 sccm และอุณหภูมิวัสคุฐาน 300°C	
3.16	รามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่กำลังคลื่นความถื่	59
	วิทยุ 50 วัตต์ อัตราการไหลของ CH4 15 sccm และอุณหภูมิวัสคุฐาน	
	300°C	
3.17	รามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่กำลังคลื่นความถื่	60
	วิทยุ 75 วัตต์ อัตราการไหลของ CH4 15 sccm และอุณหภูมิวัสคุฐาน	
	300°C	
3.18	รามานสเปกโตรสโคปีของฟีล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่กำลังคลื่นความถื่	60
	วิทยุ 100 วัตต์ อัตราการไหลของ CH₄ 15 sccm และอุณหภูมิวัสคุฐาน	
	300°C	
3.19	รามานสเปกโตรสโคปีของฟีล์มการ์บอนกล้ายเพชรที่กำลังกลื่นความถื่	61
	วิทยุ 125 วัตต์ อัตราการไหลของ CH4 15 sccm และอุณหภูมิวัสคุฐาน	
	300°C	
3.20	รามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรที่กำลังกลื่นความถื่	61
	วิทยุ 150 วัตต์ อัตราการไหลของ CH4 15 sccm และอุณหภูมิวัสคุฐาน	
	300°C	
3.21	รามานสเปกโตรสโคปีของฟีล์มการ์บอนกล้ายเพชรที่กำลังกลื่นความถื่	62
	วิทยุ 175 วัตต์ อัตราการไหลของ CH4 15 sccm และอุณหภูมิวัสคุฐาน	
	300°C	
3.22	รามานสเปกโตรสโคปีของฟีล์มการ์บอนกล้ายเพชรที่กำลังกลื่นกวามถื่	62
	วิทยุ 200 วัตต์ อัตราการไหลของ CH4 15 sccm และอุณหภูมิวัสคุฐาน	
	300°C	

รูปที่		หน้า
3.23	ความสัมพันธ์ระหว่าง ตำแหน่งของ D Peak และ G Peak กับกำลัง	63
	คลื่นความถี่วิทยุ ที่อัตราการ ใหลของ CH4 15 sccm และอุณหภูมิวัสคุ	
	ฐาน 300°C	
3.24	อัตราส่วน Intensity ratio (${ m I_D}/{ m I_G}$) กับกำลังคลื่นความถี่วิทยุ 100 ที่อัตรา	64
	การไหลของ CH4 15 sccm และอุณหภูมิวัสคุฐาน 300°C	
3.25	ความหนาของฟิล์ม DLC ที่อัตราการใหลของ CH4 ที่ 15 sccm	65
	อุณหภูมิ 300°C และกำลังคลื่นความถี่วิทยุ a.) 50 W, b.) 75 W,	
	c.) 125 W, d.) 150 W, e.) 175 W และ f.) 200 W	
3.26	ผลการวิเคราะห์ FTIR ของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรอัตราการไหลของ	67
	N ₂ แตกต่างกัน ภายใต้เงื่อนไขของอัตราการไหลของ CH ₄ 15 sccm	
	กำลังของคลื่นความถี่วิทยุ 100 วัตต์ อุณหภูมิวัสคุฐานที่ 300°C	
3.27	รามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการใหล	68
	ของ N2 ที่แตกต่างกัน และที่อัตราการใหลของ CH4 15 sccm กำลัง	
	กลื่นความถี่วิทยุ 100 วัตต์	
3.28	รามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการใหล	69
	ของ N $_2$ ที่ 0 sccm และที่อัตราการใหลของ CH $_4$ 15 sccm กำลังคลื่น	
	ความถี่วิทยุ 100 วัตต์	
3.29	รามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการใหล	69
	ของ N $_2$ ที่ 5 sccm และที่อัตราการใหลของ ${ m CH}_4$ 15 sccm กำลังกลื่น	
	ความถี่วิทยุ 100 วัตต์	
3.30	รามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการใหล	70
	ของ $ m N_2$ ที่ 7 sccm และที่อัตราการใหลของ $ m CH_4$ 15 sccm กำลังคลื่น	
	ความถี่วิทยุ 100 วัตต์	

รูปที่		หน้า
3.31	รามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรที่อัตราการใหล	70
	ของ N2 ที่ 10 sccm และที่อัตราการใหลของ CH4 15 sccm กำลังคลื่น	
	ຄວາມຄົ່ວີກຍຸ 100 ວັຕຕ໌	
3.32	รามานสเปกโตรส โคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการไหล	71
	ของ N2 ที่ 12 sccm และที่อัตราการใหลของ CH4 15 sccm กำลังคลื่น	
	ความถี่วิทยุ 100 วัตต์	
3.33	รามานสเปกโตรส โคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการไหล	71
	ของ N2 ที่ 15 sccm และที่อัตราการใหลของ CH4 15 sccm กำลังคลื่น	
	ຄວາມຄື່ວີກຍຸ 100 ວັຕຕ໌	
3.34	รามานสเปกโตรส โคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการไหล	72
	ของ N ₂ ที่ 20 sccm และที่อัตราการใหลของ CH ₄ ที่ 15 sccm กำลังคลื่น	
	ຄວາມຄື່ວີກຍຸ 100 ວັຕຕ໌	
3.35	รามานสเปกโตรส โคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการไหล	72
	ของ N ₂ ที่ 25 sccm และที่อัตราการไหลของ CH ₄ ที่ 15 sccm กำลังคลื่น	
	ຄວາມຄື່ວີກຍຸ 100 ວັຕຕ໌	
3.36	รามานสเปกโตรส โคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการไหล	73
	ของ N2 ที่ 50 sccm และที่อัตราการ ใหลของ CH4 ที่ 15 sccm กำลังคลื่น	
	ຄວາມຄື່ວີກຍຸ 100 ວັຕຕ໌	
3.37	ความสัมพันธ์ระหว่าง ตำแหน่งของ D Peak และ G Peak กับอัตราการ	74
	ใหลของ $\mathrm{N_2}$ ที่ต่างกัน และที่อัตราการใหลของ $\mathrm{CH_4}$ 15 sccm กำลังคลื่น	
	ຄວາມຄື່ວີກຍຸ 100 ວັຕຕ໌	
3.38	อัตราส่วน Intensity ratio (I _D /I _G) กับอัตราการใหล	74
	ของ N_2 ที่ต่างกัน และที่อัตราการใหลของ CH_4 15 sccm กำลังคลื่น	
	ຄວາມຄື່ວີກຍຸ 100 ວັຕຕ໌	

รูปที่		หน้า
3.39	ผลการวิเคราะห์ XPS ของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่ อัตราการใหล	76
	ของ CH4 ที่ 15 sccm $ m N_2$ ที่ 15 sccm กำลังกลื่นกวามถี่วิทยุที่ 100 วัตต์	
	และ อุณหภูมิวัสคุฐาน 300°C	
3.40	ผลการวิเคราะห์ FTIR ของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรอัตราการใหลของ	77
	N ₂ แตกต่างกัน ภายใต้เงื่อนไขของอัตราการไหลของ CH ₄ 15 sccm	
	กำลังของคลื่นความถี่วิทยุ 200 วัตต์ อุณหภูมิวัสคุฐานที่ 300°C	
3.41	รามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการไหล	78
	ของ N2 ที่แตกต่างกัน และที่อัตราการใหลของ CH4 15 sccm กำลัง	
	คลื่นความถี่วิทยุ 200 วัตต์	
3.42	รามานสเปกโตรส โคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการไหล	79
	ของ N ₂ ที่ 0 sccm และที่อัตราการใหลของ CH ₄ 15 sccm กำลังคลื่น	
	ความถี่วิทยุ 200 วัตต์	
3.43	รามานสเปกโตรส โคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการไหล	79
	ของ N ₂ ที่ 5 sccm และที่อัตราการใหลของ CH ₄ 15 sccm กำลังคลื่น	
	ความถี่วิทยุ 200 วัตต์	
3.44	รามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการไหล	80
	ของ N2 ที่ 7 sccm และที่อัตราการใหลของ CH4 15 sccm กำลังคลื่น	
	ความถี่วิทยุ 200 วัตต์	
3.45	รามานสเปกโตรส โคปีของฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรที่อัตราการไหล	80
	ของ N2 ที่ 10 sccm และที่อัตราการใหลของ CH4 15 sccm กำลังคลื่น	
	ຄວາມຄື່ວີກຍຸ 200 ວັຕຕ໌	
3.46	รามานสเปกโตรส โคปีของฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรที่อัตราการไหล	81
	ของ N2 ที่ 12 sccm และที่อัตราการใหลของ CH4 15 sccm กำลังคลื่น	
	ความถี่วิทยุ 200 วัตต์	

รูปที่		หน้า
3.47	รามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการไหล	81
	ของ N ₂ ที่ 15 sccm และที่อัตราการใหลของ CH ₄ 15 sccm กำลังคลื่น	
	ความถี่วิทยุ 200 วัตต์	
3.48	รามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการไหล	82
	ของ N ₂ ที่ 20 sccm และที่อัตราการใหลของ CH ₄ 15 sccm กำลังคลื่น	
	ความถี่วิทยุ 200 วัตต์	
3.49	รามานสเปกโตรสโคปีของฟีล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการไหล	82
	ของ N ₂ ที่ 25 sccm และที่อัตราการใหลของ CH ₄ 15 sccm กำลังคลื่น	
	ความถี่วิทยุ 200 วัตต์	
3.50	รามานสเปกโตรสโคปีของฟีล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการไหล	83
	ของ N ₂ ที่ 50 sccm และที่อัตราการใหลของ CH ₄ 15 sccm กำลังคลื่น	
	ความถี่วิทยุ 200 วัตต์	
3.51	ความสัมพันธ์ระหว่าง ตำแหน่งของ D Peak และ G Peak กับอัตราการ	84
	ใหลของ $\mathrm{N_2}$ ที่ต่างกัน และที่อัตราการใหลของ $\mathrm{CH_4}$ 15 sccm กำลัง	
	คลื่นความถี่วิทยุ 200 วัตต์	
3.52	อัตราส่วน Intensity ratio (${ m I_D}/{ m I_G}$) กับอัตราการ ใหลของ ${ m N_2}$ ที่ต่างกัน	84
	และที่อัตราการไหลของ CH4 15 sccm กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 200 วัตต์	
3.53	ผลการวิเคราะห์ XPS ของฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรที่ อัตราการไหล	86
	ของ CH4 ที่ 15 sccm N $_2$ ที่ 15 sccm กำลังคลื่นความถี่วิทยุที่ 200 วัตต์	
	และ อุณหภูมิวัสคุฐาน 300°C	
3.54	ความหนาของฟิล์ม DLC ที่อัตราการไหลของ CH4 ที่ 15 sccm	87
	อุณหภูมิ 300°C กำลังคลื่นความถี่วิทยุ200 วัตต์ และอัตราการไหลของ	
	$N_2 \vec{\eta}$ a.) 5 sccm, b.) 10 sccm, c.) 15 sccm, d.) 20 sccm, e.) 25 sccm	
	และ f.) 50 sccm	

รูปที่		หน้า
3.55	ความแข็งของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการใหลของ ${ m N_2}$ ที่	91
	แตกต่างกัน ที่อัตราการใหลของ CH4 15 sccm กำลังคลื่นความถี่วิทยุ	
	200 วัตต์ อุณหภูมิวัสคุฐาน 300°C	
3.56	ความแข็งแรงของการยึดเกาะของฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรที่ ควบคุม	92
	อัตราการใหลของ CH4 ที่ 15 sccm กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 200 วัตต์	
	อุณหภูมิวัสคุฐาน300°C โคยอัตราการใหลของ N $_2$ ที่แตกต่างกัน	
	(A) 0 sccm (B) 5 sccm (C) 10 sccm (D) 15 sccm (E) 20 sccm	
	(F) 25 sccm 11az (G) 50 sccm	
3.57	กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์กวามเสียดทานของฟิล์ม	94
	คาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการใหลของ N_2 ต่างกัน อัตราการใหลของ	
	CH4 ที่ 15 seem กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 200 วัตต์	
3.58	ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียคทานของฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรที่อัตราการ	95
	ใหลของ N₂ต่างกัน อัตราการใหลของ CH₄ ที่ 15 sccm กำลังคลื่น	
	ความถี่วิทยุ 200 วัตต์	
3.59	ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียคทานของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร ที่อัตรา	95
	การ ใหลของ ${ m N_2}$ และ ${ m CH_4}$ ที่ 15 sccm และกำลังคลื่นความถี่วิทยุ	
	ต่างกัน	
3.60	ความต้านทานความร้อนของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่กำลังอัตราการ	97
	ใหลของ № แตกต่างกัน และควบคุมอัตราการไหลของ CH4 ที่ 15	
	sccm กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 200 วัตต์ อุณหภูมิวัสคุฐาน 300°C	

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของการวิจัย

อลูมิเนียมเป็นวัสดุหลักที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนต่าง เนื่องด้วยกุณสมบัติที่ เด่นชัดคือ น้ำหนักเบา มีความแข็งแรง ไม่เป็นสนิม และสามารถขึ้นรูปชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนได้ เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์และกระทะล้อรถยนต์ และนิยมใช้กระบวนการขึ้นรูปด้วยวิธีหล่อฉีดขึ้นรูป (Aluminium Die Casting) ซึ่งวิธีนี้มีข้อดี คือสามารถลดต้นทุนการผลิตในระยะยาวได้ และการ หล่อโดยวิธีหล่อฉีดนี้จะทำให้ได้รูปร่างของชิ้นงานที่ต้องการนั้นมีขนาดใกล้เคียงกับขนาดที่ ต้องการจริง ทำให้ไม่ต้องทำการตกแต่งชิ้นงานมาก

อัตราการผลิตในการหล่อฉีดนี้จะมีอัตราการผลิตสูง อาจถึงหลายพันชิ้นต่อวัน แม้ว่าตัว แม่พิมพ์จะทำจากโลหะที่มีความแข็งแรงความต้านทานการสึกหรอที่สูง เช่น เหล็กกล้าเครื่องมือ (Tool Steel) เช่นเกรค H13 เมื่อใช้งานเป็นระยะเวลานานแม่พิมพ์เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจาก บริเวณที่สัมผัสกับน้ำโลหะจะเกิดรอยแตกร้าวที่เกิดจากความล้าเนื่องจากการเปลี่ยนอุณหภูมิ (thermal fatigue) และการสึกร่อนเนื่องจากการกัดเซาะ (erosion corrosion) ด้วยน้ำโลหะหลอมเหลว และการที่โลหะหลอมเหลวแข็งตัวและเกาะติดแม่พิมพ์ (soldering) เนื่องจากการแพร่ของอะตอม อลูมิเนียมกับอะตอมของผิวแม่พิมพ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการฉีดน้ำโลหะเข้าสู่แม่พิมพ์ หรือเกิดจากรู พรุนหรือความขรุงระของผิวแม่พิมพ์ทำให้การแกะชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์เป็นไปได้ยากและอาจ ทำให้เกิดกวามเสียหายให้แก่แม่พิมพ์ได้

การขึ้นรูปโลหะด้วยวิธีการหล่อแบบฉีดมีค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างสูง โดยเฉพาะราคาแม่พิมพ์ (อาจสูงถึง 100,000 US\$) ที่ใช้ในการขึ้นรูปนั้นคิดเป็น 20% ของค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งหมด หาก แม่พิมพ์เกิดความเสียหายจะทำให้อัตราการผลิตลดลง และหากต้องซื้อแม่พิมพ์ใหม่ก็เป็นค่าใช้จ่าย ที่สูงมากพอสมควรโดยเราสามารถยืดอายุการใช้งานให้แม่พิมพ์สามารถทำงานได้นานขึ้นก่อนที่จะ หมดอายุการใช้งานจะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก ในการยืดอายุของแม่พิมพ์สามารถทำ ได้โดยการปรับปรุงผิวหน้าของแม่พิมพ์ที่สัมผัสกับน้ำโลหะ เพื่อให้ทนต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ดังกล่าวข้างต้น ในการปรับปรุงคุณสมบัติพื้นผิวสามารถทำได้โดยการเคลือบผิว (coating) การเคลือบผิว ด้วยสารเคลือบบางๆ 2-3 ไมโครเมตร จะทำให้แม่พิมพ์ทนต่อการสึกหรอเหมือนการชุบผิวแข็ง (case hardening) และยังสามารถเลือกสารเคลือบที่ให้คุณสมบัติต่างกันได้อีกด้วย เช่นทนต่อการกัด กร่อน และการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูง และลดการติดแม่พิมพ์ของชิ้นงานหล่อในเวลาเดียวกัน ได้อีกด้วย โดยเทคนิคที่ใช้ในการเคลือบนั้นได้แก่ กระบวนการตกสะสมไอทางกายภาพ (PVD : physical vapor deposition) กระบวนการตกสะสมไอทางเคมี (CVD : chemical vapor deposition) ซึ่งกระบวนการตกสะสมไอทางเคมี นั้นจะให้ฟิล์มที่เคลือบมีความสม่ำเสมอกว่า แต่การยึดเกาะของ สารเคลือบไม่ดีเท่าที่ควรและมักจะทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูงเท่านั้นซึ่งจะส่งผลต่อโครงสร้างของ แม่พิมพ์ จึงได้มีการพัฒนากระบวนการตกสะสมไอทางเคมี ให้สามารถสร้างฟิล์มได้ที่อุณหภูมิต่ำ กว่าวิธีทั่วไป โดยอาศัยพลาสมา (plasma) ซึ่งวิธีนี้สามารถสังเคราะห์ฟิล์มได้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 500°C เรียกว่า กระบวนการตกสะสมไอทางเคมีเสริมด้วยพลาสมา (PE-CVD : plasma enhanced CVD) ซึ่งวิธีนี้จะสามารถเคลือบฟิล์มบางเพื่อช่วยยึดอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ และจะเพิ่มความ แข็งแรงในการยึดเกาะของสารเคลือบกิย์นิ่งบทิ่ด้

1.2 ทฤษฎีและหลักการ

1.2.1 คารับอน (Carbon, C)

คาร์บอน เป็นธาตุเคมีในตารางธาตุที่มีสัญลักษณ์ C และมีเลขอะตอม 6 เป็นธาตุอโลหะที่มี อยู่มาก มีวาเลนซ์ 4 และมีหลายอัลโลโทรป (allotrope) เป็นผลึกที่อนุภาคอะตอมยึดเกาะกันด้วย พันธะโควาเลนต์ตลอดทั้งก้อนผลึก ลักษณะของการจัดเรียงอนุภาคจะเป็นโครงข่าย (Network) เรียง ซ้ำๆกันไปเช่น ผลึกการ์บอนและซิลิกา เป็นต้น (A.A.R. Wood, 1991) ผลึกการ์บอนที่ก้นพบแล้วใน ปัจจุบันมี 6 แบบ คือ

1.2.1.1 IWV5 (Diamond)

อะตอมคาร์บอนหนึ่งๆในผลึกเพชร ใช้ sp³-hybrid orbital ทั้ง 4 ร่วมกับ อะตอมคาร์บอน อื่นๆอีก 4 อะตอมในลักษณะรูปทรง 4 หน้า ดังรูป 1.1 เพชรจึงมีเซลหน่วย (unit cell) เป็นแบบ ลูกบาศก์ มีศูนย์กลางที่ผิวหน้า (Faced center cubic) ซึ่งอะตอมคาร์บอนจึงจับกันด้วยพันธะโควา เลนซ์แบบข่ายงาน 3 มิติ ตลอดทั้งก้อนผลึก ทำให้ผลึกเพชรมีความแข็งมาก จุดหลอมเหลวสูง (มากกว่า 3550°C) วาเลนซ์อิเล็กตรอนทั้งหมดของคาร์บอน ถูกใช้ไปในการเกิดพันธะ จึงไม่มี อิเล็กตรอนอิสระจึงทำให้เพชรไม่นำไฟฟ้า (C.E. Nebel, 2014)



รูปที่ 1.1 โครงสร้างของเพชร

(ที่มา:www.http://phycomp.technion.ac.il/~nika/diamond_structure.html, สืบค้นเมื่อ 24 เมษายน 2557)

1.2.1.2 แกรไฟต์ (Graphite)

แกรไฟต์เกิดจากอะตอมของการ์บอนจับกันเป็นโครงข่าย 2 มิติ รูประนาบหกเหลี่ยมเรียง ซ้ำกันไปเป็นชั้น ดังรูปที่ 1.2 โดยที่การ์บอนแต่ละอะตอมยังเหลืออิเล็กตรอนเวเลนซ์ในชั้น p -Orbital ที่ไม่มีส่วนร่วมในการเกิดพันธะอีกหนึ่งอะตอมเป็นหมอกอิเล็กตรอนที่ไม่ประจำที่อยู่ ระหว่างระนาบ และ ในแนวตั้งฉากกับระนาบอะตอมการ์บอน ทำให้แรงดึงดูคระหว่างระนาบน้อย กว่าแรงดึงดูคภายในระนาบอย่างมากแกรไฟต์จึงเลื่อนไหลในแนวระนาบอะตอมได้ง่ายกว่าการ เลื่อนไหลในแนวตั้งฉาก จึงใช้แกรไฟต์ทำเป็นตัวหล่อลื่น เนื่องจากหมอกอิเล็กตรอนสามารถ เกลื่อนที่ไปได้ในแนวกับระนาบอะตอมการ์บอนแกรไฟต์จึงเป็นตัวนำไฟฟ้าโดยทิศทางการไหล ของกระแสไฟฟ้าจะขนานกับระนาบอะตอมของการ์บอน สมบัติเฉพาะของการ์บอนแกรไฟต์อีก อย่างหนึ่งกือ มีจุดหลอมเหลว 3700°C และเนื่องจากแกรไฟต์มีอัตราการขยายตัวต่ำจึงทนต่อการ เปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันได้ (A.A.R., 1991)



รูปที่ 1.2 โครงสร้างของแกรไฟต์

(ที่มา: http://iopscience.iop.org/0034-4885/75/6/062501/article, สืบค้นเมื่อ 24 เมษายน 2557)

1.2.1.3 ฟุลเลอรีน (Fullerene)

ฟูลเลอรีนเป็นผลึกการ์บอนที่มีเสถียรภาพน้อยที่สุด มีอะตอมการ์บอนเป็นจำนวนกู่ตั้งแต่ 32 อะตอมขึ้นไป รวมกันเป็นผลึกรูปทรงกล้ายลูกฟุตบอล ดังรูป 1.3 เกิดในรูปไอของการ์บอนและ ด้องใช้อุณหภูมิสูงมาก H. W. Kroto และกณะ (1992) มหาวิทยาลัยซัสเซ็ก ประเทศอังกฤษ ได้ทำ การสังเกราะห์ผลึกชนิดนี้ขึ้น โดยการฉายเลเซอร์ผ่านไอการ์บอนได้ผลึกฟูลเลอรีนที่ประกอบด้วย การ์บอน 60 อะตอม (C₆₀) เรียกว่า Buckminsterfullerene เพื่อให้เกียรติแก่ Buckminster Fuller สถาปนิกผู้กิดก้น โกรงสร้างรูปดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการสังเกราะห์ผลึกชนิดนี้เป็น C₇₀ ได้เช่นกัน จากการศึกษาสมบัติการละลายของฟูลเลอรีนพบว่า ฟูลเลอรีนที่มีจำนวนอะตอมการ์บอนน้อย (C₆₀-C₇₀) ละลายได้ดีในเบนซีนและเฮกเซน พวก C₁₀₀-C₂₅₀ ละลายได้ในตัวทำละลายที่มีจุดเดือดสูง และ ฟูลเลอรีนที่เป็น C₆₀ สามารถให้และรับอิเล็กตรอนจากออร์บิทัลเชิงโมเลกุลชนิดไพ (**π**-molecular orbitals) ได้ง่าย การก้นพบฟูลเลอรีนเป็นกวามก้าวหน้าครั้งสำคัญทางเกมี ปัจจุบันได้นำเอาผลึก ชนิดนี้มาใช้ประโยชน์มากมายโดยเฉพาะในเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ใช้ทำเป็นตัวนำยิ่งยวด และแบตเตอร์รี่



รูปที่ 1.3 โครงสร้างของฟูลเลอรีน

(ที่มา : www. http://bfi-internal.org/dsnews/v9_no7.html, สืบค้นเมื่อ 24 เมษายน 2557)

1.2.1.4. ท่อนาโนคารับอน (Carbon Nanotubes)

ท่อนาโนคาร์บอนเป็นอัญรูปใหม่ของคาร์บอน เป็นโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นแผ่นม้วนตัว เป็นท่อขนาคเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยมาก จนทำให้ดูเหมือนเป็นเส้นยาวหนึ่งมิติ และเรียกว่า ท่อนา โนคาร์บอน (M. Inagaki, 2014) ซึ่งเป็นโครงสร้างของคาร์บอนแบบใหม่ที่เพิ่งค้นพบ



รูปที่ 1.4 โครงสร้างของท่อนาโนคาร์บอน

(ที่มา : http://www.extremetech.com/extreme/167421-scientists-build-the-first-carbon-nanotubecomputer-change-computing-world-forever, สืบค้นเมื่อ 24 เมษายน 2557)

1.2.1.5. คารับอนนาโนโฟม (Nanofoam)

เมื่อไม่นานมานี้มีการค้นพบโครงสร้างคาร์บอนรูปใหม่ มีลักษณะเป็นท่อขนาดเล็ก เชื่อมต่อกันเป็นโครงร่างตาข่าย ดังรูป 1.5 ค้นพบโดย John Giapintzakis (J.G.F. Gerald, 2004) นักวิจัยจากมูลนิชิเพื่อการวิจัยและเทคโนโลยี (Foundation for Research and Technology) ที่เมือง เฮลลาส (Hellas) บนเกาะครีต (Crete) คาร์บอนรูปใหม่ที่เรียกว่า "นาโนโฟม (Nanofoam)" นี้มี ลักษณะเหมือนแผ่นบางๆ หากมองผ่านกล้องจุลทรรศน์ทางแสง (Optical microscope) จะดูเหมือน ้ฟองน้ำนาโนโฟมที่มีโครงสร้างไม่เหมือนกับการ์บอนทั้ง 4 แบบที่รู้จักกันมา มีความเป็นแม่เหล็ก ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงแรกที่มันก่อรูปขึ้นมาซึ่งโดยปกติการ์บอนไม่ใช่สารแม่เหล็ก นาโนโฟมมีความ ้เป็นแม่เหล็กเพียงพอที่จะติดกับตู้เย็นได้ หลังจากนั้นความเป็นแม่เหล็กจะลดลงและหายไป นักวิจัย ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (Australian National University) ใค้ผลิตวัสคนาโนโฟมในขณะ พยายามที่จะสร้างท่อนาโน (Nanotubes) โดยการใช้เลเซอร์กำลังสูงทำให้ชิ้นส่วนแกรไฟต์กลายเป็น ้ไอที่อุณหภูมิ 9982.2°C แต่การ์บอนที่ถูกปล่อยออกมานั้นกลับเชื่อมรวมกันเป็นนาโนโฟม และนา ์ โนโฟม 3.78ลิตร มีน้ำหนักประมาณ 7 กรัม มันจึงเป็นหนึ่งในหลายวัสคุที่เบาที่สุดเท่าที่เรารู้จักกัน Giapintzakis กล่าวถึงสมบัติทางแม่เหล็กของนาโนโฟม ที่อาจมีประโยชน์ทางด้านการแพทย์ เมื่อ ้ละลายลงไปในของเหลวและฉีดเข้าส่กระแสเลือด นาโนโฟมสามารถสร้างภาพให้เห็นในเครื่อง ้สร้างภาพที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรค โดยอาศัยคุณสมบัติกวามเป็นแม่เหล็กของไฮโครเจนอะตอม ภายในร่างกายภายใต้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic resonance imaging machine, MRI) ้นอกจากนั้นนาโนโฟมยังสามารถดูคซับพลังงานจากกลื่นวิทยุได้ โดย Giapintzakis คาคว่าหากนำ ้นาโนโฟมฉีดเข้าไปในเนื้องอก คลื่นวิทยจะสามารถให้ความร้อนกับนาโนโฟมเพื่อทำลายเซลล์เนื้อ งอก ในขณะที่เนื้อเยื่อบริเวณรอบๆ จะไม่ถูกทำลายไปด้วย



ร**ูปที่ 1.5** นาโนโฟม

(ที่มา : http://www.gizmag.com/nanofoam-body-armor/26819, สืบค้นเมื่อ 24 เมษายน 2557)

1.2.1.6. คาร์บอนคล้ายเพชร (Diamond-like carbon, DLC)

โดยทั่วไปแล้วเราจะรู้จักการ์บอน (C) ในรูปของแกรไฟด์และเพชรซึ่งภายในโครงสร้างจะ มืองก์ประกอบเฉพาะการ์บอนเท่านั้น ยังมีรูปแบบท่องการ์บอนอีกรูปแบบหนึ่งที่รู้จักกันมานาน นั่นก็คือโครงสร้างของการ์บอนที่อยู่ในรูปแบบที่เป็น การ์บอนอสัณฐานโดยเรียกว่า การ์บอนกล้าย เพชร (Diamond-like carbon, DLC) (รูปที่ 1.6) ซึ่งจะมีโกรงสร้างแตกต่างจากแกรไฟด์ที่จะมี โครงสร้างที่เหมือนกันในระนาบเดียวกันในระบบ 2 มิติ และเพชรที่มีโครงสร้างที่เหมือนกันใน ระบบ 3 มิติ โดยที่การ์บอนกล้ายเพชรมีโครงสร้างที่ผสมผสานกันระหว่าง การ์บอนที่เป็นแกรไฟด์ (sp²) และการ์บอนที่เป็นเพชร (sp³) แต่แกรไฟต์และเพชรมีเฉพาะการ์บอนเป็นองก์ประกอบ ในขณะที่การ์บอนกล้ายเพชรจะมีอะตอมของไฮโครเจนรวมอยู่ด้วย ซึ่งโครงสร้างที่เป็น sp² ของ การ์บอนกล้ายเพชร จะทำหน้าที่กวบคุมสมบัติด้านอิเล็กโทรนิก (Electronic properties) และ โครงสร้าง sp³ จะส่งผลให้การ์บอนกล้ายเพชรมีสมบัติด้านอิเล็กโทรนิก (Electronic properties) และ โครงสร้าง sp³ จะส่งผลให้การ์บอนกล้ายเพชรมีสมบัติด้านเชิงกล (Mechanical properties) โดยพันธะของ โครงสร้าง sp³ จะส่งผลให้การ์บอนกล้ายเพชรมีสมบัติด้านเชิงกล (Chetanical properties) ต่านสียดทานต่ำ (Low friction) โปร่งใส (Optical transparency) และไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมี (Chemical inertness) สมบัติเหล่านี้ก็ยังไม่สามารถเทียบเท่าเพชร โดยฟิล์มเพชร (Diamond films) สามารถเตรียมได้ที่ อุณหภูมิ 700-900 °C แต่ฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรจะสามารถเตรียมได้ที่อุณหภูมิห้อง บนแผ่น รองรับที่เป็นเหล็กหรือพลาสติกได้และพื้นผิวที่ได้ยังมีความเรียบสูง (Superior smoothness) อีกด้วย



ร**ูปที่ 1.6** เปรียบเทียบโครงสร้างของแกรไฟต์ เพชร และ คาร์บอนคล้ายเพชร (ที่มา : http://www.pvdadvancedtech.com/dlc, สืบค้นเมื่อ 24 เมษายน 2557)

ฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชรเป็นวัสดุที่ประกอบด้วยการ์บอนและไฮโดรเจน ในสภาวะกึ่ง สถานะ (metastable) ของโครงสร้างอสัณฐานของการ์บอน (amorphous carbon, a-C) ซึ่ง ประกอบด้วยโครงสร้างพันธะ sp² และ sp³ ของอะตอมการ์บอน (Robertson, 2002) หากแบ่งตาม ปริมาณธาตุและโครงสร้าง แบ่งได้ดังนี้

i) a-C:H (amorphous hydrogenated carbon films)

- 30-40% Hydrogen เรียก a-C:H hard (sp³ 40%)

- 40-50% Hydrogen เรียก a-C:H soft (sp³ 60%)

ii) คาร์บอนอสันฐาน ที่มีปริมาณ sp³ สูงกว่า 70%

- 0 % Hydrogen เรียก ta-C (tetrahedral amorphous carbon)

- 30 % Hydrogen เรียก ta-C:H (tetrahedral amorphous hydrogenate carbon) iii) 100 % sp³ เรียก diamond

ฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรมีโครงสร้างผสมระหว่างพันธะ sp² (graphitically bond) และ sp³ (diamond-bond) ของอะตอมการ์บอนและลักษณะความกล้ายเพชรขึ้นกับการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วน ของปริมาณ sp³ ต่อ sp² โดยถ้ามีปริมาณ sp³ มาก ก็จะมีกวามกล้ายเพชรมากขึ้น และในแต่ละเฟสจะ มีสมบัติแตกต่างกันดังแสดงในตารางที่ 1.1 ซึ่งเปรียบเทียบสมบัติของของการ์บอนอสัณฐานต่าง ๆ เมื่อเทียบกับกับเพชร (diamond), แกรไฟด์ (graphite), ฟูลเลอลีน (C₆₀) และ พอลิเอทิลีน โดยหาก การ์บอนอสัณฐานที่สังเคราะห์ได้ มีโครงสร้างเป็น sp³ ทั้งหมดจะได้เพชร (diamond) ซึ่งมีกวาม หนาแน่นและความแข็งสูงที่สุดในบรรดาโกรงสร้างของการ์บอนอสัณฐานทั้งหมด แต่ถ้าหาก โกรงสร้างที่ได้ไม่มีโกรงสร้างที่เป็น sp³ เลยก็จะได้ graphite, C₆₀, glassy C, evaporated C, และ sputter C ในส่วนของก่าช่องว่างพลังงาน (energy gap) หากมีก่ามากแสดงว่าโครงสร้างนั้นมีกวาม เป็นฉนวนมาก ซึ่งจากตารางที่ 1.1 จะเห็นว่าแกรไฟต์เป็นโกรงสร้างแบบเดียวที่นำไฟฟ้า แต่ถ้าหาก อัตราส่วนของ sp³ อยู่ที่ 80-88 % จะได้โครงสร้างที่เรียกว่า ta-C (tetrahedral amorphous carbon) หากมีโครงสร้างของไฮโดรเจนผสมลงไป โดยอัตราส่วนของไฮโดรเจนมีค่อ sp³ ส่งผลต่อกวาม แข็งและความหนาแน่นของฟิล์มที่สังเคราะห์ได้ โดยหากมีปริมาณของไฮโดรเจนมกจะทำให้ฟิล์ม ที่ได้มีกวามแข็งและกวามหนาแน่นลดลง และจากรูปที่ 1.7 ซึ่งแสดงเฟสไดอะแกรมของการ์บอน หากสังเคราะห์ฟิล์มจากธาตุการ์บอนอย่างเดียว เช่น กาโทดิกอาร์ก (cathodic arc) คือ การสร้าง พลาสมาจากแท่งการ์บอน โดยการอาร์กทำให้การ์บอนจากสถานะของแข็งไปอยู่ในสถานะพลาสมา แล้วสร้างฟิล์มบนวัสดุที่ต้องการฟิล์มที่ได้คือฟิล์มที่อยู่บริเวณทางด้านซ้ายของเฟสไดอะแกรม คือ จะมีเพียงโครงสร้างของ sp² และ sp³ เท่านั้นโดยอัตราส่วนของ sp²และ sp³ ที่แตกต่างกันก็จะทำให้ ได้สมบัติของฟิล์มที่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 1.1 แต่หากฟิล์มที่สังเกราะห์ได้เกิดจากพลาสมาของ แก๊สไฮโดรการ์บอน จะทำให้มี องก์ประกอบของไฮโดรเจนผสมเข้ามาทำให้ได้ฟิล์มที่เป็น ta-C:H และ a-C:H ซึ่งจะอยู่บริเวณตรงกลางของเฟสไดอะแกรม ถ้าหากมีอัตราส่วนของไฮโดรเจน ประมาณ 60-70 % ก็จะเกิดเป็นไฮโดรการ์บอนพอลิเมอร์ เช่น พอลิเอทิลีน แต่ถ้าหากมีอัตราส่วน ของไฮโดรเจนมากกว่า 70 %ไปก็จะไม่เกิดฟิล์ม



รูปที่ 1.7 เฟส ใดอะแกรมของการ์บอน (Robertson, 2002)

ตารางที่ 1.1 เปรียบเทียบสมบัติของโครงสร้างอสัณฐาน (amorphous carbons) กับ diamond, graphite, C₆₀ และ พอลิเอทิลีน (Robertson, 2002)

	sp ³ (%)	H (%)	Density	Band Gap	Hardness
			(g cm ⁻³)	(eV)	(GPa)
Diamond	100	0	3.515	55	100
Graphite	0	0	2.267	0	-
C ₆₀	0	0	-	1.6	-
Glassy C	0	0	1.3-1.55	0.01	3
Evaporated C	0	0	1.9	0.4-0.7	3

	sp ³ (%)	H (%)	Density	Band Gap	Hardness
			(g cm ⁻³)	(eV)	(GPa)
Sputter C	5	0	2.2	0.5	-
ta-C	80-88	0	3.1	2.5	80
a-C:H hard	40	30-40	1.6-2.2	1.1-1.7	10-20
a-C:H soft	60	40-50	1.2-1.6	1.7-4	<10
ta-C:H	70	30	2.4	2.0-2.5	50
Polyethylene	100	67	0.92	6	0.01

ตารางที่ 1.1 (ต่อ) เปรียบเทียบสมบัติของโครงสร้างอสัณฐาน (amorphous carbons) กับ diamond, graphite, C₆₀ และ พอลิเอทิลีน (Robertson, 2002)

1.2.2 พลาสมา

1.2.2.1 ความหมายของพลาสมา (ธีรวรรณ, 2546)

พลาสมา (Plasma) คือ สภาวะที่แก๊สเกิดการแตกตัว (ionized) ประกอบด้วย อิเล็กตรอน ใอออน และอนุภาคของแก๊ส ในสัดส่วนที่ทำให้ประจุสุทธิเป็นสูนย์ ทำให้ โดยรวมแล้วพลาสมา ยังคงสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า คำนี้ถูกบัญญัติโดย แลงมัวร์ (Irving Langmuir) ในปี ค.ศ. 1928 ใช้ เพื่อบรรยายสภาพแก๊สที่ถูกทำให้เป็นไอออนในการดิสชาร์จด้วยไฟฟ้า (F.F. 1984) ดังนั้นจึงถือได้ ว่าพลาสมาเป็นสถานะที่ 4 ของสสาร เนื่องจากมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากสถานะอื่นอย่าง ชัดเจน หากพิจารณาช่วงเปลี่ยนสถานะ ของแข็ง - ของเหลว - แก๊ส (solid-liquid-gas) ถ้าเพิ่ม อุณหภูมิ (คือการให้พลังงานจลน์แก่อนุภาคของแก๊ส) ให้กับแก๊สต่อไปเรื่อยๆ เช่นถึง 20,000 K จะ ได้พลาสมาของแก๊สนั้น (อุณหภูมิอาจค่ำกว่าก็ได้ แล้วแต่กลไกการทำให้เป็นไอออนของแก๊ส) พลาสมามีลักษณะพิเศษที่น่าสนใจ เนื่องจากแรงไฟฟ้า ถือเป็นแรงชนิดไกล (long range force) และ อนุภาคของพลาสมาทุกตัวกระทำต่ออนุภาคซึ่งกันและกัน เรียกว่าเป็นพฤติกรรมรวม (collective behavior) พฤติกรรมรวมนี้หมายถึง การเคลื่อนที่ของอนุภาคในพลาสมา ไม่เพียงแต่จะขึ้นอยู่กับ เรื่อนไขในบริเวณนั้นๆ เท่านั้น แต่เป็นผลโดยรวมจากพลาสมาส่วนใหญ่ มากกว่าจะเป็นผลมาจาก การชนกันของอนุภาคที่อยู่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากอนุภาคในพลาสมาที่สถานะสมดุล จะมีการสั่น ด้วยความถิ่ที่สูงกว่าความถิ่นกรชนกันของอนุภาค 2 ตัวที่อยู่ใกล้กัน ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า พฤติกรรมรวมนี้เป็นพฤติกรรมที่กลุ่มพลาสมาแสดงออกมาร่วมกัน พลาสมาสามารถเกิดได้โดยการ ให้สนามไฟฟ้าปริมาณมากแก่แก๊สที่เป็นกลาง เมื่อพลังงานส่งผ่านไปยังอิเล็กตรอนอิสระมาก พอที่จะทำให้อิเล็กตรอนอิสระชนกับอะตอม และทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอม กระบวนการนี้เรียกว่ากระบวนการแตกตัวเป็นไอออน (ionization) ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ จำนวนอิเล็กตรอนที่หลุดออกมานี้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากซึ่งจะทำให้แก๊สแตกตัวและกลายเป็น พลาสมาในที่สุด

1.2.2.2 กระบวนการเกิดพลาสมา (ธีรวรรณ, 2546)

(1) การแตกตัวเป็นไออน (Ionization)

ในการเกิดปฏิกิริยาของพลาสมาในห้องสุญญากาศ ซึ่งมีแก๊สไหลผ่านในระดับคงที่และ ความดันต่ำมากๆ โมเลกุลหรืออะตอมของแก๊สในสุญญากาศ อาศัยการชนของอิเล็กตรอนกับ โมเลกุลหรืออะตอมเป็นสำคัญ โดยคลื่นวิทยุหรือคลื่นไมโครเวฟทำหน้าที่เร่งอิเล็กตรอนให้มี พลังงานจลน์ไปชนกับโมเลกุลหรืออะตอมดังสมการที่ 1.1 ซึ่งในกรณีนี้แสดงว่าพลังงานจลน์ของ อิเล็กตรอนนั้นมีก่ามากกว่า ionization energy

$$e^{i} + C_{2}H_{2} \longrightarrow C_{2}H_{2}^{+} + 2e^{i}$$
 (1.1)

(2) การเกิดพลังงานกระตุ้น (Excitation)

พลังงานที่ส่งผ่านเมื่ออิเล็กตรอนกระ โคคไปอยู่ในระคับพลังงานที่สูงกว่า ทำให้อะตอมนั้น ไปอยู่ในสถานะถูกกระตุ้น ซึ่งแสดงว่าพลังงานจลน์ของอิเล็กตรอนมีค่าน้อยกว่า ionization energy ดังแสดงในสมการที่ 1.2 โคย C₂H₂* คืออะตอมของอะเซทิลีนที่อยู่ในสถานะถูกกระตุ้น

$$e^{-} + C_2 H_2 \longrightarrow C_2 H_2^* + e^{-}$$
 (1.2)

(3) กระบวนการแตกตัว (Dissociation)

กระบวนการสุดท้ายที่สามารถเกิดขึ้นได้ โดยโมเลกุลเกิดการแตกตัว (dissociation) ซึ่ง โมเลกุลของอะเซทิลีนสามารถเกิดการแตกตัวดังแสดงในสมการ 1.3 – 1.7

$$e^{T} + C_{2}H_{2} \longrightarrow C_{2}H + H + e^{T}$$
 (1.3)

$$e^{-} + C_2 H_2 \longrightarrow C_2 + 2H + e^{-}$$
 (1.4)

$$e^{-} + C_2 H_2 \longrightarrow C_2 + H_2 + e^{-}$$
 (1.5)

$$e + C_2 H_2 \longrightarrow 2CH + e^{-1}$$
 (1.6)

$$e^{i} + C_{2}H_{2} \longrightarrow C + CH_{2} + e^{i}$$
 (1.7)

ผลของการแตกตัวจะเพิ่มประสิทธิภาพของการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี คือ ผลผลิตที่ได้จะมี ความไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเร็วกว่าตอนที่อะตอมยังไม่แตกตัว เกิดการแตกตัว (dissociation) อาจ เกิดควบคู่กับ ionization หรือไม่ก็ได้ ถ้าเกิดคู่กันจะเรียกว่า dissociative ionization ซึ่งโมเลกุลของ อะเซทิลีนสามารถเกิดการ dissociative ionization ได้ดังสมการ 1.8 – 1.13

$$e^{+} + C_2H_2 \longrightarrow C^{+} + CH_2 + 2e^{-}$$
 (1.8)

$$e^{\dagger} + C_2 H_2 \longrightarrow C^{\dagger} + C + H_2 + 2e^{\dagger}$$
 (1.9)

$$e^{\dagger} + C_2 H_2 \longrightarrow C^{\dagger} + H + CH + 2e^{\dagger}$$
 (1.10)

$$e^{-} + C_2 H_2 \longrightarrow C_2^{+} + H_2 + 2e^{-}$$
 (1.11)

$$e^{+} + C_2 H_2 \longrightarrow C_2^{+} + 2H + 2e^{-}$$
 (1.12)

$$e^{+} + C_2 H_2 \longrightarrow C H_2^{+} + C + 2 e^{-}$$
 (1.13)

เมื่อแก๊ส ได้รับพลังงานจากคลื่นวิทยุ (Radio frequency, RF) หรือคลื่น ไมโครเวฟที่ความ ดันต่ำ เราจะมองเห็นพลาสมาที่เปล่งแสงออกมา เนื่องมาจากพลังงานภายนอกทำให้เวเลนซ์ อิเล็กตรอนเปลี่ยนจากสถานะพื้น ไปอยู่ในสถานะถูกกระตุ้น โดยธรรมชาติอิเล็กตรอนจะอยู่ใน สถานะกระตุ้น ได้เพียงประมาณ 10⁻¹⁸s หลังจากนั้นเวเลนซ์อิเล็กตรอนจะกลับคืนสู่สถานะพื้นพร้อม ทั้งปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปคลื่นแม่เหล็ก ไฟฟ้า ซึ่งอยู่ในช่วงความยาวคลื่นที่ตาสามารถเห็น ได้ (visible light) การเปล่งแสงของพลาสมาสามารถบ่งถึงลักษณะของแก๊สที่แตกตัว ได้ เช่น แก๊ส อาร์กอนจะเปล่งแสงสีม่วง อากาศและแก๊ส ในโตรเจนจะเปล่งแสงเป็นสีชมพูซึ่งบ่งบอกถึงสภาวะ กระตุ้นโมเลกุลของในโตรเจน

1.2.3 กระบวนการตกสะสมไอเคมี (Chemical Vapor Deposition, CVD)

การเคลือบไอทางเคมี (Chemical Vapor Deposition, CVD) คือ การเคลือบธาตุหรือ สารประกอบของแข็งที่ร้อนด้วยปฏิกิริยาเคมีจำนวนมาก จากสถานะแก๊ส (ไอ) ลงบนวัสดุฐาน (substrate) การเคลือบแบบตกสะสมไอเคมี มีการใช้งานกว้างขวางในอุตสาหกรรม เนื่องจาก สามารถทำการเคลือบธาตุหรือสารประกอบได้หลายชนิด สามารถเคลือบได้รวดเร็ว ชั้นเคลือบมี กวามหนาสม่ำเสมอ มีรูพรุนน้อย และสามารถเกลือบวัสดุที่ไม่สามารถเกลือบได้ด้วยวิธีอื่นๆ (เช่น การเกลือบด้วยไฟฟ้า) ตัวอย่างการใช้งาน เช่น การเกลือบไทเทเนียมการ์ไบด์ (TiC) ที่มีคุณสมบัติ ด้านทานการสึกหรอที่สูงมาก โดยเฉพาะที่อุณหภูมิสูง ลงบนเหลีกกล้าเครื่องมือความเร็วสูง (high speed tool steel) โดยมีความหนาของชั้นเกลือบประมาณ 5-8 ไมโครเมตร ซึ่งจะทำให้สามารถ ยึดอายุการใช้งานได้อีก 3-8 เท่า หรือการเกลือบไทเทเนียม (Ti) หรือเซอร์โกเนียม (Zr) ลงบน ชิ้นส่วนสำหรับใช้งานที่อุณหภูมิสูง หรือการเกลือบเวเฟอร์ซิลิกอน (silicon wafer) ด้วยวิธีการ เกลือบไอทางเกมีความดันต่ำ (Low Pressure Chemical Vapor Deposition, LPCVD) เป็นต้น สำหรับปฏิกิริยาเกมีของกระบวนการเกลือบไอทางเกมี สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท (ที่มา : http://www.isit.or.th) ดังสมการที่ 1.14-1.17

1.ปฏิกิริยาแตกตัวทางความร้อน เช่น SiH₄ (g) → Si (s) + 2H₂ (g)
$$(1.14)$$

2.ปฏิกิริยารีดักชัน เช่น $2BCl_3(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2B(s) + 6HCl(g)$ (1.15)

3.ปฏิกิริยาแทนที่ เช่น CrCl₃ (g) + 2Fe (s) → Cr-Fe alloy (s) + FeCl₂ (g) (1.16)

4.ปฏิกิริยา proportional เช่น 2TiCl₂ (g) → Ti (s) + TiCl₄ (g) (1.17)

1.2.3.1 ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาตกสะสมไอทางเคมี

ปฏิกิริยาพื้นฐานของปฏิกิริยาการตกสะสมไอเคมี ประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ๆ สรุปได้ดังนี้ และรูปแสดงขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาดังแสดงในรูปที่ 1.8 1.) แพร่แก๊สเข้าไปในบริเวณที่จะทำการปลูกฟิล์ม

 2.) สารตั้งต้นในสถานะแก๊สจะทำปฏิกิริยากัน ทำให้ได้สารตั้งต้นที่ทำปฏิกิริยากัน (Precursor) และ สารตั้งต้นที่ไม่ได้ทำปฏิกิริยากัน (By-Preduct)

Reactant (g) + Reactant (g) \longrightarrow Precursor (g) + By-Product (g)

3.) Precursor ที่ทำปฏิกิริยากันจะไปตกลงบนวัสคุฐาน (substrate)

4.) เกิดการเปลี่ยนสถานะของสารตั้งต้น (Precursor Adsorption) หมายถึง ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น
 ระหว่างกระบวนการปลูกฟิล์ม ซึ่งทำให้อะตอมที่เป็นแก๊สและ โมเลกุลที่จะไปยึดติดทางเคมีกับ
 ผิวหน้าของวัสดุฐาน (substrate)

Precursor (g) \rightarrow Precursor (s)

- 5.) Precursor ที่อยู่ที่ผิวหน้าจะแพร่ไปยังบริเวณที่ต้องการปลูกฟิล์ม
- 6.) เกิดปฏิกิริยาเคมีที่ผิวหน้า ซึ่งจะได้ฟิล์มที่ต้องการ

Precursor (s) \rightarrow Film (s) + By-Product (g)

7.) เกิดการคายสารตั้งต้นที่เหลือจากการทำปฏิกิริยากัน (Desorption) คือ การปล่อย By-Product ออก จากปฏิกิริยาที่ผิวหน้าวัสดุฐาน (substrate)

8.) ดูค By-Product ออกจากบริเวณที่ต้องการปลูกฟิล์ม



(ที่มา : http://cnx.org/content/m25614/latest/, สืบค้นเมื่อ 25 เมษายน 2557)

1.2.3.2 ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาตกสะสมไอทางเคมีเสริมพลาสมา (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition, PECVD)

การปลูกฟิล์มด้วยปฏิกิริยาการตกสะสมไอเคมีเสริมพลาสมา (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition, PECVD) จะใช้พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการกระตุ้นการแตกโมเลกุลเป็น พลาสมาในสภาวะสุญญากาศ โดยความถึ่งองคลื่นวิทยุที่ใช้ขึ้นอยู่กับงานที่นำไปประยุกต์ โดย ความถี่ทั่วไปที่พบเห็นกันได้แก่ 40 kHz 400 kHz 13.56 MHz และ 2.45 GHz โดยอะตอมที่แตกออก จะไปเกิดพันธะกับอะตอมอื่นๆ เพื่อสร้างสารตั้งต้นที่ทำปฏิกิริยากัน (Precursor) ซึ่งจะไป ก่อตัว และทำปฏิกิริยากับผิวหน้าของวัสคุฐาน ส่วนสารตั้งต้นที่เหลือจากการทำปฏิกิริยา (by-product) ที่ เหลือจะถูกดูดออกผ่านระบบ ปั๊มสุญญากาศ และขณะทำการเคลือบ แผ่นวัสคุฐาน จะถูกทำให้ร้อน เพื่อที่จะเพิ่มปฏิกิริยาผิวหน้าและ ลดสิ่งเจือปนที่ไม่ต้องการ เช่น ไฮโครเจน

กระบวนการตกสะสมไอเคมีเสริมพลาสมาเป็นกระบวนการที่ใช้พลังงานพลาสมาในการ สร้างหรือสนับสนุนปฏิกิริยาตกสะสมไอเคมีทำให้กระบวนการนี้มีข้อแตกต่างสำคัญคือการใช้ อุณหภูมิที่ต่ำกว่าแบบอื่นๆ ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เคลือบฟิล์มซิลิกอนไนไตรค์ (Silicon Nitride) ที่ 350°C บนชั้นโลหะอลูมิเนียม (Aluminum Metallization) ได้เนื่องจากจุดหลอมเหลวของ อลูมิเนียมอยู่ที่ 660°C

กระบวนการตกสะสมไอเคมีเสริมพลาสมาจะถูกกระทำในเตาของปฏิกิริยาสุญญากาศซึ่งมี แผ่นตัวนำ 2 แผ่นขนานกัน ซึ่งอยู่ห่างกันไม่มากนัก และสามารถปรับระยะห่างได้สำหรับทำการ ปรับปรุงกระบวนการ แผ่นวัสดุฐานจะถูกวางอยู่บนแผ่นด้านล่างซึ่งต่อสายดินเพื่อป้องกันการเกิด การการรั่วของกระแสไฟฟ้า และจะปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุที่แผ่นอิเล็คโทรดด้านบน ขณะเดียวกัน แก๊สก็จะถูกส่งเข้ามาบริเวณกึ่งกลางของอิเล็กโทรดด้านบน แก๊สส่วนหนึ่งจะเกิดเป็นพลาสมา ดังที่ ได้กล่าวในหัวข้อ 1.2.3.2 แล้วเกิดปฏิกิริยาตามหัวข้อ 1.2.4.1 และแก๊สที่เหลือจากปฏิกิริยาจะถูกดูด ออกทางอิเล็กโทรดด้านล่าง ดังแสดงในรูปที่ 1.8



รูปที่ 1.9 แสดงภายในเตาปฏิกิริยาการตกสะสมไอเคมีเสริมพลาสมา (ที่มา : http://encyclopedia.che.engin.umich.edu/Pages/CVDReactors.html, สืบค้นเมื่อ 25 เมษายน 2557)
เมื่อพลาสมาถูกสร้างขึ้นในสภาพแวคล้อมของปฏิกิริยาการตกสะสมไอเคมีสารตั้งต้นที่อยู่ ในสถานะแก๊สจำนวนเล็กน้อยจะถูกอิเล็กตรอนพุ่งชนทำให้เกิคสถานะการแตกตัว (Dissociation) และ สถานะกระตุ้น (Excitation) ทำให้ได้สารตั้งต้นที่อยู่ในสถานะกระตุ้น

Excitation	:	$A + e - \longrightarrow A^* + e -$	(1.18)
Dissociation	:	$A2 + e \rightarrow 2A + e \rightarrow$	(1.19)

เป็นผลให้สารตั้งต้นที่พร้อมจะทำปฏิกิริยาแพร่ไปยังผิวของวัสคุฐานเกิดปฏิกิริยาการดูด ซับ (Adsorption) เช่นเดียวกับปฏิกิริยาการตกสะสมไอเกมี (CVD) แต่สารตั้งต้นของปฏิกิริยาการตก สะสมไอเกมีเสริมพลาสมา (PECVD) จะเป็นอีกเส้นทางที่ขนานกับปฏิกิริยาการตกสะสมไอเกมี (CVD) ซึ่งเป็นเส้นทางที่พลังงานต้องใช้กระตุ้นให้เกิดการแตกตัวต่ำกว่า ทำให้เส้นทางของ ปฏิกิริยาการตกสะสมไอเกมีเสริมพลาสมา (PECVD) มีอัตราการปลูกฟิล์มที่สูงกว่า

ยิ่งไปกว่านั้น ไอออนที่เกิดในพลาสมาเกิดการระคมยิ่งลงบนผิววัสดุฐาน ทำให้เกิดการข้าย ที่ของ A* อะตอม และลดสิ่งเจือปนที่ไม่ต้องการออกไปจากผิว แต่ถ้าพลังงานไอออนมีมากเกินไปก็ จะ มีผลต่อกุณภาพของฟิล์มที่ได้ อย่างไรก็ตามปฏิกิริยาก็ยังคงต้องการพลังงานความร้อนมากกว่า ΔE* เพื่อกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาพื้นผิว

1.2.4 เหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อนเกรด AISI H13

เหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อนเป็นเหล็กกล้าเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน ที่อุณหภูมิสูง เช่น แม่พิมพ์ขึ้นรูปร้อน หล่อแบบฉีด อัดขึ้นรูปร้อน งานตัดร้อน เป็นต้น สิ่งสำคัญคือ เหล็กกล้าเครื่องมือจะต้องสามารถรักษาสมบัติความแข็งที่อุณหภูมิสูงได้ ด้าน ทานต่อการ เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ การอ่อนตัวที่อุณหภูมิสูงและมีความเหนียวที่ดี เนื่องจากธาตุผสมที่ส่งเสริม ให้เหล็กกล้าเครื่องมือมีสมบัติดังกล่าวได้แก่ โครเมียม (Cr) โมลิบดีนัม (Mo) และวาเนเดียม (V) ซึ่ง ในการวิจัยนี้ได้ใช้เหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อนเกรด AISI H13 อันเนื่องมาจาก เหล็กกล้ากลุ่มนี้สามารถนำมาใช้งานอย่างกว้างขวางในภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ทำแม่พิมพ์ขึ้นรูปร้อน ทุกชนิด ทั้งงานขึ้นรูปโลหะ พลาสติก และแก้ว ซึ่งมืองค์ประกอบของธาตุดังแสดงในตารางที่ 1.2 คุณสมบัติทางกายภาพดังแสดงในตารางที่ 1.3 และสมบัติทางกลดังแสดงในตาราง 1.4

ตารางที่ 1.2 องค์ประกอบของธาตุของเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อนเกรด AISI H13

(J.K. Davis, 1990)	(J.R.	Davis,	1996)
--------------------	-------	--------	-------

Element (%)									
С	Si	Fe	Cr	Мо	Ni	V			
0.32 - 0.40	1.0	≥ 90.95	5.13 - 5.25	1.33 - 1.4	0.30	1.0			

ตารางที่ 1.3 คุณสมบัติทางกายภาพของเหล็กกล้าเครื่องมือ AISI H13 (Thai-German special steel center, 2010)

คุณสมบัติ	อุณหภูมิทดสอบ									
การทนความร้อน (W/m•K)	20°C		350°C		700°C					
สภาพอบอ่อน	27.2 30.5		27.2		30.5		30.5			33.4
สภาพชุบแข็งและอบลื่นตัว	25.5		27.6			30.3				
สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความ	อุณหภูมิทดสอบ									
ร้อนระหว่าง 20°C ถึง (10⁻́	100°C	2	200°C	300°C	2	400°C				
m/m•K)	10.9		11.9	12.3		12.7				

ตารางที่ 1.3 (ต่อ) คุณสมบัติทางกายภาพของเหล็กกล้าเครื่องมือ AISI H13 (Thai-German special steel center, 2010)

สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความ	500°C	600	°С	700°C	ļ			
ร้อนระหว่าง 20°C ถึง (10⁺ m/m•K)	13.0	13.	.3	13.5		-		
สัมประสิทธิ์การยื ดตัว (10 ³ N/mm ² = GPa)	อุณหภูมิทดสอบ							
	200°C		400°C			800°C		
	224.9		21	13		124		
ความจุความร้อนที่ 100°C (J/•°C)	0.44							
ความหนาแน่น (g/cm³)	7.85							
สภาพทางแม่เหล็ก			ซึม	ซับ				

I 5													
ค่าความแข้งเ	เรง		อุณหภูมทดสอบ										
(Hot tensile str	ength)	20°C 200°C)°C		300°C	400°C		500°C		(500°C	
0.2% Y.S.	Min	1240 1150			1070	940		75	50		400		
(N/mm ² =MPa)	max	1370		13	20		1240	1130		91	10		590
U.T.S.	min	1420		13	70		1290	1180		99	90		640
(N/mm ²)	max	1560		15	30		1425	1320		11	30		800
	min	29		2	9		29	32		3	5		48
% R.A.	max	45		4	5		45	53		5	9		77
ค่าสัมประสิทธิ์ _เ	อุณหภูมิทดสอบ												
ตัว E in N/mm ² (20°C	10	00°C	200°	C	300°C	400°C	5	00°C	600°	С	700°C	
ชุบแข็งและอบคื	นตัวให้												
ความแข็งที่ 43	HRC	216		212	206	5	200	193		185	174		161
และทดสอบที่อุเ	นหภูมิ												
อบอ่อนและทด	สอบที่						0.1	1.7					
20°C							21	1 /					
ชุบแข็งและทดส	สอบที่						~	20					
20°C							20	98					

ตารางที่ 1.4 คุณสมบัติทางกลของเหล็กกล้าเครื่องมือ AISI H13 (Thai-German special steel center, 2010)

1.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในอุตสาหกรรมการหล่ออลูมิเนียมนั้นกระบวนการหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียมแบบจืด (Die casting) นั้นเป็นที่นิยมอย่างสูงเนื่องจากวิธีการนี้มีอัตราการผลิตที่สูง และยังช่วยลดต้นทุนใน กระบวนการผลิตได้เป็นอย่างมากในเรื่องแม่พิมพ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงาน เนื่องจากแม่พิมพ์ สำหรับงานหล่ออลูมิเนียมแบบจีดนั้นทำจากเหล็ก H13 ซึ่งเป็นเหล็กที่นิยมใช้สำหรับงานร้อน (Hot work tool steel) จึงทำให้สามารถนำแม่พิมพ์กลับมาใช้ใหม่ได้ แต่เมื่อใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง แม่พิมพ์ก็เกิดความเสียหายขึ้นได้ (รูปที่ 1.10)โดยส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับแม่พิมพ์นั้น มักจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับความร้อน เช่น ความล้าเนื่องจากความร้อน (Thermal fatigue) การกัด กร่อนเนื่องจากอุณหภูมิของน้ำโลหะที่สัมผัสกับผิวแม่พิมพ์ (Erosion) การเกาะติดแม่พิมพ์ของน้ำ โลหะเมื่อเกิดการแข็งตัว (Soldering) การแตกเนื่องจากเกิดความเค้นเนื่องจากแรงกระแทกของ แม่พิมพ์ขณะฉีดขึ้นรูป (Stress crack) C. Mitterer, (2000)



รูปที่ 1.10 ความเสียหายที่เกิดขึ้นในแม่พิมพ์เนื่องจากความร้อน C. Mitterer (2000)

การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์เมื่อเกิดความเสียหายเนื่องจากเหตุผลดังกล่าวข้างค้น สามารถทำได้หลายวิธีเช่นการขัดผิวหน้าแม่พิมพ์ที่มีน้ำโลหะเกาะ การเชื่อมรอยแตกที่เกิดขึ้นใน ขึ้นงาน แต่วิธีบำรุงรักษาเบื้องด้นเหล่านี้สามารถทำได้ตราบเท่าที่ไม่ทำให้รูปทรงเดิมของชิ้นงาน เกิดความคลาดเกลื่อนไปจากเดิมมากนัก ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์จึงใช้เทคนิดด้านการเกลือบผิวเข้า มาช่วยยืดอายุการใช้งานแม่พิมพ์ โดยสามารถสังเกราะห์สารเกลือบได้หลายชนิดตามความ เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น สารเกลือบ TiN TiC ช่วยเพิ่มความแข็งให้แก่แม่พิมพ์ Ti(C,N) ช่วยเพิ่ม กวามแข็งและลดค่าสัมประสิทธ์ความเสียดทาน Ti(B,N) (Ti,Al)(C,N) ช่วยลดการเกิดออกชิเดชัน C. Jarms และคณะ (1998) C. Heau และคณะ (1999) H. Jehn และคณะ (1986) J. Laimer และคณะ (1993) ซึ่งเทคนิกที่ใช้ในการเกลือบฟิล์มที่ใช้ในการวิจัยนี้ก็อ กระบวนการตกสะสมไอเกมี หรือ ชีวี ดี (CVD : Chemical Vapor Deposition) เป็นกระบวนการเกลือบผิวโดยอาศัยกระบวนการทางเกมี โดยทำให้สสารสถานะไอทำปฏิกิริยากัน แล้วกลายเป็นสารประกอบสถานะของแข็งเกลือบอยู่บน ชิ้นงาน ซึ่งปกติปฏิกิริยาดังกล่าวเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนจึงจำเป็นต้องให้ความร้อนแก่วัสดุฐาน เพื่อให้สารเคลือบที่อยู่บนวัสดุฐานทำปฏิกิริยากัน โดยอุณหภูมิที่ให้แก่วัสดุฐานนั้นอาจสูงถึง 900 -1,000 °C K. Spear (1989)

L. Marcinauskas และ A. Grigonis (2007) ศึกษาการสังเคราะห์ฟิล์มคาร์บอนลงบนวัสดุ ฐานที่เป็นแผ่นซิลิกอน (111) ด้วยวิธีพลาสมาเจ็ทซีวีดี (Plasma Jet CVD) รูปที่1.11 โดยใช้แก๊ส อะเซทิลีน (C₂H₂) เป็นสารตั้งต้นในการทำให้เกิดเปลวไฟภายใต้ความดันบรรยากาศ ซึ่งอุณหภูมิที่ ใช้ในการสังเคราะห์ฟิล์มคาร์บอนนั้นขึ้นอยู่กับอัตราส่วนระหว่าง Ar/C₂H₂ ซึ่งที่อัตราส่วน Ar/C₂H₂ เท่ากับ 12 60 และ 100 อุณหภูมิวัสคุฐานเป็น 480 930 และ 980°C ตามลำคับ จากผลการทคลอง พบว่า เมื่ออัตราส่วน Ar/C₂H สูงขึ้น อัตราการตกสะสมของฟิล์มการ์บอนลคลง และจากผลการ วิเคราะห์เทกนิกอินฟราเรคสเปกโตรสโกปี (FTIR) พบว่าเมื่อลดอัตราการไหลของแก๊สอะเซทิลีน จะทำให้สัคส่วนของ sp² และ sp³มีก่าเพิ่มขึ้น

S. Rahman และคณะ (2012) ศึกษาความดันที่มีผลต่อโครงสร้างของฟิล์มเพชร โดย สังเคราะห์ฟิล์มเพชรลงบนวัสดุฐานที่เป็นแผ่นซิลิกอน (100) ด้วยวิธีซีวิดีโดยอาศัยขด ลวดความร้อน (Hot filament CVD : HFCVD) รูปที่1.11ซึ่งขดลวดที่ใช้ในการทดลองเป็นขดลวด แทนทาลัม (Tantalum) และใช้แก๊สผสมระหว่างมีเทน และไฮโดรเจน ที่อัตราส่วน 2 ต่อ 200 ตามลำคับ ความดันที่ใช้ในการทดลองอยู่ที่ 2 และ 5 ทอร์ (266.6 และ 666.6 Pa) อุณหภูมิที่ใช้ใน การทดลอง สำหรับวัสดุฐานอยู่ที่ 800°C และอุณหภูมิขดลวดความร้อนอยู่ที่ 2,400°C จากผลการ วิเคราะห์รามานสเปกโตรสโคปีพบว่าที่การเพิ่มความดันจาก 2 เป็น 5 ทอร์ (266.6 และ 666.6 Pa) ทำให้โครงสร้างเกิดการเปลี่ยนแปลงจากคาร์บอนกล้ายเพชรไปเป็นโครงสร้างหลายผลึกของเพชร ในระดับนาโน (nanocrystalline diamond structure)

เนื่องจากอุณหภูมิที่ใช้ในการสังเคราะห์สารเคลือบด้วยวิธีชีวิดีนั้นสูงมากจึงเป็นข้อจำกัด สำหรับชิ้นงาน ซึ่งในงานอุตสาหกรรมหล่ออลูมิเนียมด้วยวิธีการฉีดขึ้นรูปนั้นแม่พิมพ์ทำจากเหล็ก H13 ซึ่งที่อุณหภูมิ 845 °C จะเป็นอุณหภูมิอบอ่อน J.R Davis (1996) ซึ่งจะทำให้โครงสร้างเดิมของ ชิ้นงานเกิดความเสียหายได้ ดังนั้นจึงมีการคิดค้นการลดอุณหภูมิในการทำปฏิกิริยา เช่น กระบวนการตกสะสมไอเกมิโดยอาศัยกลื่นไมโครเวฟช่วยให้เกิดพลาสมา W. Jaremboon และคณะ (2003) สังเคราะห์ฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชรด้วยระบบไมโครเวฟพลาสมาชีวิดี (Microwave Plasma CVD) รูปที่1.11 ลงบนแผ่นวัสดุฐานที่เป็นเหล็กรอบสูง (High speed steel) โดยอุณหภูมิที่วัสดุฐาน อยู่ในช่วง 450 – 500°C เพื่อศึกษาผลของการขัดผิวด้วยผงเพชร ผลของการให้ค่าไบแอสกวามต่าง ศักย์และอัตราส่วนการไหลของของมีเทนต่อไฮโดรเจนที่มีต่อความแข็ง ซึ่ง Wirat Jaremboon และ กณะพบว่าสำหรับแผ่นวัสดุฐานที่ขัดด้วยผงเพชรและเกลือบโดยใช้ก่าไบแอสกวามต่างศักย์ -150 โวลต์ ฟิล์มที่ได้จะมีโครงสร้างเพชรแบบเฮกซะโกนอล (hexagonal diamond) ส่วนแผ่นวัสดุฐานที่ 150 โวลต์ ฟิล์มที่ได้จะเป็นฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชรนอกจากนี้ยังพบว่าแผ่นวัสดุฐานที่เกลือบด้วย ฟิล์มจะมีก่ากวามแข็งมากกว่าแผ่นวัสดุฐานที่ยังไม่ได้เกลือบ



ร**ูปที่ 1.11** กระบวนการสังเคราะห์ฟิล์มบางด้วยวิธีซีวีดีต่างชนิดกัน J. Fricke (2003)

(a) hot filament, (b) NIRIM – type microwave plasma reactor,

(c) ASTEX- type microwave plasma reactor, and (d) DC arc jet (plasma torch)

J. C และคณะ (2000) ศึกษาสมบัติทางกายภาพและความด้านทานต่อการสึกหรอของฟิล์ม คาร์บอนคล้ายเพชรที่ได้สังเคราะห์ด้วยวิธีการตกสะสมไอเคมีโดยอาศัยคลื่นความถี่วิทยุในการช่วย ให้เกิดพลาสมาความหนาแน่นสูง (High Density plasma CVD : HDPECVD) จากแก๊สอะเซทิลีน และไฮโดรเจนลงบนแผ่นซิลิกอน (100) อุณหภูมิวัสดุฐานที่ใช้ในการทดลองอยู่ที่ 150°C จากผล การวิเคราะห์ความด้านทานความสึกหรอที่ภายใต้บรรยากาศปกติ ภายใต้บรรยากาศในโตรเจน และ ภายใต้บรรยากาศที่มีความเป็นสุญญากาศสูง (Ultra high vacuum) ด้วยเครื่องวัดความสึกหรอ แบบพินออนแฟลต (pin-on flat) ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานที่ภายใต้บรรยากาศปกติมีก่า 0.13 – 0.14 ที่ภายใต้บรรยากาศที่มีความเป็นสุญญากาศสูงค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานอยู่ในช่วง 0.02 – 0.05 และที่ ภายใต้บรรยากาศที่มีความเป็นสุญญากาศสูงค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานมีก่าน้อยกว่า 0.005 ในงานวิจัยนี้ได้ใช้กระบวนการเคลือบซีวีดีโดยอาสัยกลิ่นความถิ่วิทยุช่วยในการเกิด พลาสมา โดยศึกษาผลของแก๊สที่ใช้เป็นสารตั้งด้น อัตราการใหลของแก๊สที่ใช้เป็นสารตั้งต้น กำลัง ของกลิ่นความถิ่วิทยุ เป็นต้น A. Erdemir (2000) และคณะทำการศึกษาผลกระทบของชนิดของแก๊ส ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของความเสียดทานและความสึกหรอในกระบวนการสังเคราะห์ฟิล์ม การ์บอนคล้ายเพชรด้วยวิธีการตกสะสมใอเคมีเสริมพลาสมา (PECVD) ลงบนวัสดุฐานที่เป็นเหล็ก H13 โดยแก๊สที่ใช้ในการทดลองก็อ มีเทน (CH₄) อะเซทิลีน (C₂H₂) อีเทน (C₂H₆) และเอทิลีน (C₂H₄) โดยทำการอุณหภูมิที่สังเคราะห์ฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรที่อุณหภูมิห้อง จากผลการทดสอบการสึก หรอและค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชร พบว่าที่อัตราส่วนระหว่าง ใฮโดรเจนต่อการ์บอนมากจะให้ก่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานและการสึกหรอที่ค่ำกว่าฟิล์มที่มี อัตราส่วนระหว่างไฮโดรเจนต่อการ์บอนน้อย คือ ก่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานและการสึกหรอ ของ อะเซทิลีน (C₂H₂) เอทิลีน (C₂H₄)อีเทน (C₂H₆) และ มีเทน (CH₄) มีก่าจากมากไปน้อย ตามถ้าดับ

การวิเคราะห์เทคนิคอินฟราเรคสเปคโตรสโคปี (Fourier Transform Infrared Spectroscopy, FTIR) เป็นเทคนิคที่ใช้หาโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ โดยใช้หลักการการดูดกลืนรังสี อินฟราเรค เมื่อรังสีอินฟราเรคถูกดูดกลืน พลังงานนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานการหมุนและการ สั่นของโมเลกุล โดยโมเลกุลของสารแต่ละชนิด จะให้สเปคตรัมที่เป็นเอกลักษณ์ของพันธะใน โมเลกุลนั้นๆ ซึ่งเป็นสามารถใช้ศึกษาหมู่ฟังก์ชันและพันธะของธาตุองค์ประกอบ ดังแสดงในรูปที่ 1.12



ร**ูปที่ 1.12** หลักการทำงานของเทคนิคอินฟราเรคสเปกโตรสโคปี (ที่มา : http://science.kmutt.ac.th/sic/index.php/chemistry, สืบค้นเมื่อ 25 เมายน 2557)

Jaebum Kim และ Chongmu Lee (2003) ศึกษาอิทธิพลของอัตราส่วนระหว่างแก๊สมีเทนด่อ แก๊สอาร์กอน โดยการปรับเปลี่ยนอัตราการใหลของมีเทน ด้วยวิธีการตกสะสมไอเคมีเสริม พลาสมาโดยอาศัยคลื่นความถี่วิทยุช่วยในการเกิดพลาสมาลงบนแผ่นซิลิกอน (100) พบว่าอัตราการ ตกสะสมของสารเคลือบเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณแก๊สอาร์กอน เพิ่มขึ้นถึง 60% และเมื่อปริมาณแก๊ส อาร์กอน มากกว่า 60% อัตราการตกสะสมของสารเคลือบลดลงอย่างรวดเร็ว จากการศึกษาพบว่า อัตราการตกสะสมของสารเคลือบนั้นจะขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของพลาสมา จากผลการวิเคราะห์ ผลด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี (FTIR) พบสเปกตรัมในช่วงเลขคลื่น 2800-3000 cm⁻¹ ซึ่ง แสดงถึงการสั่นในหมู่ฟังก์ชัน C-H แบบ stretching ซึ่งความแหลมของสเปกตรัมจะลดลงเมื่อเพิ่ม อัตราส่วนของแก๊สอาร์กอนและลดอัตราส่วนของแก๊สมีเทนทำให้ ปริมาณ sp² ในฟิล์มการ์บอน คล้ายเพชรลดลง

รามานสเปกโตรสโกปีเป็นเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของฟิล์มบาง การ์บอนคล้ายเพชร ดังแสดงในรูปที่ 1.13 เนื่องด้วยเทคนิคนี้สามารถวิเคราะห์โครงสร้างของฟิล์ม การ์บอนคล้ายเพชรซึ่งมีลักษณะที่ไม่เป็นระเบียบ ซึ่งเทคนิคส่วนใหญ่ในการวิเคราะห์ฟิล์มการ์บอน คล้ายเพชรมักถูกรบกวนได้มาก ทำให้รามานสเปกโตรสโกปีมักถูกใช้เพื่อตรวจสอบยืนยันชั้น เคลือบคาร์บอนที่มีสมบัติคล้ายเพชร รามานสเปกตรัมของฟิล์ม การ์บอนคล้ายเพชร จะพบ สเปกตรัมเกิดขึ้นสองตำแหน่งโดยที่ตำแหน่งแรก คือ ตำแหน่งแกรไฟต์ที่มีการเรียงตัวอย่างไม่เป็น ระเบียบ (disordered graphite) ซึ่งถูกเรียกว่า ดีพิค (D-peak) และตำแหน่งที่สอง คือ ตำแหน่งของ แกรไฟต์ ซึ่งถูกเรียกว่า จีพิค (G-peak) จากตำแหน่งทั้งสองแสดงให้เห็นว่าชั้นเคลือบมีโครงสร้าง ของการ์บอนคล้ายเพชร

รามานสเปกโตรสโคปี (Raman spectroscopy) ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการบ่งชี้ ลักษณะเฉพาะ ของฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชร ปกติแล้วเพชรแบบผลึกเดี่ยว (single crystal)จะมี สเปกตรัมของรามานที่ตำแหน่งเลขคลื่นที่ 1332 cm⁻¹ มีลักษณะเป็นพืกที่คมชัด (sharp peak) ซึ่งมา จากการสั่นของการ์บอนที่มีพันธะแบบ sp³ S. Prawer. และคณะ(1998) ส่วนเพชรแบบผลึกหก เหลี่ยม (hexagonal diamond) ที่เตรียมจากเทคนิค shock loading จะมีสเปกตรัมรามานที่ 1315 – 1326 cm⁻¹ แต่มีลักษณะเป็นพิคฐานกว้าง (broad peak) D.S, Knight (1988) ส่วนเพชรที่มีผลึกระดับ นาโน (nanocrystalline diamond) จะมีสเปกตรัมของรามานที่ 1100 – 1500 cm⁻¹ และ 1620 cm⁻¹ Prawer. S และคณะ (2000) พืคที่มีลักษณะเป็นสองพิคอยู่แยกกันอย่างชัดเจนที่ตำแหน่งเลขคลื่น 1360 cm⁻¹ และ 1580 cm⁻¹ ซึ่งสอดคล้องกับดีพิค (D peak) และ จีพิค (G peak) ตามลำดับ จะเป็น สเปกตรัมของการ์บอนอสัณฐาน (amorphous carbon : a-C) แต่ถ้า D peak และ G peak ซ้อนกัน เหลื่อมกันอยู่จะแสดงถึงความเป็นการ์บอนคล้ายเพชร D.S, Knight (1988), Q. Wei and J. Narayan (2000)



ร**ูปที่ 1.13** หลักการทำงานของเทคนิครามานสเปกโตรสโกปี (ที่มา : http://www.chem.umd.edu/surface-analysis-center/, สืบค้นเมื่อ 25 เมายน 2557)

Y.T. Kim และคณะ (2003) ศึกษาผลกระทบของกำลังคลื่นความถิ่วิทขุและความดันต่อ โครงสร้างของพันธะในฟิล์มคาร์บอนเพชร โดยทำการสังเคราะห์ฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรลงบน แผ่นซิลิกอน จากแก๊สมีเทน และ ไฮโครเจน ด้วยวิธีการตกสะสมไอเคมีเสริมพลาสมาโดยอาศัย คลื่นความถิ่วิทขุในการช่วยให้เกิดพลาสมา จากผลการทดลองพบว่าที่กำลังของคลื่นความถิ่วิทขุ เพิ่มขึ้นจะทำให้อัตราการตกสะสมฟิล์มคาร์บอนเพิ่มขึ้น และที่ความดันเพิ่มขึ้นจาก 53.3 Pa เป็น 106.6 Pa จะให้อัตราการตกสะสมฟิล์มการ์บอนเพิ่มขึ้น และที่ความดันเพิ่มขึ้นจาก 53.3 Pa เป็น 106.6 Pa จะให้อัตราการตกสะสมของฟิล์มการ์บอนเพิ่มขึ้น แต่เมื่อความดันเพิ่มมากกว่า 106.6 Pa เป็น 800 Pa อัตราการตกสะสมของฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชรกลับลดลงจาก 12,000 Å เป็น 1,330 Å และทำให้อัตราส่วนระหว่างก่า I_D ต่อ I_G (Intensity of D peak and G peak : I_D/I_G) มีก่าลดลง ซึ่ง แสดงถึงปริมาณ sp³ ในฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชรเพิ่มขึ้น เนื่องจากการชนกันของอะตอมของ ใฮโครเจนที่เพิ่มมากขึ้นกับฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชร

Suriany Sarmid และคณะ (2006) ศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิวัสดุฐานที่มีอิทธิพลต่อ โครงสร้างของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรด้วยวิธีการตกสะสมไอเคมีเสริมพลาสมาจากแก๊สมีเทนลง บนวัสดุฐานที่เป็นแผ่นซิลิกอน จากผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิครามานสเปกโตรสโคปีพบว่า ที่ อุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก 25°C เป็น 30°C พบว่าพีค G มีค่าเพิ่มขึ้นจาก 1540 เป็น 1590 cm⁻¹ ซึ่งแสดงถึง ปริมาณ sp² เพิ่มขึ้น และเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น 200°C พบว่าพีค G ลดลงจาก 1590 เป็น 1560 cm⁻¹ ซึ่งแสดงถึงปริมาณ sp³ เพิ่มขึ้น และจากอัตราส่วนระหว่าง I_D/I_G ที่อุณหภูมิ 30°C มีค่า 1.3940 และ เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น 200°C ค่า I_D/I_G ลดลงเหลือ 0.8368 ซึ่งแสดงถึงปริมาณ sp³ ที่เพิ่มขึ้นเมื่อ อุณหภูมิสูงขึ้น

J. Takadoum (2003) ศึกษาสมบัติเชิงกลของและสมบัติการต้านทานความสึกหรอของ ฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรและฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรเจือธาตุในโตรเจนด้วยวิธีพีอีซีวีดี และ ปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของวัสคุฐาน ลงบนวัสคุฐานที่เป็นเหล็กกล้ารอบสูง (high speed steel) จากผล การวิเคราะห์อินฟราเรคสเปกโตรสโกปี (FTIR) พบหมู่ฟังก์ชัน C-H ในช่วงเลขคลื่น 2700-3000 cm⁻¹ N-H ในช่วง 3200-3600 cm⁻¹และ C-C, C-N, C=N ในช่วง 1250-1600 cm⁻¹ ผลการวิเคราะห์ ้ความแข็งพบว่า สำหรับตัวอย่างที่ไม่ได้เจือชาตุในโตรเจน ค่าความแข็งมีค่าลดลงจาก 30 GPa เหลือ 9 GPa เมื่อเพิ่มอุณหภูมิจาก 300°C เป็น 600°C เนื่องจากเกิดกระบวนการกราฟิไทเซชัน (graphitization) ซึ่งทำให้เฟส sp³ ลุคลง สำหรับชิ้นงานที่เจือธาตุในโตรเจนมีค่าความแข็งที่ต่ำกว่า ้ ตัวอย่างที่ไม่เจือธาตไนโตรเจน ซึ่งมีค่าความแข็งคงที่ ที่ 15 GPa ตลอดทกช่วงอณหภมิ แสดงให้ ้เห็นถึงคุณสมบัติต้านทานความร้อนที่ดีกว่าตัวอย่างที่ไม่เจือธาตุไนโตรเจน จากการวิเคราะห์ก่า สัมประสิทธิ์ความเสียคทานด้วยวิธีการขัดสีระหว่างลูกบอลบนแผ่นคิสก์ (ball on disc tribometer) พบว่าที่อุณหภูมิ 600°C สำหรับชิ้นงานที่เจือธาตุในโตรเจนมีค่าสัมประสิทธิความเสียคทานที่คงที่ ที่ 0.15 สำหรับชิ้นงานที่ไม่เจือธาตุในโตรเจนค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานมีค่าเพิ่มขึ้นจาก 0.15 ้เป็น 0.4 และจากการทดสอบอัตราการสึกหรอของฟิล์มการ์บอนพบว่าชิ้นงานที่เจือธาตุในโตรเจนมี ้อัตราการสึกหรอที่ต่ำกว่าชิ้นงานที่ไม่ได้เจือธาตุไนโตรเจน แสดงให้เห็นว่าเมื่อเจือธาตุไนโตรเจน จะช่วยเพิ่มสมบัติทางกลได้ดีขึ้น

Steven M. Smith และคณะ (2001) สังเคราะห์ฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรด้วยวิธีการตกสะสม ใอเคมีเสริมพลาสมาจากแก๊สมีเทนและ ในโตรเจน ลงบนแผ่นซิลิกอน เพื่อศึกษาผลกระทบของ อัตราการใหลของแก๊ส ในโตรเจนและอุณหภูมิของวัสดุฐานที่แตกต่างกันต่อสมบัติเชิงกล จากผล การทดลองพบว่าเมื่อเพิ่มอัตราการใหลของแก๊ส ในโตรเจนเป็น 1 ลิตรต่อนาที พบว่าอัตราการตก สะสมของฟิล์มการ์บอนเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มอัตราการใหลของในโดรเจนเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 ลิตรต่อนาที อัตราการตกสะสมของฟิล์มการ์บอนลดลง และที่อุณหภูมิวัสดุฐานเพิ่มขึ้น อัตราการตกสะสมของ ฟิล์มการ์บอนลดลง จากผลการวิเคราะห์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี (FTIR) พบหมู่ฟังก์ชันของ CH₂ ซึ่งเป็นการสั่นแบบ symmetric และ asymmetric ในช่วงเลขกลื่น 2800-3000 cm⁻¹ และพบหมู่ ฟังก์ชันของ N-H ซึ่งเป็นการสั่นแบบ cis และ trans ในช่วงเลขกลื่น 3175-3450 cm⁻¹ จากผลการ ทคสอบสมบัติเชิงกลพบว่าเมื่อ อัตราการไหลของแก๊สไนโตรเจนเพิ่มขึ้นพบว่า ก่าความเค้น (stress) เพิ่มขึ้น ก่าความแข็งเพิ่มขึ้น และก่ามอดูลัสความยืดหยุ่นมีค่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากในโตรเจนที่เพิ่มเข้า ใปทำหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นมลทิน (impurity) ในฟิล์มการ์บอน จากผลการทดสอบสมบัติด้าน กวามร้อนด้วยการนำไปเผาที่ช่วงอุณหภูมิ 400 -1,000°C จากผลการวิเคราะห์อินฟราเรดสเปกโตรส โกปี (FTIR) ของชิ้นงานหลังจากผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 600°C ไม่พบหมู่ฟังก์ชัน C-H แสดงให้เห็น ว่าเกิดการสูญเสียไฮโดรเจน จากผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิกรามานสเปกโตรสโกปีพบพีค D และ G ที่อุณหภูมิ 600°C และ 800°C โดยที่อุณหภูมิ 800°C เกิดพีกเด่นชัดที่สุด แต่ที่อุณหภูมิ 1000°C กลับไม่พบพีก D และ G ซึ่งสอดกล้องกับผลการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรสน์อิเล็กตรอนแบบส่อง ผ่าน (TEM) ซึ่งพบว่าที่อุณหภูมิ 800°C มีความเป็นผลึกสูงที่สุด

1.4 ขอบเขตของโครงการวิจัย

งานวิจัยนี้ทำการพัฒนาและสร้างสารเคลือบด้วยวิธีการตกสะสมไอเคมีเสริมพลาสมา (PECVD) เพื่อยืดอายุการใช้งานของแม่พิมพ์สำหรับงานหล่ออลูมิเนียมรวมถึงการผลิตสารเคลือบ บนชิ้นงานที่ทำจากวัสดุประเภทเดียวกับแม่พิมพ์ที่ใช้อยู่ทั่วไป ได้แก่ เหล็กกล้าไร้สนิม H-13 หรือ พวกโลหะผสมโครเมียม ที่ผ่านการชุบผิวแข็ง ทดสอบสมบัติของสารเคลือบที่ได้ เป็นขั้นตอน ดังนี้คือ ขั้นแรกทำการทดสอบคุณสมบัติทั่วไป ได้แก่ คุณสมบัติทางเคมี โครงสร้างของสารเคลือบ กวามแข็งทางด้านการยึดเกาะของฟิล์ม ขั้นต่อมาทำการทดสอบความทนต่อการขัดสี และความ ด้านทานทางความร้อน

1.5 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษากระบวนการสังเคราะห์ฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรและการเกลือบผิวแม่พิมพ์

2. เพื่อพัฒนาสารเคลือบผิวแม่พิมพ์เพื่อยืดอายุแม่พิมพ์ ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการขึ้นรูป ชิ้นงานด้วยวิธีหล่อฉีด (die casting)

3. ศึกษาตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อการสังเคราะห์ฟิล์ม

4. ศึกษาสมบัติเชิงกลของชั้นฟิล์มที่ได้จากการสังเคราะห์

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบถึงกระบวนการสังเคราะห์ฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร

2. ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการเคลือบผิวแม่พิมพ์

3. ได้สารเคลือบผิวแม่พิมพ์ที่สามารถยืดอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ได้

4. เป็นแนวทางในการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนารวมทั้งเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ในภากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้ในอนากต

5. งานวิจัยและเผยแพร่ผลงาน

1.7 สถานที่ทำการวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทที่ 2

วิชีดำเนินงานวิจัย

การดำเนินการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและสารเคมีที่ใช้ในกระบวน การเคลือบฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร รวมถึงขั้นตอนการวิจัย

2.1 วัสดุและอุปกรณ์การทดลอง

วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการเคลือบฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร วิเคราะห์ และทดสอบ ดังตารางที่ 2.1

เครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมี	บริษัทผู้ผลิต	แบบรุ่น	รูปที่
Substrate materials			
H 13 steel	Modify		2.1 (a)
(\emptyset 25 mm, thick 3.5 mm)			
Glass slide	Rabbit lab	CAT No.	2.1 (b)
$(25.4 \times 46.2 \times 1.2 \text{ mm}^3)$		7101A	
Vacuum system			
Rotary pump	Leybold	Trivac D 16	2.2 (a)
		BCS-PFPE	
Air cooling unit	Leybold	Turbovac 855	2.2 (b)
		31/41	
Turbomolecular pump	Leybold	Turbovac 151	2.2 (c)
		С	
Turbodrive	Leybold	Turbo.Drive	2.2 (d)
		TD20 classic	
Penning Gauge	Leybold	PenningVac	2.2 (e)
		PTR 90	

ตารางที่ 2.1 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

เครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมี	บริษัทผู้ผลิต	แบบรุ่น	รูปที่
Pirani Gauge	Leybold	Thermovac Transmitter TTR 91	2.2 (f)
Pressure display unit	Leybold	Display Two	2.2 (g)
RF Generator	Stolberg	CITO 1310	2.3
Mass flow controller unit			
Mass flow controller	MKS Instrument	1179A	2.4 (a)
4-Channel Readout	MKS Instrument	247D	2.4 (b)
Substrate Heater			
Heater	Modify		2.5
Power supply	Modify		2.5
Ultrasonic Cleaner	Crest Ultrasonnic	CP 200 HT	2.6 (b)
Chemical solution and Gasses			
Acetone	J.T. Baker		2.6 (a)
Argon Gas			2.7
Nitrogen Gas			2.7
Methane Gas			2.7
Fourier Transform Infared (FTIR) Spectroscopy	Bruker	EQUINOX 55	2.8
Raman Spectroscopy	JOBIN YVON HORIBA	T64000 triple monochromator	2.9

ตารางที่2.1 (ต่อ) วัสคุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการทคลอง

เครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมี	บริษัทผู้ผลิต	ແບບຊຸ່ນ	รูปที่
X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)	Kratos	AXIS Ultra	2.10
		DLD	
Scaning Electron Microscope (SEM)	JEOL	JSM-5800 LV	2.11
Thermal gravimetric Analyzer (TGA)	Perkin Elmer	TGA7	2.12
Nano indentation tester	CSM	NHTX S/N:	2.13
	instrument	02-02877	
Scratch test	CSM	RST S/N: 01-	2.14
	instrument	02877	
Wear test	CSM	High	2.15
	instrument	Temperature	
		Tribometer	

ตารางที่2.1 (ต่อ) วัสคุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการทคลอง



ร**ูปที่ 2.1** วัสคุฐานที่ใช้ในการทคลอง (a) กระจกสไลด์ (b) H13 (c) H13 ที่ขัดผิว



ร**ูปที่ 2.2** อุปกรณ์ที่ใช้ในในการเคลือบฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรในส่วนระบบสุญญากาศ

- (a) Rotary pump (b) Air cooling unit (c) Turbomolecular pump (d) Turbodrive
- (e) Peening Gauge (f) Pirani Gauge (g) Pressure display unit



ร**ูปที่ 2.3** เครื่องกำเนิดคลื่นความถี่วิทยุ RF Generator CITO 1310



รูปที่ 2.4 ระบบควบคุมอัตราการ ใหลของแก๊ส (a) Mass flow controller (b) 4-Channel readout



ร**ูปที่ 2.5** ระบบควบคุมอุณหภูมิวัสคุฐาน (Heater controller)



ร**ูปที่ 2.6** อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในในการทำความสะอาควัสคุฐาน (a) อะซิโตน (Acetone) (b) เครื่องสั่นอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Cleaner)



รูปที่ 2.7 แก๊สที่ใช้ในระบบการเคลือบฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร



รูปที่ 2.8 เครื่องวิเคราะห์อินฟราเรคสเปกโตรสโคปี

(Fourier transform infrared spectroscopy, FTIR)



รูปที่ 2.9 เครื่องรามานสเปกโตรสโคปี (Raman Spectroscopy)



รูปที่ 2.10 เครื่องวิเคราะห์เอ็กซ์เรย์โฟโตอิเล็กตรอนสเปคโตรสโกปี

(X-ray Photoelectron Spectroscopy)



ร**ูปที่ 2.11** กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)



รูปที่ 2.12 Thermal gravimetric Analyzer (TGA)



รูปที่ 2.13 Nano-indentator



รูปที่ 2.14 Tribometer (Scratch test)



ฐปที่ 2.15 Tribometer (Ball on disc)

2.2 การดำเนินการทดลอง

เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรต่างๆที่มีผลกระทบต่อฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชร ซึ่งตัวแปรที่ ศึกษาในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ อุณหภูมิวัสคุฐาน อัตราการไหลของแก๊ส และกำลังของคลื่นความถี่ วิทยุ

2.2.1 การสังเคราะห์ฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร

2.2.1.1 กิจกรรมที่ 1 : การเตรียมชิ้นงานตัวอย่าง

- 1. นำเหล็ก H13 มาทำการขัดหน้าชิ้นงานด้วยเครื่องขัดกับกระดาษทรายและผงอะลูมินา
- 2. นำกระจกสไลค์ และเหล็ก H13 ล้างค้วยเครื่องอัลตร้าโซนิคในอะซิโตน
- 3. เป่าชิ้นงานให้แห้งด้วยเครื่องเป่าผม
- 4. นำชิ้นงานเข้าเครื่อง PECVD

2.2.1.2 กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของของแก๊สมีเทนต่อการเกิดฟิล์ม DLC

ในการทดลองครั้งนี้ได้ควบคุมอัตราการไหลของแก๊สอาร์กอน (Ar) ที่ 20 sccm อุณหภูมิ วัสคุฐาน และได้ปรับเปลี่ยนอัตราการไหลของแก๊สมีเทน (CH₄) ที่ 5 10 15 20 และ 50 sccm ดัง แสดงในตารางที่ 2.2

Condition	Ar (sccm)	CH ₄ (sccm)	Rf power (watt)	Temp (°C)
1	20	5	100	300
2	20	10	100	300
3	20	15	100	300
4	20	20	100	300
5	20	50	100	300

,				
ตารางที่ 2.2	พารามิเตอร์ที่ศึกบ	ษาอัตราการ	ใหลของแก๊สมีเทน	(CH_4)

2.2.1.3 กิจกรรมที่ 3 : ศึกษากำลังของคลื่นความถี่วิทยุที่เหมาะสมในการเกิด DLC ที่อุณหภูมิ 25°C

ในการทดลองครั้งนี้ได้ควบคุมอัตราการไหลของแก๊สอาร์กอน (Ar) และ แก๊สมีเทน (CH₄) ที่ 20 และ 15 secm ตามลำดับ และได้มีการปรับเปลี่ยนกำลังของคลื่นความถี่วิทยุที่ 50 75 125 150 175 และ 200 secm ดังแสดงในตารางที่ 2.3

Condition	Ar (sccm)	CH ₄ (sccm)	Rf power (watt)	Temp (°C)	
6	20	15	50	25	
7	20	15	75	25	
8	20	15	125	25	
9	20	15	150	25	
10	20	15	175	25	
11	20	15	200	25	

ตารางที่ 2.3 พารามิเตอร์ที่ศึกษากำลังของคลื่นความถี่วิทยุที่อุณหภูมิห้อง

2.2.1.4 กิจกรรมที่ 4 : ศึกษากำลังของคลื่นความถี่วิทยุที่เหมาะสมในการเกิด DLCที่อุณหภูมิ300°C

ในการทดลองครั้งนี้ได้ควบคุมอัตราการไหลของแก๊สอาร์กอน (Ar) และ แก๊สมีเทน (CH4) ที่ 20 และ 15 secm ตามลำดับ และได้มีการปรับเปลี่ยนกำลังของคลื่นความถี่วิทยุที่ 50 75 125 150 175 และ 200 secm ดังแสดงในตารางที่ 2.4

Condition	Ar (sccm)	CH_4 (sccm)	Rf power (watt)	Temp (°C)
12	20	15	50	300
13	20	15	75	300
14	20	15	125	300
15	20	15	150	300
16	20	15	175	300
17	20	15	200	300

ตารางที่ 2.4 พารามิเตอร์ที่ศึกษากำลังของคลื่นความถี่วิทยุที่อุณหภูมิ 300°C

2.2.1.5 กิจกรรมที่ 5 : ศึกษาสัดส่วนของแก๊สไนโตรเจนที่เหมาะสมที่กำลังของคลื่นความถี่วิทยุ 100 วัตต์

หลังจากได้พารามิเตอร์ในการสังเคราะห์ฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรเบื้องต้นคือ ที่อัตราการ ใหลของแก๊สมีเทน (CH₄) ที่ 15 seem และที่อุณหภูมิวัสคุฐาน 300 °C จึงได้ทำการทคลองเติมธาตุ ในโตรเจนจากแก๊สไนโตรเจน (N₂)โดยทำการปรับเปลี่ยนอัตราการไหลที่ 5 7 10 12 15 20 25 และ 50 seem ดังแสดงในตาราง 2.5

Condition	Ar	CH_4	N_2	Rf power	Temp
	(sccm)	(sccm)	(sccm)	(watt)	(°C)
18	20	15	5	100	300
19	20	15	7	100	300
20	20	15	10	100	300
21	20	15	12	100	300
22	20	15	15	100	300
23	20	15	20	100	300
24	20	15	25	100	300
25	20	15	50	100	300

ตารางที่ 2.5 พารามิเตอร์ที่ศึกษาอัตราการไหลของ N_2 ที่กำลังของคลื่นความถี่วิทยุ 100 วัตต์

2.2.1.6 กิจกรรมที่ 6 : ศึกษาสัดส่วนของแก๊สในโตรเจนที่เหมาะสมที่กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 200 วัตต์

หลังจากได้สังเคราะห์ฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่ได้ทำการโด๊ปไนโตรเจนดังในกิจกรรมที่ 5 พบว่าไม่เกิดพันธะระหว่าง C กับ N จึงได้เพิ่มกำลังของคลื่นความถี่วิทยุเป็น 200 วัตต์โดยคง พารามิเตอร์อื่นไว้เช่นเดียวกับการทดลองที่ 5 ดังแสดงในตารางที่ 2.6

Condition	Ar	CH_4	N_2	Rf power	Temp
	(sccm)	(sccm)	(sccm)	(watt)	(°C)
26	20	15	5	200	300
27	20	15	7	200	300
28	20	15	10	200	300
29	20	15	12	200	300
30	20	15	15	200	300
31	20	15	20	200	300
32	20	15	25	200	300
33	20	15	50	200	300

ตารางที่ 2.6 พารามิเตอร์ที่ศึกษาอัตราการใหลของแก๊ส ในโตรเจนที่กำลังคลื่นของความถี่วิทยุ 200 วัตต์

2.2.1.7 กิจกรรมที่ 7 : ศึกษาผลของกำลังของคลื่นความถี่วิทยุที่มีต่อสมบัติฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร

หลังจากได้พารามิเตอร์ในการสังเคราะห์ฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชรที่โด๊ปไนโตรเจนที่ เหมาะสม คือ ที่อัตราการไหลของแก๊สมีเทน (CH₄) ที่ 15 sccm อัตราการไหลของแก๊สไนโตรเจน (N₂) ที่ 15 sccm และที่อุณหภูมิวัสคุฐาน 300 °C โดยทำการปรับเปลี่ยนกำลังของคลื่นความถิ่วิทยุที่ กำลัง 50 และ150 วัตต์ ดังแสดงในตาราง 2.7

ตารางที่ 2.7 พารามิเตอร์ที่ศึกษาฟิลม์การ์บอนกล้ายเพชรที่ โด๊ปไน โตรเจน โดยปรับเปลี่ยนกำลัง กลื่นของกวามถี่วิทยุ

Condition	Ar	CH ₄ N ₂		Rf power	Temp
	(sccm)	(sccm)	(sccm)	(watt)	(°C)
34	20	15	15	50	300
35	20	15	15	150	300

2.2.2 การทดสอบความแข็งของฟิลั่มคารับอนคล้ายเพชร

เทคนิคการวัดความแข็งด้วยการกดวัดระดับนาโนเมตร (Nanoindentation technique) เป็น การวัดความแข็งของฟิล์มบาง รอยกคมีความลึกระดับนาโนเมตร ขณะทำการกดหัวกคเพชรจะ ก่อยๆทำการกดลงไปทีละน้อย จนผิวเคลือบเกิดการเปลี่ยนรูปจากแบบยืดหยุ่นเป็นแบบถาวร (Plastic deformation) ด้วยเครื่องวิเคราะห์ความแข็งฟิล์มบาง (Nano-indentator) ดังแสดงในรูปที่ 2.13

ผลการทคสอบแสดงความสันพันธ์ระหว่างแรงกค (Load) และระยะลึก (displacement) สามารถหาก่าความแข็ง สมบัติของการยึดหยุ่น สมบัติการคืบของฟิล์ม โดยเทคนิคนี้สามารถ วิเคราะห์ทั้งการให้แรงกดและไม่มีแรงกค ดังแสดงในในรูปที่ 2.16



รูปที่ 2.16 ลักษณะกราฟทคสอบความแข็ง (W.C. Oliver)

การหาความแข็งของฟิล์มบางสามารถคำนวณได้จากความต้านทานการเปลี่ยนรูป จากสมการที่ 2.1

$$H = P_{max} / A \tag{2.1}$$

พื้นที่ของรอยกดสามารถหาได้จากฟังก์ชันของพื้นที่ F(b) ที่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ ตัดขวางของหัวกดกับความลึกของการกด (b) ความลึกของการกดไม่ควรเกิน 1/10 ของความหนา ฟิล์ม เพราะจะทำให้มีอิทธิพลของวัวคุฐานทำให้ก่าความแข็งที่ได้คลาดเกลื่อน ซึ่งสามารถหาพื้นที่ รอยกดได้จากสมการที่ 2.2

$$A = F(h_c) \tag{2.2}$$

$$F(h) = 24.5 h^2$$
 (2.3)

$$\mathbf{h}_{c} = \mathbf{h}_{max} - [\mathbf{\mathcal{E}}\mathbf{P}_{max}/(d\mathbf{P}/d\mathbf{h})]$$
(2.4)

เมื่อ h_{max} คือ ระยะความลึกสูงสุด (nm) dP/dh คือ ความชันของกราฟสภาวะไร้แรงกระทำ (Unloading) & คือ ค่าคงที่ของหัวกด

การวัคค่ามอดูลัสความยืดหยุ่นสามารถหาได้จากความสัมพันธ์ของพื้นที่สัมผัสและ Unloading Stiffness (dP/dh) ดังสมการที่ 2.5

$$S = \beta \frac{2}{\pi} E_{\text{eff}} \sqrt{A}$$
 (2.5)

เมื่อ	S	กือ มอดูถัสกวามยึดหยุ่น (MPa)
	β	คือ ค่าคงที่ของหัวกด
	E_{eff}	คือ ก่ามอดูลัสยึคหยุ่นประสิทธิผล (MPa)

ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้นำไปทดสอบความแข็งด้วยเครื่องนาโนอินเดนเทเตอร์รุ่น NHTX S/N: 02-02877 : CSM instrument คังรูปที่ 2.13 โดยมีสภาวะในการทดสอบคังนี้ ภาระสูงสุดที่ 100 mN อัตราการให้ภาระที่ 200 mN/min อัตราการปลอดภาระที่ 200 mN/min กดค้างไว้เป็นระยะเวลา 3 วินาที โดยหัวกดที่ใช้เป็นหัวกดเพชรชนิด Berkovich

2.2.3 การทดสอบความแข็งแรงในการยึดเกาะของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร

มาตรฐานการทคสอบ ASTM C1642-05 เป็นวิธีการทคสอบหาความสามารถในการเกาะ ยึดและรูปแบบความเสียหายทางกลของผิวเคลือบเซรามิกได้แก่ คาร์ไบด์, ไนไตรด์, ออกไซด์, เพรช และ DLC เคลือบบนโลหะหรือเซรามิก ที่มีความแข็งมากกว่า 5 GPa และความหนาผิวเคลือบ 0.1-3.0 µm

โดยทั่วไประบบการทดสอบความแข็งแรงในการยึดเกาะ (Adhesion Strength) ประกอบด้วยส่วนหลักๆ 6 ส่วนดังรูปที่ 2.17 คือ

- 1. หัวลาก (Stylus)
- 2. ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของชิ้นงานทคสอบ
- 3. ระบบให้แรงกดในการทดสอบ
- 4. เซ็นเซอร์วัดแรงกด
- 5. กล้องจุลทรรศน์
- 6. ระบบบันทึกข้อมูลการทดสอบ



รูปที่ 2.17 เกรื่องทดสอบความสามารถในการเกาะยึด (ASTM C1642-05)

จากการทดสอบความสามารถในการเกาะยึด (Adhesion Strength) โดยการลากของหัวเพชร ทำให้เกิดลักษณะความเสียหายของผิวเคลือบดังรูปที่ 2.18 จะปรากฏความเสียหายเป็นสองรูปแบบ ที่ตำแหน่งการให้แรง LC1 และ LC2 สามารถกำนวณหาก่าแรงขูดวิกฤต (Critical scratch load) ได้ โดยสมการที่ 2.6 โดยที่ LC1 คือ ฟิล์มเริ่มเกิดรอยแตก และ LC2 คือ ฟิล์มเริ่มเกิดการกะเทาะ

$$L_{CN} = \left[L_{rate} \times \frac{l_n}{X_{rate}} \right] + L_{start}$$
(2.6)

Stylus drag coefficient หรือ DSC เป็นอัตราส่วนของแรงที่ด้านการเกลื่อนที่กับแรงที่ให้แก่ หัวถากกำนวนได้โดยสมการที่ 2.7

$$D_{sc} = L_T / L_N \tag{2.7}$$

- เมื่อ D_{sc} คือ Stylus drag coefficient LT คือ Tangential Force หรือแรงต้านการเคลื่อนที่ที่กระทำต่อหัว เพชร (N)
 - LN คือ Normal Force แรงที่ให้แก่หัวเพชร (N)



ร**ูปที่ 2.18** ลักษณะความเสียหายที่เกิดบนผิวเกลือบ (ASTM C1642-05)

ซึ่งในการทดลองนี้ได้นำฟิล์มที่ได้ไปทดสอบความแข็งแรงในการยึดเกาะของฟิล์ม การ์บอนคล้ายเพชรด้วยเครื่อง RST S/N: 01-02877 : CSM instrument ดังแสดงในรูปที่ 2.14 โดย เงื่อนไขในการทดสอบดังนี้ แรงที่ใช้กดเป็นแบบก้าวหน้า เริ่มต้นที่ 0.9 N และ สิ้นสุดที่ 100 N อัตรา

44

การให้แรงต่อเวลาเท่ากับ 99.99 N/min ความเร็วที่หัวกคลากผ่านผิวเคลือบเท่ากับ 10.09 mm/min เป็นระยะทาง 10 mm โดยหัวกคที่ใช้เป็นหัวกคเพชรชนิค Rockwell รัศมี 200 μm

2.2.4 การทดสอบความเสียดทานของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร

ในการทคลองนี้ได้นำฟิล์มที่ได้ไปทคสอบความเสียคทานของฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชร ด้วยเครื่องไตร โบมิเตอร์ รุ่น High Temperature Tribometer : CSM instrument ดังแสดงในรูปที่ 2.15 โดยมีสภาวะในการทคสอบดังนี้

ความเร็วที่ใช้ 4 cm/s rpm ซึ่งรัศมี 4.5 mm. ส่วนความเร็วรอบสูงสุดที่ใช้ได้คือ 500 rpm แรงที่ใช้ 2 นิวตัน จำนวนรอบที่ทดสอบ 10,000 รอบ บอลที่ใช้ : Al₂O₃ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 mm

2.2.5 การทดสอบความต้านทานอุณหภูมิสูงของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร

นำฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรที่เกลือบบนกระจกสไลด์มาขูดออกให้อยู่ในรูปผงแล้วนำใส่ กระดาษอะลูมิเนียมแล้วนำไปวิเกราะห์กวามต้านทานอุณหภูมิสูงด้วยเกรื่อง Thermal gravimetric Analyzer ยี่ห้อ Perkin Elmer รุ่น TGA7 ดังแสดงในรูปที่ 2.12 ภายใต้บรรยากาศออกซิเจน ในช่วง อุณหภูมิ 50 – 1,000 °C ที่อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 10 °C/min

ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง

ในการวิจัยนี้ได้ทำสังเคราะห์ฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชร ภายใต้บรรยากาศผสมของแก๊ส มีเทน ในโตรเจนและอาร์กอน โดยอาศัยพลังงานจากคลื่นความถี่วิทยุที่ทำให้แก๊สตั้งต้นดังกล่าว แตกตัว โดยแปรผันค่าอัตราส่วนของสารตั้งต้น กำลังวัตต์ของคลื่นความถี่วิทยุและอุณหภูมิในการ ทำปฏิกิริยา จากนั้นทำฟิล์มที่ได้ไปวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะ ผลการวิจัยในครั้งนี้แบ่งออกเป็นสอง ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งที่เป็นการศึกษาพารามิเตอร์ในการสังเคราะห์ฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรด้วยวิธี ตกสะสมไอเคมีเสริมพลาสมา (PECVD) ซึ่งในส่วนนี้ได้วิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของฟิล์มคาร์บอน คล้ายเพชรด้วยเทคนิคอินฟราเรคสเปกโตรสโคปี (Fourier transform infrared spectroscopy, FTIR) และเทคนิครามานสเปคโทรสโคปี (Raman Spectroscopy) ส่วนที่สองเป็นการศึกษาการโด๊ปฟิล์ม คาร์บอนคล้ายเพชรด้วยในโตรเจนและสมบัติของฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชร โดยศึกษาก่าความแข็ง ความแข็งแรงในการยึดเกาะ สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน และความด้านทานความร้อน

3.1 การศึกษาตัวแปรในการสังเคราะห์ฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรด้วยวิธีตกสะสมไอเคมีเสริม

พลาสมา (PECVD)

3.1.1 ศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของของแก๊สมีเทนต่อการเกิดฟิล์ม DLC

3.1.1.1 ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี

จากการแปรผันอัตราการใหลของแก๊สมีเทนจาก 5- 50 sccm โดยให้แก๊สอาร์กอนคงที่ ที่ 20 sccm ผลการวิเคราะห์ฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรด้วยเทคนิค FTIR พบการสั่นของหมู่ฟังก์ชัน C-H ในช่วงเลขคลื่น 2800 – 3000 cm⁻¹ ซึ่งในช่วงนี้เป็นลักษณะเฉพาะของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ X. B. Yan (2004), และ J. Robertson (2002) ในทุกอัตราการใหลของ แก๊สมีเทน ดังแสดงในรูปที่ 3.1 ซึ่งพีคของ FTIR สามารถบ่งบอกปริมาณหมู่ฟังก์ชันนั้นได้คร่าวๆ ซึ่งพีคที่มีความแหลมมากจะบ่งบอกถึงปริมาณของหมู่ฟังก์ชันนั้นมาก



ร**ูปที่ 3.1** ผลการวิเคราะห์ FTIR ของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการไหลของ CH₄ แตกต่างกัน ภายใต้เงื่อนไขอุณหภูมิวัสคุฐาน 300°C และกำลังของคลื่นความถี่วิทยุ 100 วัตต์

```
จากรูปที่ 3.1 จะพบการสั่นของหมู่ฟังก์ชันดังนี้
ในช่วงเลขคลื่น 1373 cm<sup>-1</sup> พบหมู่ฟังก์ชัน sp<sup>3</sup> – CH<sub>3</sub> symmetric
ในช่วงเลขคลื่น 1446 cm<sup>-1</sup> พบหมู่ฟังก์ชัน sp<sup>3</sup> – CH<sub>2</sub>
ในช่วงเลขคลื่น 1645 cm<sup>-1</sup> พบหมู่ฟังก์ชัน sp<sup>2</sup> C-C หรือ sp<sup>2</sup> C=C
ในช่วงเลขคลื่น 2156 cm<sup>-1</sup> พบหมู่ฟังก์ชัน C=C
ในช่วงเลขคลื่น 2866 cm<sup>-1</sup> พบหมู่ฟังก์ชัน sp<sup>3</sup> – CH<sub>3</sub> symmetric หรือ sp<sup>3</sup> – CH<sub>2</sub>
symmetric
ในช่วงเลขคลื่น 2922 cm<sup>-1</sup> พบหมู่ฟังก์ชัน sp<sup>3</sup> – CH<sub>2</sub> asymmetric หรือ sp<sup>3</sup> – CH
ในช่วงเลขคลื่น 2952 cm<sup>-1</sup> พบหมู่ฟังก์ชัน sp<sup>3</sup> – CH<sub>3</sub> asymmetric
```

3.1.1.2. ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิครามานสเปกโตรสโกปี

จากการวิเคราะห์ผลรามานสเปกโตรสโคปีของการศึกษาอิทธิพลของอัตราการไหลของ CH4 แตกต่างกันที่ 5 10 15 20 และ 50 sccm โดยควบคุมให้อุณหภูมิวัสคุฐานและกำลังของคลื่น ความถี่วิทยุคงที่ ที่ 300 °C และ 100 วัตต์ ตามลำคับ คังแสคงในรูปที่ 3.2 -3.7 ซึ่งพบว่าทุกช่วงอัตรา การไหลของ CH4 จะพบพืกที่อยู่ในช่วงความยาวคลื่นที่ประมาณ 1100 cm⁻¹ ซึ่งพืกที่พบในช่วงนี้ เป็นพีกของกระจกสไลด์เนื่องจากฟิล์มที่เคลือบมีลักษณะก่อนข้างใสจึงค้องเร่งกำลังของเลเซอร์รา มานในการวิเคราะห์จึงทำให้พบพีกในช่วงนี้ได้ และจากนั้นจะแขกเป็นสองพีกอข่างชัคเจนที่อัดรา การใหลของ CH4 มากกว่า 5 sccm ซึ่งสอดกล้องกับการวิเคราะห์ผลด้วยเทคนิก FTIR ที่เริ่มพบการ ปรากฏของหมู่ฟังก์ชัน C-H ในช่วงเลขกลื่น 2850-2590 cm⁻¹ ซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะของฟิล์ม การ์บอนกล้ายเพชร ที่อัตราการไหลของแก๊สมีเทน 5 sccm (รูปที่ 3.1)และเมื่อเพิ่มอัตราการไหลของ แก๊สมีเทนมากขึ้น ลักษณะดังกล่าวจะเด่นชัคขึ้น และเมื่อทำการแขกสเปกตรัมหลัก (raw spectrum) ของแต่ละอัตราการไหลของ CH4 ออกเป็นสองเส้นโค้งแบบเกาส์เซียน (Gaussian curve fitting) ด้วย ซอฟต์แวร์ของ Magic plot พบว่ามีขอดกลื่นของดำแหน่ง D peak และ G peak ซึ่งขึ้นขันลักษณะของ ฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรปรากฏที่กวามขาวกลื่นในช่วง 1330 – 1350 cm⁻¹ และ 1580 – 1590 cm⁻¹ ตามลำคับ ซึ่ง D peak เป็นดำแหน่งที่แสดงถึงโครงสร้างของแกรไฟต์ที่มีการจัดเรียงตัวกันของ อะตอมคาร์บอนอย่างไม่เป็นระเบียบ (disordered graphite) ส่วน G peak แสดงถึงโครงสร้างของ แกรไฟต์ ก่าอัตราส่วนกวามเข้มระหว่าง D peak และ G peak (I_D/I_G) มีก่าระหว่าง 0.63 – 0.69 ดัง แสดงในตารางที่ 3.1



ร**ูปที่ 3.2** รามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการไหลของ CH₄ แตกต่างกัน ภายใต้เงื่อนไขอุณหภูมิวัสคุฐาน 300°C และกำลังของคลื่นความถี่วิทยุ 100 วัตต์



ร**ูปที่ 3.3** รามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการไหล ของ CH₄ ที่ 5 sccm ที่กำลังคลื่นของความถี่วิทยุ 100 วัตต์



ร**ูปที่ 3.4** รามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรที่อัตราการไหล ของ CH4 ที่ 10 sccm ที่กำลังของกลื่นกวามถี่วิทยุ 100 วัตต์





ร**ูปที่ 3.6** รามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรที่อัตราการไหล ของ CH4 ที่ 20 sccm ที่กำลังของกลิ่นกวามถี่วิทยุ 100 วัตต์



ร**ูปที่ 3.7** รามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการไหล ของ CH₄ ที่ 50 sccm ที่กำลังของกลื่นความถี่วิทยุ 100 วัตต์

	D peak	G peak	Intensity
CH ₄ (sccm)	(cm ⁻¹)	(cm ⁻¹)	ratio (I_D/I_G)
5	0	0	0
10	1343.98	1583.96	0.66
15	1340.76	1586.51	0.63
20	1336.53	1583.06	0.69
50	1344.36	1584.37	0.66

ตารางที่ 3.1 แสดงตำแหน่ง Peak D, Peak G และ Intensity ratio (I_D/ I_G) ของฟิล์มคาร์บอนคล้าย เพชรที่อัตราการใหลของ CH₄ ต่างกัน และที่กำลังของคลื่นความถิ่วิทยุ 100 วัตต์

จากตารางที่ 3.1 เมื่อนำมาพล๊อตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของ D peak และ G peak กับ อัตราการ ใหลของ CH4 ดังแสดงในรูปที่ 3.8 พบว่า เมื่ออัตราการ ใหลของ CH4 เพิ่มขึ้น ตำแหน่งของ D peak และ G peak มีก่าก่อนข้างกงที่ และเมื่อนำสัดส่วนระหว่างกวามเข้มระดับ พลังงานระหว่าง D และ G (I_D/I_G) มาพล๊อตกราฟกับอัตราการ ใหลของ CH4 ดังแสดงในรูปที่ 3.9 พบว่า I_D/I_G มีก่ากงที่ที่ประมาณ 0.66 ที่ทุกอัตราการ ใหลของแก๊สมีเทน แสดงว่าหลังจากเกิดฟิล์ม
การ์บอนคล้ายเพชร ที่สัดส่วน CH₄/Ar มากกว่า 5/20 sccm แล้ว การเพิ่มสัดส่วนของแก๊สมีเทน ใม่ได้ส่งผลต่อลักษณะหรือสัดส่วน I_D/I_G ที่บ่งบอกถึงสัดส่วนของแกรไฟต์ที่เรียงตัวไม่เป็นระเบียบ (disorder graphite) ต่อสัดส่วนของแกรไฟต์แต่อย่างใด

ดังนั้นในการศึกษาขั้นต่อๆไปจะใช้สัดส่วน CH4/Ar ที่ 15/20 เพื่อให้มั่นใจว่าเกิดฟิล์ม การ์บอนกล้ายเพชรอย่างแน่นอน



รูป 3.8 ความสัมพันธ์ระหว่าง ตำแหน่งของ D Peak และ G Peak กับอัตราการใหล



ของ CH₄ ที่กำลังของคลื่นความถี่วิทยุ 100 วัตต์

ร**ูป 3.9** กราฟแสดงค่าอัตราส่วน Intensity ratio (I_D/I_G) กับอัตราการไหลของ CH₄ ที่กำลังของคลื่นความถี่วิทยุ 100 วัตต์

CH ₄ (sccm)	N ₂ (sccm)	RF (Watt)	Temp (°C)	Peak	Atomic conc %	Mass conc%
				Na 1s	4.33	7.68
5		100	100 300	O 1s	11.99	14.8
5	-	100		N 1s	-	-
				C 1s	83.68	77.53
				\rightarrow sp ²	63.01	
				\rightarrow sp ³	7.28	
				\rightarrow C=O	13.38	
				Na 1s	0.91	1.67
15	- 100	100	300	O 1s	11.43	14.55
15		100		N 1s	-	-
				C 1s	87.93	82.79
				\rightarrow sp ²	72.14	
				\rightarrow sp ³	7.54	
				\rightarrow C=O	7.97	

3.1.1.3. ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเอ๊กซ์เรย์โฟโตอิเล็กตรอนสเปคโตรสโคปี (XPS)

ตารางที่ 3.2 แสดงผลการวิเคราะห์ด้วยเทกนิก XPS



ร**ูปที่ 3.10** ผลการวิเคราะห์ XPS ของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่ อัตราการไหลของ CH₄ ที่ 5 sccm กำลังคลื่นความถี่วิทยุที่ 100 วัตต์ และ อุณหภูมิวัสคุฐาน 300°C



ร**ูปที่ 3.11** ผลการวิเคราะห์ XPS ของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่ อัตราการไหลของ CH₄ ที่ 15 sccm กำลังคลื่นความถี่วิทยุที่ 100 วัตต์ และ อุณหภูมิวัสคุฐาน 300°C

จากผล XPS ของฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรที่สังเกราะห์ที่ 5 sccm และ 15 sccm ดังแสดงใน ตารางที่ 3.1 และรูปที่ 3.10 - 3.11 พบว่าฟิล์มที่พบ Na 1 และ O 1s ซึ่งน่าจะเป็นร่องรอยลายนิ้วมือ หรือออกซิเจนที่บริเวณผิวเนื่องมาจากขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างในการวิเคราะห์ XPS ที่บริเวณ พื้นผิว และมีคาร์บอน 83.6% ซึ่งประกอบด้วย sp² เป็นหลัก โดยการเพิ่มสัดส่วนของแก๊สมีเทนจาก 5 sccm เป็น 15 sccm ทำให้สัดส่วน sp²/sp³ เพิ่มขึ้นจาก 8.6 เป็น 9.5 แสดงว่าการเพิ่มอัตราการไหล ของแก๊สมีเทนทำให้เกิดเฟส sp² ซึ่งก็คือแกรไฟต์ที่เพิ่มขึ้น

3.1.1.4. ผลการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (SEM)



รูปที่ 3.12 ความหนาของฟิล์ม DLC ที่อัตราการไหลของ CH₄ ที่ a.) 5 sccm b.) 10 sccm c.) 15 sccm d.) 20 sccm และ e.) 50 sccm



ร**ูปที่ 3.12 (ต่อ)** ความหนาของฟิล์ม DLC ที่อัตราการใหลของ CH₄ ที่ a.) 5 sccm b.) 10 sccm c.) 15 sccm d.) 20 sccm และ e.) 50 sccm

ส่วนผลจากการดูภาพตัดขวางของฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชร (รูปที่ 3.12) ซึ่งพบว่าฟิล์มที่ได้ มีลักษณะก่อนข้างแน่น (massive) และกวามหนาตั้งแต่ 165- 565 nm เนื่องจากฟิล์มที่นำมาทำการ วิเกราะห์ไม่ได้นำมาจากบริเวณเดียวกัน ทำให้กวามหนาที่ได้ไม่แน่นอน

3.1.2 ศึกษากำลังของคลื่นความถี่วิทยุที่เหมาะสมในการเกิด DLC ที่อุณหภูมิ 25°C และ 300 °C
3.1.2.1 ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี



ร**ูปที่ 3.13** ผลการวิเคราะห์ FTIR ของฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรที่กำลังของกลื่นความถี่แตกต่างกัน ภายใต้เงื่อนไขอัตราการไหลของ CH415 sccm อุณหภูมิวัสคุฐานที่อุณหภูมิ 25 °C

เมื่อคงสัคส่วนของ CH4/Ar ให้คงที่ ที่ 15/20 sccm และแปรผันกำลังของคลื่นความถี่วิทยุ จาก 50 –175 วัตต์ ที่อุณหภูมิ 25°C คังแสดงในรูปที่ 3.13 พบการสั่นของหมู่ฟังก์ชัน

> ในช่วงเลขคลื่น 1371 cm⁻¹ พบหมู่ฟังก์ชัน sp³ – CH₃ symmetric ในช่วงเลขคลื่น 1446 cm⁻¹ พบหมู่ฟังก์ชัน sp³ – CH₂ ในช่วงเลขคลื่น 1618 cm⁻¹ พบหมู่ฟังก์ชัน sp² C-C หรือ sp² C=C ในช่วงเลขคลื่น 2158 cm⁻¹ พบหมู่ฟังก์ชัน C=C ในช่วงเลขคลื่น 2870 cm⁻¹ พบหมู่ฟังก์ชัน sp³ – CH₃ symmetric หรือ sp³ – CH₂ symmetric ในช่วงเลขคลื่น 2920 cm⁻¹ พบหมู่ฟังก์ชัน sp³ – CH₂ asymmetric หรือ sp³ – CH ในช่วงเลขคลื่น 2949 cm⁻¹ พบหมู่ฟังก์ชัน sp³ – CH₃ asymmetric



ร**ูปที่ 3.14** ผลการวิเคราะห์ FTIR ของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่กำลังของคลื่นความถี่แตกต่างกัน ภายใต้เงื่อนไขอัตราการไหลของ CH₄ 15 sccm อุณหภูมิวัสคุฐานที่ 300°C

และเมื่อเพิ่มอุณหภูมิการทำปฏิกิริยาจากอุณหภูมิ 25°C เป็น 300°C พบหมู่ฟังก์ชันดังแสดง ในรูปที่ 3.14 ดังนี้ ในช่วงเลขคลื่น 1379 cm⁻¹ พบหมู่ฟังก์ชัน sp³ – CH₃ symmetric ในช่วงเลขคลื่น 1456 cm⁻¹ พบหมู่ฟังก์ชัน sp³ – CH₂ ในช่วงเลขคลื่น 1695 cm⁻¹ พบหมู่ฟังก์ชัน sp² C-C หรือ sp² C=C ในช่วงเลขคลื่น 2160 cm⁻¹ พบหมู่ฟังก์ชัน C=C ในช่วงเลขคลื่น 2870 cm⁻¹ พบหมู่ฟังก์ชัน sp³ – CH₃ symmetric หรือ sp³ – CH₂ symmetric ในช่วงเลขคลื่น 2925 cm⁻¹ พบหมู่ฟังก์ชัน sp³ – CH₂ asymmetric หรือ sp³ – CH ในช่วงเลขคลื่น 2927 cm⁻¹ พบหมู่ฟังก์ชัน sp³ – CH₂ asymmetric หรือ sp³ – CH ในช่วงเลขคลื่น 2937 cm⁻¹ พบหมู่ฟังก์ชัน sp³ – CH₃ asymmetric หรือ sp³ – CH₂

จากการสังเคราะห์ฟิล์มการ์บอนที่อุณหภูมิห้องและที่ 300°C พบว่าที่อุณหภูมิห้อง ฟิล์มจะ แสดงลักษณะหมู่ฟังก์ชันของฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรที่กำลังของกลื่นกวามถิ่วิทขุมากกว่า 75วัตต์ และเมื่อเพิ่มอุณหภูมิการทำปฏิกิริยาเป็น 300°C ลักษณะหมู่ฟังก์ชันของฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชร ปรากฏเด่นชัดตั้งแต่กำลังของกลื่นกวามถิ่วิทยุ 50 วัตต์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิช่วยเร่งปฏิกิริยา ในการเกิดฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชร

3.1.2.2 ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิครามานสเปกโตรสโคปี

จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี (FTIR) ของฟิล์มคาร์บอนคล้าย เพชรที่อัตราการไหลของแก๊สมีเทน 15 sccm อุณภูมิวัสดุฐานที่อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 300°C พบว่าที่อุณหภูมิ 300 °C นั้นเกิดพันธะระหว่าง C-H ในในช่วงเลขคลื่น 2800-3000 cm⁻¹ ซึ่งเป็น ลักษณะเฉพาะของการ์บอนคล้ายเพชรได้ดีกว่า จึงได้ทำการวิเคราะห์ด้วยเทคนิครามานสเปกโตรส โคปี เฉพาะฟิล์มที่สังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 300°C ดังแสดงในรูปที่ 3.15- 3.22



ร**ูปที่ 3.15** รามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่กำลังคลื่นความถี่วิทยุแตกต่างกัน อัตราการไหลของ CH₄ 15 sccm และ อุณหภูมิวัสคุฐาน 300 °C



ร**ูปที่ 3.16** รามานสเปก โตรส โคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 50 วัตต์ อัตราการไหลของ CH4 15 sccm และ อุณหภูมิวัสคุฐาน 300 °C



ร**ูปที่ 3.17** รามานสเปก โตรส โคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 75 วัตต์ และอัตราการไหลของ CH₄ 15 seem และ อุณหภูมิวัสคุฐาน 300 °C



ร**ูปที่ 3.18** รามานสเปก โตรส โคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 100 วัตต์ และอัตราการ ใหลของ CH₄ 15 sccm และ อุณหภูมิวัสคุฐาน 300 °C



ร**ูปที่ 3.19** รามานสเปก โตรส โคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 125 วัตต์ และอัตราการใหลของ CH₄ 15 sccm และ อุณหภูมิวัสดุฐาน 300 °C



ร**ูปที่ 3.20** รามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 150 วัตต์ และอัตราการไหลของ CH₄ 15 sccm และ อุณหภูมิวัสคุฐาน 300 °C



ร**ูปที่ 3.21** รามานสเปก โตรส โคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 175 วัตต์ และอัตราการใหลของ CH4 15 sccm และ อุณหภูมิวัสดุฐาน 300 °C



ร**ูปที่ 3.22** รามานสเปก โตรส โคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 200 วัตต์ และอัตราการใหลของ CH₄ 15 sccm และ อุณหภูมิวัสคุฐาน 300 °C

RF power	D peak	G peak	Intensity
(watt)	(cm ⁻¹)	(cm ⁻¹)	ratio (I_D/I_G)
50	1332.31	1585.25	0.87
75	1340.89	1583.62	0.71
100	1340.76	1586.51	0.63
125	1336.93	1581.21	0.68
150	1333.85	1586.32	0.74
175	1360.21	1581.71	0.70
200	1338.09	1585.79	0.72

ตารางที่ 3.3 ตำแหน่ง Peak D, Peak G และ Intensity ratio (I_D/I_G) ของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร ที่ กำลังคลื่นความถี่วิทยุต่างกัน ที่อัตราการไหลของ CH₄ 15 sccm และ อุณหภูมิวัสดุฐาน

300 °C



รูป 3.23 ความสัมพันธ์ระหว่าง ตำแหน่งของ D Peak และ G Peak กับกำลังคลื่นความถี่วิทยุ ที่อัตราการ ใหลของ CH4 15 seem และ อุณหภูมิวัสดุฐาน 300°C



ร**ูป 3.24** อัตราส่วน Intensity ratio (I_D/I_G) ที่อัตราการไหลของ CH₄ 15 sccm อุณหภูมิวัสคุฐาน 300°C ที่กำลังคลื่นความถี่วิทยุแตกต่างกัน

จากการวิเคราะห์ผลรามานสเปกโตรสโคปีของการศึกษาอิทธิพลของกำลังของคลื่นความถึ่ วิทยุที่แตกต่างกัน ที่ 50 75 100 125 150 175 และ 200 วัตต์ โดยควบคุมให้อุณหภูมิวัสคุฐานและ อัตราการไหลของ CH₄ ที่ 300°C และ 15 sccm ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 3.15 – 3.22 ซึ่งพบว่าทุก ช่วงกำลังของคลื่นความถึ่วิทยุจะพบพืคที่อยู่ในช่วงความยาวคลื่นที่ประมาณ 1100 cm⁻¹ ซึ่งพืกที่พบ ในช่วงนี้เป็นพืกของกระจกส ไลด์ และเมื่อทำการแยกสเปกตรัมหลัก (raw spectrum) ของแต่ละ ชิ้นงานออกเป็นสองเส้น โค้งแบบเกาส์เซียน (Gaussian curve fitting) จะพบยอคคลื่นของตำแหน่ง D peak และ G peak ที่ความยาวคลื่นในช่วง 1330 – 1360 cm⁻¹ และ 1580 – 1590 cm⁻¹ ค่าอัตราส่วน I_p/I_G มีก่าระหว่าง 0.63 – 0.87 ดังแสดงในตารางที่ 3.3

จากตารางที่ 3.3 เมื่อนำมาพถือตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของ D peak และ G peak กับ อัตราการ ใหลของ CH₄ ดังแสดงในรูปที่ 3.23 พบว่าตำแหน่งของ D peak มีแนวโน้มที่ เพิ่มขึ้นเมื่อกำลังของคลื่นความถิ่วิทยุเพิ่มขึ้น ส่วน G Peak ค่อนข้างคงที่ และเมื่อนำสัดส่วนระหว่าง ความเข้มระดับพลังงานระหว่าง D และ G (I_D/I_G) มาพล๊อตกราฟดังแสดงในรูปที่ 3.24 พบว่าค่า I_D/I_G มีแนวโน้มลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มกำลังของคลื่นความถิ่วิทยุที่ทำให้สารตั้งต้นแตก ตัวมีผลทำให้การเรียงตัวของแกรไฟต์ส่วนที่ไม่เป็นระเบียบลดลงหรือส่วนที่เป็นระเบียบเพิ่มขึ้น



3.1.2.3. ผลการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (SEM)

ร**ูป 3.25** ความหนาของฟิล์ม DLC ที่อัตราการใหลของ CH₄ ที่ 15 sccm อุณหภูมิ 300°C และกำลัง คลื่นความถี่วิทยุ a.) 50 W, b.) 75 W, c.) 125 W, d.) 150 W, e.) 175 W และ f.) 200 W

ส่วนผลจากการดูภาพตัดขวางของฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชร (รูปที่ 3.25) ซึ่งพบว่าฟิล์มที่ได้ มีลักษณะค่อนข้างแน่น (massive) และความหนาตั้งแต่ 120- 395 nm ซึ่งเมื่อกำลังของคลื่นความถี่ วิทยุเพิ่มขึ้นความหนาของฟิล์มที่ได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วย

3.1.3. สรุปผลการศึกษาตัวแปรเบื้องต้นในการสังเคราะห์สารเคลือบฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร

จากการศึกษาเบื้องต้นเพื่อหาสัดส่วน CH4 ที่เหมาะสมในการเกิดฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร โดยการแปรผันอัตราการไหลของ CH4 จาก 5- 50 seem โดยให้อัตราการไหลของอาร์กอนคงที่ ที่ 20 seem กำลังของคลื่นความถี่วิทยุ 100 วัตต์ และอุณหภูมิ 300°C พบว่าจะเกิดฟิล์มคาร์บอนคล้าย เพชรที่อัตราการไหลของ CH4 มากกว่า 5 seem ซึ่งในการทคลองต่อๆไปจะใช้ที่ 15 seem เพื่อความ มั่นใจในการเกิดฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร

นอกจากนี้ได้ทดลองแปรผันก่ากำลังของกลื่นกวามถี่วิทยุจาก 50-200 วัตต์ พบว่าเกิดฟิล์ม การ์บอนกล้ายเพชรที่ทุกกำลังและการเพิ่มกำลังของกลื่นกวามถี่วิทยุทำให้ฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชร ที่ได้มีสัดส่วนของแกรไฟต์และการ์บอนที่เรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบเพิ่มขึ้น และยังพบอีกว่าการ เพิ่มอุณหภูมิการทำปฏิกิริยาเกิดฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรได้ง่ายขึ้น ซึ่งทำให้สามารถสรุปเงื่อนไขใน การสังเกราะห์ฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรเพื่อใช้ในการศึกษาการโด๊ปด้วยในโตรเจนต่อไปได้ดังนี้

- 1. สัคส่วนของ CH4/Ar คือ 15/20 sccm
- 2. กำลังของคลื่นความถี่วิทยุ 100 วัตต์ หรือมากกว่า
- 3. อุณภูมิวัสคุฐานที่ใช้อยู่ที่ 300°C

3.2 การศึกษาการอิทธิพลของธาตุในโตรเจนที่มีผลต่อการสังเคราะห์ฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร
 3.2.1 ศึกษาสัดส่วนของแก๊สในโตรเจนที่เหมาะสมที่กำลังของคลื่นความถี่วิทยุ 100 วัตต์
 3.2.1.1 ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี



ร**ูปที่ 3.26** ผลการวิเคราะห์ FTIR ของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรอัตราการไหลของ N₂ แตกต่างกัน ภายใต้เงื่อนไขของอัตราการไหลของ CH₄ 15 sccm กำลังของคลื่นความถี่วิทยุ 100 วัตต์ อุณหภูมิวัสดุฐานที่ 300°C

ผลการวิเคราะห์ฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรด้วยเทคนิค FTIR จากการศึกษาอิทธิพลของอัตรา การใหลของ N₂ แตกต่างกัน ภายใต้เงื่อนไขของอัตราการไหลของ CH₄ 15 sccm กำลังของคลื่น ความถี่วิทยุ 100 วัตต์ อุณหภูมิวัสคุฐานที่ 300°C คังแสดงในรูปที่ 3.26 พบการสั่นของหมู่ฟังก์ชัน

> ในช่วงเลขคลื่น 1371 cm⁻¹ พบหมู่ฟังก์ชัน sp³ – CH₃ symmetric ในช่วงเลขคลื่น 1444 cm⁻¹ พบหมู่ฟังก์ชัน sp³ – CH₂ ในช่วงเลขคลื่น 1616 cm⁻¹ พบหมู่ฟังก์ชัน C=C หรือ C=N ในช่วงเลขคลื่น 2160 cm⁻¹ พบหมู่ฟังก์ชัน C=C หรือ C=N ในช่วงเลขคลื่น 2852 cm⁻¹ พบหมู่ฟังก์ชัน sp³ – CH₂ symmetric ในช่วงเลขคลื่น 2922 cm⁻¹ พบหมู่ฟังก์ชัน sp³ – CH₂ asymmetric หรือ sp³ – CH ในช่วงเลขคลื่น 2966 cm⁻¹ พบหมู่ฟังก์ชัน sp² – CH₂ symmetric หรือ sp³ – CH₃ asymmetric

ซึ่งพบว่าใกล้เคียงกับฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรที่ไม่ได้โค๊ปไนโตรเจนในหัวข้องที่ 3.1.1

3.2.1.2 ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิครามานสเปกโตรสโคปี

เมื่อนำฟิล์มการ์บอนกล้าเพชรที่สังเกราะห์ได้มาวิเกราะห์ด้วยเทกนิกรามานสเปกโตรสโก ปีได้ผลดังแสดงในรูปที่ 3.27 -3.36 โดยมีพึก D และ G ในช่วง 1360 และ 1580 cm⁻¹ ตามลำดับ



ร**ูปที่ 3.27** รามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการไหลของ N₂ ที่แตกต่างกัน และที่อัตราการไหลของ CH₄ 15 sccm กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 100 วัตต์





ร**ูปที่ 3.29** รามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการไหลของ N₂ ที่ 5 sccm และที่อัตราการไหลของ CH₄ 15 sccm กำลังคลื่นความถี่วิทยุ100 วัตต์



ร**ูปที่ 3.30** รามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการไหลของ N₂ ที่ 7 sccm และที่อัตราการไหลของ CH₄ 15 sccm กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 100 วัตต์



ร**ูปที่ 3.31** รามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการไหลของ N₂ ที่ 10 sccm และที่อัตราการไหลของ CH₄ 15 sccm กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 100 วัตต์



ร**ูปที่ 3.32** รามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการไหลของ N₂ ที่ 12 sccm และที่อัตราการไหลของ CH₄ 15 sccm กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 100 วัตต์



ร**ูปที่ 3.33** รามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการไหลของ N₂ ที่ 15 sccm และที่อัตราการไหลของ CH₄ 15 sccm กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 100 วัตต์



ร**ูปที่ 3.34** รามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการไหลของ N₂ ที่ 20 sccm และที่อัตราการไหลของ CH₄ ที่ 15 sccm กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 100 วัตต์



ร**ูปที่ 3.35** รามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการไหลของ N₂ ที่ 25 sccm และที่อัตราการไหลของ CH₄ 15 sccm กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 100 วัตต์



ร**ูปที่ 3.36** รามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการไหลของ N₂ ที่ 50 secm และที่อัตราการไหลของ CH₄ 15 secm กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 100 วัตต์

ตารางที่ 3.4 ตำแหน่ง Peak D, Peak G และ Intensity ratio (I_D/ I_G) ของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร ที่อัตราการไหลของ N₂ แตกต่างกัน ที่อัตราการไหลของ CH₄ 15 secm ที่กำลังคลื่น ความถี่วิทยุ 100 วัตต์

	D peak	G peak	T /T	
$N_2(sccm)$	(cm ⁻¹)	(cm^{-1})	$\mathbf{I}_{\mathrm{D}}/\mathbf{I}_{\mathrm{G}}$	
0	1340.76	1586.51	0.63	
5	1365.39	1577.81	0.81	
7	1365.33	1581.74	0.99	
10	1361.66	1588.40	1.03	
12	1366.08	1582.28	1.02	
15	1364.11	1583.22	0.96	
20	1364.43	1581.95	1.05	
25	1362.84	1587.68	1.11	
50	1363.33	1584.56	1.06	



ร**ูป 3.37** ความสัมพันธ์ระหว่าง ตำแหน่งของ D Peak และ G Peak กับอัตราการใหลของ N₂ ที่ต่างกัน และที่อัตราการใหลของ CH₄ 15 sccm กำลังคลื่นความถิ่วิทยุ 100 วัตต์



ร**ูป 3.38** อัตราส่วน Intensity ratio (I_D/I_G) กับอัตราการไหลของ N_2 ที่ต่างกัน และที่อัตราการไหลของ CH_4 15 sccm กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 100 วัตต์

จากการวิเคราะห์ผลรามานสเปกโตรสโคปีของการศึกษาอิทธิพลของอัตราการใหลของ N₂ ที่แตกต่างกัน ที่ 0 5 7 10 12 15 20 25 และ 50 sccm โดยควบคุมให้อุณหภูมิวัสคุฐาน 300°C อัตรา การใหลของ CH4 ที่ 15 sccm และกำลังของคลื่นความถี่วิทยุที่ 100 วัตต์ ดังแสดงในรูปที่ 3.27 – 3.36 และเมื่อทำการแขกสเปกตรัมหลัก (raw spectrum) ของแต่ละชิ้นงานออกเป็นสองเส้นโค้งแบบเกาส์ เชียน (Gaussian curve fitting) จะพบขอดคลื่นของตำแหน่ง D peak และ G peak ที่ความขาวคลื่น ในช่วง 1340 – 1370 cm⁻¹ และ 1575 – 1590 cm⁻¹ ค่าอัตราส่วน I_D/I_G มีค่าระหว่าง 0.63 – 1.11 ดัง แสดงในตารางที่ 3.4

จากตารางที่ 3.4 เมื่อนำมาพล๊อตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของ D peak และ G peak กับ อัตราการ ใหลของ N₂ ดังแสดงในรูปที่ 3.37 พบว่าตำแหน่งของ D peak และ G peakมี แนวโน้มคงที่เมื่ออัตราการ ใหลของ N₂ เพิ่มขึ้น แต่เมื่อนำสัดส่วนระหว่างความเข้มระดับพลังงาน ระหว่าง D และ G (I_D/I_G) มาพล๊อตกราฟดังแสดงในรูปที่ 3.38 พบว่าค่า I_D/I_G มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่ง บ่งบอกว่าฟิล์มที่ได้มีสัดส่วนของเฟสการ์บอนที่เรียงตัวไม่เป็นระเบียบเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เป็นผลมาจาก การเติมแก๊ส ในโตรเจนเพิ่มเข้าไปในระบบ ซึ่งส่งผลให้ความดันในห้องปฏิกิริยา (Chamber) เพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีผลทำให้พลังงานในการเรียงตัวของอะตอมลดลง ทำให้ส่วนที่เรียงตัวไม่เป็นระเบียบเพิ่มขึ้น

3.2.1.3. ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเอ๊กซ์เรย์โฟโตอิเล็กตรอนสเปคโตรสโคปี (XPS)

CH ₄	N ₂	RF	Temp	Peak	Atomic	Mass
(sccm)	(sccm)	(Watt)	(°C)		conc %	conc%
				Na 1s	4.33	1.42
15	15	5 100	300	O 1s	11.99	15.9
15	13			N 1s	10.03	10.97
				C 1s	76.47	71.71
				\rightarrow sp ²	49.47	
				\rightarrow sp ³	19.65	
				\rightarrow C=O	7.34	

ตารางที่ 3.5 แสดงผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XPS



ร**ูปที่ 3.39** ผลการวิเคราะห์ XPS ของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่ อัตราการไหลของ CH₄ ที่ 15 sccm N₂ ที่ 15 sccm กำลังคลื่นความถี่วิทยุที่ 100 วัตต์ และ อุณหภูมิวัสคุฐาน 300°C

จากผลการวิเคราะห์ XPS ทำให้ทราบว่าเมื่อเพิ่มอัตราการไหลของ N₂ เข้าไปในระบบ ซึ่ง จะทำให้ในฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชรจะในโตรเจนเป็นองก์ประกอบของฟิล์ม แต่ไม่ปรากฏพันธะ ระหว่าง C กับ N ดังที่ได้แสดงในผล FTIR ซึ่งอาจจะทำให้สรุปได้ว่า N ที่ได้อยู่ในรูปอิสระ และที่ สำคัญการเพิ่ม N จะทำให้สัดส่วน sp³ เพิ่มขึ้นจาก 7.5 at % (ตารางที่ 3.2) เป็น 19.6 at % (ตารางที่ 3.5) คาดว่า N จะไปช่วยเสริมการเกิด sp³

3.2.2 ศึกษาสัดส่วนของแก๊สในโตรเจนที่เหมาะสมที่กำลังของคลื่นความถี่วิทยุ 200 วัตต์



3.2.2.1 ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี



จากผลการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันด้วย FTIR (รูปที่ 3.26) ยังไม่ปรากฏหมู่ฟังก์ชันระหว่าง C และ N ซึ่งกาดว่าน่าจะเกิดจากกำลังของกลื่นความถี่วิทยุไม่เพียงพอ จึงได้เพิ่มกำลังของกลื่นความถี่ วิทยุจาก 100 วัตต์ เป็น 200 วัตต์ แล้วทดลองแปรผันอัตราการไหลของ N₂ จาก 5-50 sccm

ผลการวิเคราะห์ฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรด้วยเทคนิก FTIR จากการศึกษาอิทธิพลของอัตรา การใหลของ N₂ แตกต่างกัน ภายใต้เงื่อนไขของอัตราการใหลของ CH₄ 15 sccm กำลังของคลื่น ความถี่วิทยุ 200 วัตต์ อุณหภูมิวัสคุฐานที่ 300°C ดังแสดงในรูปที่ 3.40 พบการสั่นของหมู่ฟังก์ชัน

> ในช่วงเลขคลื่น 1616 cm⁻¹ พบหมู่ฟังก์ชัน C=N ในช่วงเลขคลื่น 2063 cm⁻¹ พบหมู่ฟังก์ชัน C=N ในช่วงเลขคลื่น 2852 cm⁻¹ พบหมู่ฟังก์ชัน sp³ – CH₂ symmetric ในช่วงเลขคลื่น 2922 cm⁻¹ พบหมู่ฟังก์ชัน sp³ – CH₂ asymmetric หรือ sp³ – CH ในช่วงเลขคลื่น 2952 cm⁻¹ พบหมู่ฟังก์ชัน sp² – CH₂ symmetric หรือ sp³ – CH₃ asymmetric

3.2.2.2 ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิครามานสเปกโตรสโคปี

ในการทดลองครั้งนี้ได้ทำการสังเคราะห์ฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชร ภายใต้อัตราการไหลของ N₂ ที่ 0 5 7 10 12 15 20 25 และ 50 sccm โดยใช้กำลังของกลื่นกวามถี่วิทยุ 200 วัตต์ อุณหภูมิวัสดุ ฐาน 300°C และวิเคราะห์ด้วยเทคนิกรามานสเปกโตรสโกปีดังแสดงในรูปที่ 3.41 -3.50 โดยมีพีก D และ G ในช่วง 1360 และ 1580 cm⁻¹ ตามลำดับ



ร**ูปที่ 3.41** รามานสเปก โตรส โคปีของฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการ ไหลของ N₂ ที่แตกต่างกัน และที่อัตราการ ไหลของ CH₄ 15 sccm กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 200 วัตต์



และที่อัตราการไหลของ CH4 15 sccm กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 200 วัตต์



ร**ูปที่ 3.43** รามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการไหลของ N₂ ที่ 5 sccm และที่อัตราการไหลของ CH₄ 15 sccm กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 200 วัตต์



ร**ูปที่ 3.44** รามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการไหลของ N₂ ที่ 7 sccm และที่อัตราการไหลของ CH₄ ที่ 15 sccm กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 200 วัตต์



ร**ูปที่ 3.45** รามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการไหลของ N₂ ที่ 10 sccm และที่อัตราการไหลของ CH₄ 15 sccm กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 200 วัตต์



ร**ูปที่ 3.46** รามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการไหลของ N₂ ที่ 12 sccm และที่อัตราการไหลของ CH₄ 15 sccm กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 200 วัตต์



ร**ูปที่ 3.47** รามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการไหลของ N₂ ที่ 15 secm และที่อัตราการไหลของ CH₄ 15 secm กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 200



ร**ูปที่ 3.48** รามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการไหลของ N₂ ที่ 20 sccm และที่อัตราการไหลของ CH₄ 15 sccm กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 200 วัตต์



ร**ูปที่ 3.49** รามานสเปกโตรสโคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการไหลของ N₂ ที่ 25 sccm และที่อัตราการไหลของ CH₄ 15 sccm กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 200 วัตต์



ร**ูปที่ 3.50** รามานสเปก โตรส โคปีของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการ ไหลของ N_2 ที่ 50 sccm และที่อัตราการ ไหลของ CH₄ ที่ 15 sccm กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 200 วัตต์

ตารางที่ 3.6 ตำแหน่ง Peak D, Peak G, I_D, I_G และ Intensity ratio (I_D/I_G) ของฟิล์มคาร์บอนคล้าย เพชรที่อัตราการไหลของ N₂ แตกต่างกัน ที่อัตราการไหลของ CH₄ 15 seem ที่กำลัง คลื่นความถี่วิทยุ 200 และที่อุณหภูมิวัสคุฐาน 300°C

	D peak	G peak	т /т
$N_2(sccm)$	(cm^{-1})	(cm^{-1})	$\mathbf{I}_{\mathrm{D}}/\mathbf{I}_{\mathrm{G}}$
0	1340.76	1586.51	0.63
5	1357.88	1581.85	0.94
7	1364.78	1582.50	0.83
10	1359.10	1568.62	1.14
12	1362.26	1576.25	0.85
15	1359.31	1572.03	1.08
20	1359.81	1575.92	0.91
25	1359.21	1578.54	1.04
50	1361.14	1575.14	1.09



ร**ูป 3.51** ความสัมพันธ์ระหว่าง ตำแหน่งของ D Peak และ G Peak กับอัตราการไหลของ N₂ ที่ต่างกัน และที่อัตราการไหลของ CH₄ 15 seem กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 200 วัตต์



รูป 3.52 อัตราส่วน Intensity ratio (I_D/I_G) กับอัตราการไหลของ N_2 ที่ต่างกัน และที่อัตราการไหลของ CH_4 15 sccm กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 200 วัตต์

จากการวิเคราะห์ผลรามานสเปกโตรสโคปีของการศึกษาอิทธิพลของอัตราการใหลของ N₂ ที่แตกต่างกัน ที่ 0 5 7 10 12 15 20 25 และ 50 sccm โดยควบคุมให้อุณหภูมิวัสดุฐาน 300°C อัตราการใหลของ CH₄ ที่ 15 sccm และกำลังของคลื่นความถี่วิทยุที่ 200 วัตต์ ดังแสดงในรูปที่ 3.41 – 3.50 และเมื่อทำการแยกสเปกตรัมหลัก (raw spectrum) ของแต่ละชิ้นงานออกเป็นสองเส้นโด้ง แบบเกาส์เซียน (Gaussian curve fitting) จะพบยอดคลื่นของตำแหน่ง D peak และ G peak ที่ความ ยาวคลื่นในช่วง 1340 – 1365 cm⁻¹และ 1570 – 1590 cm⁻¹ค่าอัตราส่วน I_D/I_G มีค่าระหว่าง 0.63 – 1.14 ดังแสดงในตารางที่ 3.6

จากตารางที่ 3.6 เมื่อนำมาพล๊อตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของ D peak และ G peak กับ อัตราการไหลของ N₂ ดังแสดงในรูปที่ 3.51 พบว่าตำแหน่งของ D peak และ G peak ที่คงที่ เมื่ออัตราการไหลของ N₂ เพิ่มขึ้น และเมื่อนำสัดส่วนระหว่างความเข้มระดับพลังงานระหว่าง D และ G (I_D/I_G) มาพล๊อตกราฟดังแสดงในรูปที่ 3.52 พบว่าค่า I_D/I_G มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งน่าจะเกิดมา จากเหตุผลเดียวกันที่ได้แสดงไว้ในหัวข้อ 3.2.1.2

3.2.2.3. ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเอ๊กซ์เรย์โฟโตอิเล็กตรอนสเปคโตรสโคปี (XPS)

CH ₄	N_2	RF	Temp	Peak	Atomic	Mass
(sccm)	(sccm)	(Watt)	(°C)		conc %	conc%
				Na 1s	-	-
15	15	200	300	O 1s	14.29	17.89
15	13	200		N 1s	9.93	10.88
				C 1s	75.78	71.22
				\rightarrow sp ²	16.14	
				\rightarrow sp ³	39.02	
				\rightarrow C=O	20.53	

ตารางที่ 3.7 แสดงผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XPS



ร**ูปที่ 3.53** ผลการวิเคราะห์ XPS ของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่ อัตราการไหลของ CH₄ ที่ 15 sccm N₂ ที่ 15 sccm กำลังคลื่นความถี่วิทยุที่ 200 วัตต์ และ อุณหภูมิวัสคุฐาน 300°C

จากผลการวิเคราะห์ XPS พบว่าการเพิ่ม N₂ และกำลังคลื่นความถี่วิทยุ 200 วัตต์ ทำให้ สัดส่วน sp³ เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยจะมี sp³ 39 at % ซึ่งมากกว่าฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร ที่ สังเคราะห์ที่เงื่อนไขเดียวกัน แต่ใช้กำลังของคลื่นความถี่วิทยุที่ 100 วัตต์ (มีสัดส่วน sp³ ที่ 19.6 at %) และฟิล์มที่ไม่ได้โด๊ป N₂ (มีสัดส่วน sp³ ที่ 7.5 at %) ซึ่งแสดงให้เห็นว่านอกจากสัดส่วน sp³ จะ เพิ่มขึ้นตาม N₂ ที่เพิ่มขึ้นแล้วยังเพิ่มตามกำลังของคลื่นความถี่วิทยุอีกด้วย



3.2.2.4. ผลการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (SEM)





รูป 3.54 ความหนาของฟิล์ม DLC ที่อัตราการไหลของ CH_4 ที่ 15 sccm อุณหภูมิ 300°C กำลังคลื่นความถี่วิทยุ200 วัตต์ และอัตราการไหลของ N_2 ที่ a.) 5 sccm, b.) 10 sccm, c.) 15 sccm, d.) 20 sccm, e.) 25 sccm และ f.) 50 sccm
จากผล SEM พบว่าการเพิ่มอัตราการใหลของ N₂ ที่กำลังของคลื่นความถิ่วิทยุที่ 200 วัตด์ ทำให้ฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่สังเคราะห์ได้ค่อยๆเปลี่ยนจากแน่น (Massive) ไปเป็นโครงสร้าง แบบคอลัมนา (Columnar) โดยเมื่ออัตราการใหลของ N₂ เท่ากับ 25 seem ฟิล์มที่ได้มีโครงสร้างเป็น แบบแท่ง (Nano-rod) ชัคเจน ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่าโครงสร้างที่สังเคราะห์ได้อาจจะเป็น Carbon nanotube ทั้งนี้ควรจะต้องศึกษาในรายละเอียดต่อไปในอนาคต ทั้งนี้การเปลี่ยนโครงสร้างคังกล่าว เกิดจากการเพิ่มความคันเนื่องจากการเติม N₂ ตามลักษณะของ Thornton diagram (A. Anders, 2010)

3.2.3 สรุปผลการศึกษาการอิทธิพลของธาตุในโตรเจนที่มีผลต่อการสังเคราะห์ฟิล์มคาร์บอนคล้าย เพชร

ในการสังเคราะห์ฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชรโดยการเติมในโตรเจนเพื่อศึกษาอิทธิพลอัตรา การใหลของ N₂ และจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิครามานพบว่าที่กำลังของคลื่นความถิ่วิทยุ 100 และ 200 วัตต์ ก่า I_D/I_G มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราการไหลของ N₂เพิ่มขึ้น แสดงแสดงถึงการเพิ่มขึ้น ของการ์บอนที่มีโครงสร้างไม่เป็นระเบียบลคลงซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Shengyin Li และ กณะ(2009) และ Huayu Zhang และกณะ(2007) ซึ่งได้อธิบายว่าเมื่ออัตราการไหลของ N₂ ที่เพิ่มขึ้น ไปทำหน้าที่ลดความเข้มข้นของ CH₄ ในระบทำให้การเรียงตัวเป็นระเบียบของการ์บอนลคลง

จากการวิเคราะห์อินฟราเรคสเปกโตรสโคปีของฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรที่ทำการเดิมธาตุ ในโตรเจนจากแก๊สไนโตรเจนที่อุณหภูมิวัสดุฐาน 300°C และที่กำลังของกลื่นความถิ่วิทยุที่ 100 และ 200 วัตต์ ดังแสดงในรูปที่ 3.26 และ 3.39 ตามลำดับ พบว่าที่กำลังของกลื่นความถิ่วิทยุที่ 100 วัตต์ เกิดพันธะระหว่าง C-H สังเกตได้จากพีกในช่วงเลขกลื่น 2800-3000 cm⁻¹ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ ของการ์บอนกล้ายเพชรมีลักษะแหลมกว่าเมื่อเทียบกับพีกที่กำลังของกลื่นความถิ่วิทยุที่ 200 วัตต์ ในช่วงเลขกลื่นเดียวกัน และในช่วงกลื่นความถิ่ 2000-2200 cm⁻¹ เป็นช่วงที่เกิดพันธะระหว่าง C=C หรือ C=N ซึ่งในช่วงเลขกลื่นนี้เป็นช่วงที่พันธะ C=C และ C=N ซ้อนทับกันทำให้แยกได้ยากว่า เป็นพันธะระหว่าง C=C หรือ C=N กันแน่ แต่เมื่อพิจารณาที่กำลังของกลื่นความถิ่วิทยุที่ 100 วัตต์ พบว่าลักษณะพีกในช่วงเลขกลื่น 2000-2200 cm⁻¹ มีลักษณะเช่นเดียวกันกับพีล์มการ์บอนกล้ายเพชร ที่ไม่ได้ทำการเจือธาตุในโตรเจน คือที่ภายใต้เรื่อนไขการเปลี่ยนแปลงกำลังของกลื่นความถิ่วิทยุที่ อัตราการใหลของแก๊สมีเทน 15 sccm ที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิ 300°C ดังแสดงในรูปที่ 3.1 3.13 และ 3.14 ตามลำดับ แต่ที่กำลังของกลื่นความถี่วิทยุ 200 วัตต์ ลักษณะของพืกในช่วงเลขกลื่น 2000-2200 cm⁻¹ มีลักษณะเปลี่ยนไป ดังแสดงในรูปที่ 3.40 พืกที่แสดงถึงพันธะระหว่าง C≡N มีลักษณะ เด่นชัดขึ้นเมื่อเทียบกับที่กำลังของกลื่นความถี่วิทยุที่ 100 วัตต์

จากการศึกษาถึงอิทธิพลของการเติมธาตุในโตรเจนในฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรพอจะสรุป ใด้ว่า ที่อัตราการใหลของแก๊สในโตรเจนที่สูงขึ้นทำให้สัคส่วน พันธะ C-H ในช่วงเลขคลื่น 2800-3000 cm⁻¹ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของคาร์บอนคล้ายเพชรลคลง เนื่องจากไอออนของคาร์บอน บางส่วนเกิดปฏิกิริยากับไอออนของในโตรเจน เกิดเป็นพันธะระหว่าง C-N ในช่วงเลขคลื่น 2000-2200 cm⁻¹ และ เมื่อกำลังของคลื่นความถี่วิทยุเพิ่มขึ้นจาก 100 วัตต์เป็น 200 วัตต์ พีคของพันธะ C-N ปรากฏเด่นชัดขึ้น

จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิครามานสเปกโตรสโคปีพบว่าเมื่อทำการเติมธาตุในโตรเจนเข้า ใปในฟิล์มคาร์บอนพบว่า ค่า I_D/I_G มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับฟิล์มคาร์บอนที่ไม่ได้เติมธาตุในโตรเจน ทั้งที่กำลังของคลื่นความถี่วิทยุที่ 100 ดังแสดงตารางที่ 3.4 และรูปที่ 3.38 และที่กำลังของคลื่น ความถี่วิทยุ 200 วัตต์ดังแสดงในตารางที่ 3.6 และ รูปที่ 3.52 พบว่าเมื่ออัตราการไหลของแก๊ส ในโตรเจนเพิ่มขึ้น ค่า I_D/I_G มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งแสดงถึงสัดส่วนโครงสร้างคาร์บอนที่เรียงตัวไม่ เป็นระเบียบมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลของการวิเคราะห์อินฟราเรคสเปกโตรสโคปีที่สัดส่วนของ ความเป็นการ์บอนคล้ายเพชรที่ลดลง นอกจากนั้นผลการวิเกราะห์ XPS แสดงให้เห็นว่าการเพิ่ม ในโตรเจนเข้าไปในระบบทำให้สัดส่วน sp³ เพิ่มขึ้นและ sp² ลดลง ดังนั้นการเติมไนโตรเจนจะทำ ให้โครงสร้างเป็นระเบียบลดลงแต่ทำให้ได้โครงสร้าง sp³ เพิ่มขึ้น

จากข้อมูลในตารางที่ 3.1 3.3 3.4 และ3.6 ก่า I_p/I_G ต่ำสุดที่ 0.63 และเมื่อนำไปเทียบกับ งานวิจัยของ Robertson (2002) พบว่าฟิล์มที่มีอัตราส่วน $I_p/I_G \sim 0.6$ -0.9 มีสัดส่วนโครงสร้าง sp^3 ที่ ประมาณ 40-50% ดังแสดงในตารางที่ 1.1 แต่อย่างไรก็ตามโครงสร้างแบบ sp^3 ที่ได้จากกอัตราส่วน I_p/I_G ไม่ได้หมายถึงโครงสร้างแบบ sp^3 ระหว่างการ์บอนเท่านั้น ซึ่งอาจจะเป็น $sp^3 - CH_2$ หรือ $sp^3 - CH$ เป็นต้น ซึ่งต่างจากอัตราส่วน I_p/I_G ที่ได้จากการวิเคราะห์รามานสเปกโตรสโคปีจากฟิล์ม ประเภทเตตระฮิดรอลอะมอร์ฟิสการ์บอน (ta-C) ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ฟิล์มที่สังเคราะห์ได้ไม่ได้มี ความแข็งมากนักแม้จะมีโครงสร้างแบบ sp^3 สูงก็ตาม

3.3 ผลการวิเคราะห์สมบัติเชิงกลของฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชร

3.3.1 ผลการวิเคราะห์ความแข็ง

จากการวิเคราะห์ความแข็งของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรภายใต้เงื่อนไขอัตราการไหลของ N₂ ต่างกัน ที่อัตราการไหลของ CH₄ 15 sccm กำลังของคลื่นความถี่วิทยุ 200 วัตต์ และอุณหภูมิวัสดุ ฐาน 300°C ด้วยเทคนิคนาโนอินเดนเทชัน ดังแสดงในตารางที่ 3.7 พบว่าความแข็งของฟิล์ม คาร์บอนคล้ายเพชรที่ทำการเจือธาตุในโตรเจนนั้นให้ค่าความแข็งที่สูงกว่าฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร ที่ไม่ได้ทำการเจือธาตุในโตรเจน เมื่อเทียบกับชิ้นงานเหล็ก H13 ที่ไม่ได้ทำการเคลือบฟิล์มคาร์บอน กล้ายเพชร ซึ่งให้ความแข็งอยู่ที่ 3.38 GPa (ณัฐพงศ์, 2555) ซึ่งจากตารางที่ 1.1 แสดงให้เห็นว่าที่ สัดส่วน sp³ 40% ความแข็งที่ได้มีก่าอยู่ในช่วง 10-20 GPa ซึ่งจากผล XPS พบว่าการโด๊ปไนโตรเจน จำทำให้สัดส่วน sp³ ซึ่งเป็นเฟสที่ส่งผลให้ฟิล์มที่ได้มีความแข็งเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 3.7 ค่าความแข็งของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการไหลของ № แตกต่างกัน และ ควบคุมอัตราการไหลของ CH4 ที่ 15 seem กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 200 วัตต์ อุณหภูมิ วัสคุฐาน 300°C

N ₂ (sccm)	CH ₄ (sccm)	RF (Watt)	Temp (°C)	Hardness (GPa)
0	15	200	300	4.9
5	15	200	300	5.5
10	15	200	300	2.3
15	15	200	300	12.1
20	15	200	300	3.0
25	15	200	300	12.1
50	15	200	300	3.0

จากตารางที่ 3.7 สามารถนำมาพล๊อตกราฟระหว่างความแข็งกับอัตราการไหลของ N₂ ที่ แตกต่างกัน ดังแสดงในรูปที่ 3.55 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าที่อัตราการไหลของ N₂ ที่ 15 sccm มีค่าความ แข็งมากที่สุด



ร**ูปที่ 3.55** ความแข็งของฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรที่อัตราการไหลของ N₂ ที่แตกต่างกัน ที่อัตราการ ใหลของ CH₄ 15 sccm กำลังกลื่นความถี่วิทยุ 200 วัตต์ อุณหภูมิวัสดุฐาน 300°C

3.3.2 ผลการวิเคราะห์แรงยึดเกาะ

การทดสอบสมบัติการเกาะยึด (Adhesion Strength) ของผิวเคลือบ โดยใช้เครื่อง Scratch testing machine เพื่อใช้เป็นตัวช่วยบอกรูปแบบการเสียหายของผิวเคลือบภายใต้แรงกดต่างๆ และ ความสามารถในการเกาะยึดระหว่างผิวเคลือบกับวัสดุพื้น ในการทดสอบจะเป็นการกำหนดให้เพิ่ม แรงกดแบบเพิ่มขึ้น โดยที่ แรงเริ่มด้น (Begin load) เท่ากับ 0.99 N แรงระยะสุดท้าย (End load) เท่ากับ 99.99 N ความเร็วในการเคลื่อนที่เท่ากับ 10.09 mm/min และระยะทางเท่ากับ 10 mm โดยทำ การวิเคราะห์พฤติกรรมการเสียหายของฟิล์มประกอบด้วย แรงกดเริ่มด้น แรงกดที่ทำให้ผิวเคลือบ เกิดการแตกและหลุดลอก (Lc1, Lc2) ซึ่งฟิล์มต่างเงื่อนไขการสังเคราะห์ให้ค่าแรงกดที่ทำให้ฟิล์ม เสียหายต่างกัน ซึ่งการวิเคราะห์แรงยึดเกาะของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการไหลของ N₂ ต่างกัน อัตราการไหลของ CH₄ 15 secm กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 200 วัตต์ ด้วยเทคนิก scratch test แสดงในรูปที่ 3.56



ร**ูปที่ 3.56** ความแข็งแรงของการยึดเกาะของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่ ควบคุมอัตราการไหลของ CH₄ ที่ 15 sccm กำลังคลื่นความถิ่วิทยุ 200 วัตต์ อุณหภูมิวัสดุฐาน 300°C โดยอัตราการ ไหลของ N₂ ที่แตกต่างกัน (A) 0 sccm (B) 5 sccm (C) 10 sccm (D) 15 sccm (E) 20 sccm (F) 25 sccm และ (G) 50 sccm

ตารางที่ 3.8 ค่าแรงที่ใช้ในการทคสอบความแข็งแรงในการยึดเกาะของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่ อัตราการใหลของ № แตกต่างกัน และควบคุมอัตราการใหลของ CH4 ที่ 15 sccm กำลัง คลื่นความถี่วิทยุ 200 วัตต์ อุณหภูมิวัสคุฐาน 300°C

			N_2 (sccm)				
Load (N)	0	5	10	15	20	25	50
LC 1	N/A	N/A	N/A	15.36	N/A	N/A	N/A
Lc 2	11.5	16.35	12.6	24.43	8.85	6.97	11.74
Lc 3	31.59	40.1	41.11	N/A	13.4	42.03	40.16

จากการทดสอบความแข็งแรงในการยึดเกาะของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรพบว่าที่อัตราการ ใหลของ N₂ 15 sccm เกิดรอยแตก (crack) ของฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชรก่อนที่ฟิล์มจะเริ่มกะเทาะ (delamination) หลุดออกมา ส่วนที่อัตราการใหล 0 5 10 20 25 และ 50 sccm นั้นไม่เกิดรอยแตกแต่ ฟิล์มกลับกระเทาะหลุดออกเลย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าที่อัตราการใหลของ N₂ ที่15 sccm มีแรงยึดเกาะ ดีที่สุด

3.3.3 ผลการวิเคราะห์ก่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่อัตราการ ใหลของ N₂ที่ต่างกัน อัตราการไหลของ CH₄ ที่ 15 sccm กำลังคลื่นความถี่วิทขุ 200 วัตต์ อุณหภูมิ วัสดุฐาน 300 °C ซึ่งในการทดลองนี้ได้ศึกษาผลของอัตราการไหลของ N₂ ที่มีผลต่อค่าสัมประสิทธิ์ ความเสียดทาน ซึ่งที่จำนวนรอบของการทดสอบที่ 9,900 รอบ ซึ่งมีระยะทางทั้งหมดเท่ากับ 89.1 เมตร (รัศมีในการทดสอบเท่ากับ 4.5 มิลลิเมตร) มีค่าสัมประสิทธ์ความเสียดทานดังแสดงในตาราง ที่ 3.10 และ รูปที่ 3.72 ซึ่งผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานดังแสดงในตาราง ที่ 3.10 และ รูปที่ 3.72 ซึ่งผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานที่เพิ่มขึ้น เมื่อได้มีการเจือธาตุในโตรเจน และพบว่าฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่เจือธาตุในโตรเจน ผิวหน้าของ ฟิล์มจะมีความขรุงระเพิ่มขึ้น ดังแสดงในรูป 3.54 e. เมื่อปริมาณของในโตรเจนในฟิล์มมีค่ามากขึ้น เนื่องจากในโตรเจนที่ไปจับกับการ์บอนนั้นมีขนาดโตขึ้น และอาจเกิดเป็นคอลัมนา (Columnar) ดัง แสดงในรูป 3.54 (d.) หรือนาโนรอด (Nano-rod) ดังแสดงในรูป 3.54 (f.) และ (g.) ซึ่งส่งผลให้ก่า สัมประสิทธิ์ความเสียดทานนั้นมีค่าเพิ่มขึ้นด้วย

200 วัตต์							
	_		N ₂	Flowrate (s	sccm)		
	0	5	10	15	20	25	50
Friction coefficient	0.39	0.47	0.64	0.66	0.63	0.59	0.55





ร**ูปที่ 3.57** สัมประสิทธิ์ความเสียดทานของฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรที่อัตราการไหลของ № ต่างกัน อัตราการไหลของ CH4 ที่ 15 seem กำลังกลื่นกวามถี่วิทยุ 200 วัตต์



ร**ูปที่ 3.58** ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรที่อัตราการไหลของ N₂ ต่างกัน อัตราการไหลของ CH₄ ที่ 15 sccm กำลังกลื่นความถี่วิทยุ 200 วัตต์

ซึ่งจากรูปที่ 3.58 แสดงให้เห็นว่าการโด๊ปในโตรเจนที่ปริมาณมากขึ้นนั้นส่งผลให้ก่า สัมประสิทธิ์ความเสียดทานมีแนวโน้มที่สูงขึ้น เนื่องจากค่า I_D/I_G ที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดการ์บอนที่เรียง ตัวไม่เป็นระเบียบเพิ่มขึ้น และนอกจากนี้จากการวิเคราะห์ด้วย SEM พบว่าพื้นผิวฟิล์มการ์บอน กล้ายเพชรที่ได้มีลักษณะขรุขระ และเป็นแท่งนาโนรอด ดังแสดงในรูปที่ 3.54



ร**ูปที่ 3.59** สัมประสิทธิ์ความเสียดทานของฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรที่อัตราการไหลของ N₂ และ CH₄ ที่ 15 sccm และ กำลังกลื่นความถี่วิทยุต่างกัน

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร ที่กำลังคลื่น กวามถี่วิทยุต่างกัน อัตราการไหลของ N₂ และ CH₄ ที่ 15 sccm อุณหภูมิวัสดุฐาน 300°C ซึ่งในการ ทดลองนี้ได้ศึกษาผลของอัตราการไหลของ N₂ ที่มีผลต่อค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน ซึ่งที่ จำนวนรอบของการทดสอบที่ 9,900 รอบ ซึ่งมีระยะทางทั้งหมดเท่ากับ 89.1 เมตร (รัศมีในการ ทดสอบเท่ากับ 4.5 มิลลิเมตร) ดังแสดงในรูปที่ 3.59 พบว่าเมื่อกำลังของคลื่นความถี่วิทยุเพิ่มขึ้นค่า สัมประสิทธิ์ความเสียดทานมีก่าลดลง ซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับที่ได้อธิบายในรูปที่ 3.24 ซึ่งก็คือเมื่อ กำลังของคลื่นความถิ่วิทยุเพิ่มมากขึ้นทำให้โครงสร้างของการ์บอนมีพลังงานมากขึ้นที่จะจัดเรียง โครงสร้างให้เป็นระเบียบมากขึ้น ทำให้ฟิล์มที่ได้มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานลดลงดังกล่าว

3.3.4 ผลการวิเคราะห์ความต้านทานต่อความร้อน

จากผลการศึกษาความด้านทานความร้อยด้วยเทคนิค TGA (รูปที่3.60) ของฟิล์มการ์บอน คล้ายเพชรที่ไม่ได้ โต๊ปไน โตรเจนพบว่าในช่วงแรก ประมาณ 0-50°C น้ำหนักของฟิล์มการ์บอน คล้ายเพชรจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องมาจากการเกิดพันธะ H₂O ขึ้น แต่เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นในช่วง 50-250°C น้ำหนักของฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชรจะลดลงเล็กน้อย เนื่องมาจากการระเหยไปของ H₂O แต่ เมื่อเพิ่มอุณหภูมิในช่วง 250-400°C น้ำหนักของฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชรจะลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่ง กาดว่าน่าจะเกิดจากการสลายตัวของพันธะระหว่าง C และไปจับกับ O₂ ในบรรยากาศที่ใช้ในการ วิเคราะห์จนเกิดเป็น CO₂ แล้วระเหยออกไป หลังจากนั้นน้ำหนักของฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชร ก่อนข้างจะคงที่หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องเฟสออกไซด์ที่เสลียร แต่ฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชรที่โด๊ป ด้วยไนโตรเจนจะช่วยชะลอปรากฏการณ์ในช่วงอุณหภูมิ 250-400°C ให้เกิด CO₂ ลดลง ทำให้ น้ำหนักของฟิล์มการ์บอนคล้ายเพชรลดลงอย่างช้าๆอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้การโด๊ปไนโตรเจนอาจทำ ให้เกิดเฟส α -C₃N₄, β -C₃N₄, C₂N หรือ CN₂ ซึ่งเสลียรที่อุณหภูมิสูงมากกว่า



ร**ูปที่ 3.60** ความต้ำนทานความร้อนของฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรที่กำลังอัตราการไหลของ N₂ แตกต่างกัน และควบคุมอัตราการไหลของ CH₄ ที่ 15 sccm กำลังคลื่นความถี่วิทยุ 200 วัตต์ อุณหภูมิวัสคุฐาน 300°C

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

4.1 สรุปผล

4.1.1 จากการสังเคราะห์ฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรโดยการหาตัวแปรเบื้องต้นพบว่าฟิล์ม
การ์บอนคล้ายเพชรเกิดได้ดีที่สุดที่อัตราการไหลของแก๊สมีเทนที่ 15 sccm ที่อุณหภูมิวัสดุฐาน
300 °C และกำลังของคลื่นความถิ่วิทยุมากกว่า 75 วัตต์

4.1.2 ฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรที่เจือธาตุในโตรเจนเกิดพันธะระหว่าง C-N ที่กำลังของกลื่น กวามถี่วิทยุ 200 วัตต์

4.1.3 ฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรที่สังเกราะห์ได้กวามหนาโดยเฉลี่ย 300 นาโนเมตร

4.1.4 ของฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรที่ไม่ได้เจือธาตุไนโตรเจน มีก่ากวามแข็ง 4.92 GPa และ ก่ากวามแข็งของฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรที่เจือธาตุไนโตรเจน มีก่ากวามแข็งสูงสุดที่ 12.15 GPa

4.1.5 แรงยึดเกาะของฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรไม่ได้โด๊ปในโตรเจนกวามแข็งแรงในการยึด เกาะที่ต่ำกว่าฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรที่โด๊ปในโตรเจน โดยลักษณะของฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชร ไม่ได้โด๊ปในโตรเจนเกิดการกระเทาะหลุดออกมา แต่ฟิล์มการ์บอนกล้ายเพชรที่โด๊ปในโตรเจนเกิด เพียงรอยแตก ในช่วงตำแหน่งการให้แรงเดียวกัน (LC 2)

4.1.6 หลังการวิเคราะห์การสูญเสียน้ำหนักของฟิล์มตามอุณหภูมิด้วยเทคนิค TGA พบว่า ฟิล์มที่โด๊ปด้วยในโตรเจนที่ 15 sccm สูญเสียน้ำหนักมากสุดเพียง 25% ซึ่งน้อยกว่าฟิล์มที่ไม่ได้ด๊ป ในโตรเจนที่สูญเสียน้ำหนักสูงสุดที่ 46.5%

4.2ข้อเสนอแนะ

4.2.1. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ โด๊ปไน โตรเจนที่ทำให้ โครงสร้างของฟิล์มที่มีลักษณะ เป็นนาโนรอด

4.2.2 ควรติดตั้งเกรื่องแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าที่คงที่และระบบสำรองไฟฟ้าที่ส่งเข้าเครื่องพี อีซีวีดี เนื่องจากแหล่งจ่ายไฟของตึกที่ใช้ในการทำวิจัยนั้นมีความไม่คงที่ทำให้ระบบกำเนิดคลื่น ความถี่วิทยุเกิดความไม่สม่ำเสมอ ซึ่งส่งผลให้ระบบอื่นๆเกิดความผิดปกติตามมา ดังต่อไปนี้ ระบบ กำเนิดความร้อนที่ให้แก่วัสดุฐานไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ตลอดช่วงการทำการทดลองได้ ระบบหัวจ่ายแก๊สเข้าสู่ห้องทำปฏิกิริยาซึ่งค่าแก๊สที่ไหลผ่านมีค่าไม่คงที่

4.2.3 ควรมีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และคลื่นความถึ่ วิทยุ มาตรวจเช็คตามรอบการดูแลรักษา

4.2.4 ผู้ทำการวิจัยควรวางแผนการทคลองให้รอบคอบเผื่อไปถึงกรณีที่เครื่องเกิดปัญหาเป็น ระยะเวลานานซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถคำเนินการต่อไปได้ในระยะเวลาที่กำหนด

บรรณานุกรม

- ณัฐพงส์ กลขุนทด (2555). พฤติกรรมการด้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงาน ขึ้นรูปร้อนเกรด AISI H13 โดยการเคลือบผิวด้วยคาร์บอนที่มีคุณสมบัติกล้ายเพชร. วิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ธีรวรรณ บุญญวรรณ (2546). เอกสารคำสอนฟิสิกส์ของพลาสมา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1-2.
- A, Anders (2010). "A structure zone diagram including plasma-based deposition and ion etching". *Thin Solid Films*.(518) 15 4087-4090
- A.A.R. Wood (1991). "Carbon and Graphite". Advanced Ceramic Materials. 57-62.
- A, Erdemir., O, Eryilmaz., I, BNilufer., and G, Fenske (2000). "Effect of source gas chemistry on tribological performance of diamond-like carbon films". *Diamond Relat. Mater.* 9 632-637.
- C, Heau., R, Fillit, F., Vaux, and F, Pascaretti (1999). Surf. Coat. Technol. 120-121 200.
- C, Jarms., H, Stock., and P, Mayr (1998). Surf. Coat. Technol. 108-109 206.
- C, Mitterer (2000). "Application of hard coatings in aluminium die casting soldering, erosion and thermal fatigue behaviour". *Surf. Coat. Technol.*, 125 233–239
- C1624 05 Standard Test Method for Adhesion Strength and Mechanical Failure Modes of Ceramic Coatings by Quantitative Single Point Scratch Testing
- C.E. Nebel., (2014). "3.14 Surface Electronic Properties of Diamond". Comprehensive Hard Materials. 339-364.
- D.S, Knight., and W.B, White (1988). "Characterization of diamond films by Raman spectroscopy". J. Mater.Res. 4 385-393
- D, Sobol., Die Cast. Eng. 29 (11–12) (1985) 52.
- F, F Chen (1984). "Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion". *Plasma Physics*, Plenum Press New York. (1) 1-13.

H, Jehn., S, Hofmann., V, ckborn., W, Munz., and J, Vac (1986). Sci. Technol. A 4 (6) 2701.

- H, Ruiqiang, M, Shengli, C, K. Paul (2012), "Effects of Diamond-like Carbon Coatings with Different Thickness on Mechanical Properties and Corrosion Behavior of Biomedical NiTi Alloy", *Rare Metal Materials and Engineering*.41 9
- H, Liang., L, Delian., C, xian., Y, Li., and C, Yuqing (2012). "The deposition of thick tetrahedral amorphous film by argon ion bombardment". Appl. Surf. Sci. 258 4794-4800
- H.W. Kroto (1992), "Introduction", Carbon, 30 (8) 1139-1141.
- H, Zhang., L, Liu., Y, Wang., H, Ma., and F, Liu. (2007). "Structure and Mechanical Performance of Nitrogen Doped Diamond-like Carbon Films". J. Mater. Sci. Technol. 23 (4)
- J, C., C, Donnet., J. Fontaine., M. Belin., A. Grill., V. Patel., and C. Jahnes (2000). "Diamond-like carbon prepared by high density plasma". *Diam. Relat. Matter.*, 9 (3-6) 638-642
- J, Fricke (2003). "Mechanical reconstruction of an industrial 915 MHz Microwave cavity plasma reactor system for chemical vapor deposition diamond processes". Diploma thesis, Technische Fachhochschule Wiladu.
- J, Kim., and C, Lee (2003). "Dependence of the Physical Properties DLC Films by PECVD on the Ar Gas Addition". *Journal of the Korean Physical Society*, 42 S956-S960
- J, Laimer., H, Karner., H, Stori., and P, Rodhammer (1993). Mater. Sci. Forum 140 142–493.
- J, Robertson, (2002). "Diamond-like amourphous carbon". Mater. Sci. Eng., R. 37 129-281
- J.G.F Gerald., T. Hyde., R.G. Elliman., and B.L. Davies (2004). "Unconventional magnetic behavior in all carbon nano-foam". *Research School of Physical Sciences and Engineering*.
- J.R, Davis (1996). "Carbon and Alloy Steels". ASM Specialty Handbook, Davis & Associates, Metals Park, OH.
- J, Takadoum., J, Rauch., J, Cattenot., and N, Martin (2003). "Comparative study of mechanical and tribological properties of CN_x and DLC films deposited by PECVD technique". *Surf. Coat. Technol.* 174–175, 427–433

- K, Spear (1989). "Diamond ceramic coating of the future". J. Am. Cream. Soc., 72 (2) 171-91
- L, Marcinauskas., and A, Grigonis (2007). "Surface and structural analysis of carbon coating produced by plasma jet CVD". *Matters. Sci.*, 12 (4)
- L, Wan., and R, Ergerton (1996). Thin Solid Films. 276 34
- M, Inagaki., F, Kang., M, Toyoda., and H, Konno (2014). "Chapter 2-Carbon Nanotubes: Synthesis and Formation". *Adv. Matter. Res.* 15-40
- Q, Wei., and J, Narayan (2000). "Superhard diamond like carbon: preparation, theory, and properties". Int. Mater. Rev. 45 133-164
- S, Li., W, Wu., X, Wang., F, Wang., Y, Tang., and W, Sun. (2009). "Properties of N-doped Diamond-like Carbon Films Prepared by the PLD Method". Plasma and Fusion Research: Rapid Communications. 4 S1008
- S, Prawer., K.W, Nugent., and D.N, Jamieson (1998). "The raman spectrum of amorphous diamond". *Diamond Relat. Mater.* 7 106-110.
- S, Prawer., K.W, Nugent., D.N, Jamieson., J.O, Orwa., L.A, Bursil., and J.L, Peng (2000). "The Raman spectrum of nanocrystalline diamond". *Chem. Phys. Lett.* 332 93-97
- S, Rahman., M, Othman., and P, May (2012). "Raman and Photoluminescence Spectroscopy of Nanocry stalline Diamond Films grown by Hot Filament CVD" Adv. Matter. Res. 501 271-275
- S, Sarmid., K, Oeraman., B, Ismail., and S, Sakrani (2006). "Effect of Substrate Temperature on the Properties of Diamond-like Carbon Deposited by PECVD in Methane Atmosphere". *Proceedings of Annual Fundamental Scion Seminar*.
- S, Smith., S, Voight., H, Tompkins., A, Hooper., A, Talin., and J, Vella (2001). "Nitrogen-doped plasma enhanced chemical vapor deposited (PECVD) amorphous carbon: processes and properties". *Thin Solid Films*. 398–399, 163–169
- W, Jarernboon., V, Amornkitbamrung., and T, Burinprakhon. (2003). "Diamond like carbon Films from microwave plasma chemical vapor deposition". *KKU Res J (GS)3 : supplement*

- W.C. Oliver, Measurement of hardness and elastic modulus by Instrumented indentation: Advances in understanding and refinements to methodology, The University of Tennessee and Oak Ridge National Laboratory, Department of Materials Science and Engineering, Knoxville, Tennessee.
- X, Yan., T, Xu., S, Yang., H, Liu., and Q, Xue (2004). "Characterization of hydrogenated diamond-like carbon films electrochemically deposited on a silicon substrate". J. Phys. D: Appl. Phys. 37 2416–2424
- Y, Kima,, S, Choa., W, Choib., B, Hongb., and D, Yoon (2003). "Dependence of the bonding structure of DLC thin films on the deposition conditions of PECVD method". Surf. Coat. Technol. 169 –170 291–294

ภาคผนวก ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ Advanced Materials Research Vol. 893 (2014) pp 528-532 Online available since 2014/Feb/19 at www.scientific.net © (2014) Trans Tech Publications, Switterland doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.893.528

Comparison of DLC and N-doped DLC synthesized by RF-PECVD

Witit Janchocktawe e^{1, a}, Vishnu Rachpech^{1,b}, Jessada Wannasin^{1, c} ¹Department of Mining and Materials Engineering, Faculty of Engineering, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112, Thailand "wenakawa@gmail.com, ^b rvishnu@eng.psu.ac.th, ⁵wannasin@msn.com

Keywords: Diamond-like carbon; Nitrogen-doped DLC; PECVD

Abstract. Diamond-like carbon (DLC) films and nitrogen doped DLC (NDLC) were deposited on glass slide and H13 steel by plasma-enhanced chemical vapor deposition using a commercial RF 13.56 MHz (RF-PECVD). The films have been prepared from CH₄ for DLC and CH₄+N₂ mixtures for NDLC. The deposition process was at 300°C under argon atmosphere for 120 min. Bonding energy and diamond like carbon characteristic of DLC and NDLC films have been characterized by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and Raman spectroscopy. Thermalgravimetric Analyzer (TGA) was used to evaluate the thermal stability of the films which were scrapped off from a glass slide substrate. The mechanical properties was characterized, such as hardness by nano-indentation technique, scratch test by Rockwell diamond tip in progressive mode and friction coefficient have been measured in ambient air using a ball-on-disk tribometer.

Introduction

Diamond-like-carbon films (DLC) form a class of amorphous materials that combined high hardness, low friction coefficient, a high wear resistance to sliding surfaces even without any lubricants. DLC films can be deposited at low temperatures and high deposition rates by various techniques, including ion-beam deposition, plasma source ion implantation, DC and RF magnetron sputtering arc-physical vapor deposition (arc-PVD), plasma enhanced chemical vapor deposition (PECVD) and laser ablation. The presence of some dopants (silicon, nitrogen, itianium, tungsten, and boron) may improve the durability of DLC films at elevated temperatures [1]. In this study, we explore the effects of addition of nitrogen into DLC to improve theirs thermal stability. Therefore, hardness, adhesion and friction coefficient of DLC films synthesized by PECVD system were investigated.

Experimental

DLC films were deposited using a pure CH₄, Ar and N₂ gas mixture by PECVD system. DLC and NDLC films have been deposited on glass slide and H13 steel, mirror polished substrates, (2.5 cm in diameter and 4 mm in thickness). Plasma of PECVD was created radio frequency (13.56 MHz) generator. The reactor has two parallel plate electrodes, the upper was showerhead type gases precursors distribution, the bottom one was substrate holder equipped heater and thermocouple Ktype. The pumping unit is composed from a rotary pump and a turbomolecular pump to ensure high vacuum quality. Before deposition the substrates were ultrasonically cleaned in acetone. This substrate was etched in situ in argon plasma for 10 minutes. Films deposition conditions are showed in Table 1.

The films were characterized by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and Raman spectroscopy using argon ion laser (532 nm) for characterization of CH and CN_x bonds. DLC and NDLC were examined under a scanning electron microscope (SEM). DLC and NDLC

All rights reserved. No part of contents of this paper may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the written permission of TTP, www.tp.net. (ID: 202:12.73 65-03039/14,06.44.95) were scrapped off the glass slide into powder for film measurement thermal stability of DLC and NDLC films were measured using Thermalgravimetric Analyzer (TGA) under oxygen atmosphere condition.

Hardness was measured by a Nano Hardness Tester (NHT) CSM Instrument. Berkovich pyramid diamond tip with 100 mN load was applied.

Scratch test was measured by a Revetest (RST) CSM Instrument. Rockwell diamond tip was used in a progressive mode from 0.9 N to 100 N.

Wear test was using a ball-on disk method was used for wear tests. An alumina ball of 6 mm diameter was used as a friction part. Loading of 2 N was applied. The sliding speed was set at 4 cm/s and the overall sliding distance was 280 m.

rane r Deposition conditions of DLC and NDLC in	Fable 1	De	position	conditions	of DL	C and	NDLC	film
---	---------	----	----------	------------	-------	-------	------	------

Condition	DLC	NDLC
Base pressure (Pa)	$< 4.4 \times 10^{-2}$	$< 4.4 \times 10^{-2}$
Operating pressure (Pa)	4.1×10	7.3×10
CH4 flow rate (sccm)	15	15
Ar flow rate (sccm)	20	20
N ₂ flow rate (sccm)	-	15
Deposition time (min)	120	120
Substrate Temperature (°C)	300	300
Rf power (Watt)	200	200

Results and discussion



Examination under a scanning electron microscopy (SEM), as shown in Figure 1, showed that the thickness of DLC and NDLC films were around 300 nm. The typical Raman spectra of DLC and NDLC films without baseline was shown in Figure 2. A broad peak with Raman shift was ranging from 1100 to 1700 cm⁻¹. D peak and G peak were around 1330-1350 cm⁻¹ and 1580-1590 cm⁻¹, respectively. When the Raman spectra was fitted with Gaussian function, for DLC films D peak position was 1334 cm⁻¹. G peak was 1588 cm⁻¹ and Ig/I_G was 0.70. For NDLC, the D peak position was 1349 cm⁻¹, G peak was 1580 cm⁻¹ and Ig/I_G was 0.66. Robertson [2] reported that the sp³ fraction have 40-50% of Ig/I_G in range –0.6-0.9. The decrease in Ig/I_G and the shift in their position to lower wavelengths were indicatives of less extended graphitic domains, which were attributed to an increase in the degree of disorder of the sp² bonds and an increase in the number of sp³ bonds in the structure [3].

529

Raman spectra of CN films were similar to amorphous carbon (a-C) films. Although the characteristic peak due to covalent C=N bonds was observed at 2200 cm⁻¹ in the visible Raman spectra of carbon nitride films with higher nitrogen content [4], it was not observed in our Raman spectrum. It may indicate that the nitrogen content is very low in nitrogen-doped DLC films.

The FTIR spectra shown in Figure 3 indicated that the region between 2800-3000 cm⁻¹ which corresponded to the C-H local vibrations and stretching modes. In DLC and NDLC films weak peaks appeared in the range of 2800-3050 cm⁻¹. The three peaks, approximately 2850, 2920 and 2955 cm⁻¹ corresponded to sp⁻³-CH₂ symmetric vibrational frequencies, sp⁻³-CH₂ or CH asymmetric vibrational frequencies and sp⁻³-CH₃ asymmetric vibrational frequencies [5, 6]. The FTIR spectrum of NDLC film was in the range of 1250-2200 cm⁻¹. The peaks at approximately 1600, 1625 and 1682 cm⁻¹ were assigned to the sp² C=N bonds and the one approximately 2100 cm⁻¹ to CN bondings [7].



Fig. 2 Raman spectra of: (a) DLC film and (b) NDLC film.

Fig. 3 FTIR spectra of: (a) DLC film and (b) NDLC film.

Thermal stability of DLC and NDLC films from Thermalgravimetric Analyzer (TGA) were shown in Figure 4. At the beginning Weight % of DLC films increased sharply due to the decomposition of the CH bond in the film and the reaction with the oxygen. After 100°C the weight% gradually decreased to about 50% and stable at -400°C. For NDLC film, weight% gradually decreased to 75% and stable after -300°C. It was found that at temperature lower than 400°C, DLC films decomposed at a slower rate. But at temperature higher than 400°C, the NDLC seem to be better thermal resistance. Because of the N-H bond that would be only found in NDLC is more thermal stable than C-H bond [8].

The friction and wear testing of DLC and NDLC samples were carried out in a ball-on-disk tribometer at room temperature under a 2 N load. The sliding speed was set to 4 cm/s and the overall sliding distance was 280 m (10,000 cycles). An alumina ball using as a friction partner with 6 mm diameter were used. Figure 5 showed the friction coefficient of DLC and NDLC samples. The friction coefficient of NDLC was higher than DLC and tended to increase until 10,000 cycles. The friction coefficient increased due to the formation of C_nN phase, which might obstruct the friction mechanism of amorphous carbon films [9].



The hardness was measured by nano-indentation. The hardness of the NDLC film was 12.1 GPa. This was relatively higher than DLC (4.9 GPa). It should be noted here that the hardness value were very low in compare to DLC hardness of 30 GPa that reported by other researchers. It was probably because of too high indentation load for quite thin DLC films. The relatively higher hardness of N-doped DLC might come from high hardness CN which presented in the film [10].

Progressive mode with loading 0 to 100 N was used in the scratch test. In the DLC sample film was delaminated with load 11.7 N. For NDLC sample, film was cracked with load 16.4 N. The film on NDLC showed better adhesion properties than DLC. Scratch track at firstly cracking point were shown in Figure 6.



Figure.6 Optical micrograph of film after scratch test a.) DLC and b.) NDLC

Conclusion

DLC and N-doped DLC films were deposited on a glass slide and H13 steel substrates by RF-PECVD technique. The chemical bonding of the films were characterized by FTIR and Raman spectroscopy. FTIR results show the peak of DLC and NDLC at the wavelength between 2800-3000 cm⁻¹ which corresponded to C-H bonding. Whereas, the C-N bonding which appeared in the range of 1250-2200 cm⁻¹ was only found from N-doped DLC film. Raman spectra show, DLC films D peak position was 1334 cm⁻¹, G peak was 1588 cm⁻¹ and I_D/I_G was 0.70, for NDLC D peak position was 1349 cm⁻¹, G peak was 1580 cm⁻¹ and I_D/I_G was 0.66. Raman spectra of CN films was not observed in Raman spectrum. This might indicate that the nitrogen content was showed that the NDLC film could withstand high temperatures over DLC film at the temperature higher than 400°C. The result of hardness by nano-indentation showed that NDLC was relatively harder than DLC. The wear test by ball-on-disc showed higher friction coefficient of NDLC than DLC which might be due

531

to the formation of $C_x N$ phase which obstruct the friction mechanism of amorphous carbon films. Our results indicated that NDLC was better than DLC, except its higher friction coefficient. We intend to focus our next work on this point.

Acknowledgements

This work was supported by Higher Education Research Promotion and National Research University Project of Thailand (Funding No. ENG 5400551g), office of the Higher Education Commission and the Materials Engineering Research Center (MERC), Department of Mining and Materials Engineering, Faculty of Engineering, Prince of Songkla University, Thailand.

Reference

[1] A. Erdemir, G.R. Fenske, Tribol. Trans. 39 (1996), 787.

- [2] J. Robertson (2002), Matter. Sci. Eng. 37 (2002), 129.
- [3] E. C. Oliveira, S. A. Cruz and P. H. L. Aguiar, J. Braz. Chem. Soc. 23 (9) (2012), 1657.
- [4] D. Marton, K.J. Boyd, J.W. Rabalis, Int. J. Mod. Phys. B 9 (1995) 3526.
- [5] C. Thomsen, S. Reich, Phys. Rev. Lett. 85 (2000) 5214.
- [6] T. Heitz, B. Drevillon, C. Godet, J.E. Bouree, Phys. Rev. B 58 (1998), 13957.
- [7] T. Szorenyi, C. Fuchs, E. Fogarassy, J. Hommet, F.L. Normand, Surf. Coat. Technol. 125 (2000), 308.
- [8] S. M. Smith, S. A. Voight, H. Tompkins, A. Hooper, A. A. Talin, J. Vella. Thin Solid Film. 398-399 (2001), 163.
- [9] T.Ohana, A. Goto, K.Y amamoto, T. Nakamura, A. Tanaka, Y.Osawa. Diamond Relat. Mater. 10 (2001), 1093.
- [10] J. Takadoum, J.Y. Rauch, J.M. Cattenot, N. Martin. Surface and Coatings Technology 174 175 (2003), 427.

532

Advanced Materials and Engineering Materials III 10.4028/www.scientific.net/AMR.893

Comparison of DLC and N-Doped DLC Synthesized by RF-PECVD 10.4028/www.scientific.net/AMR.893.528